



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 558]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2011/चैत्र 10, 1933

No. 558]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2011/CHAITRA 10, 1933

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2011

सं. 38 (आरई-2010)/2009-2014

का.आ. 673(अ).—2010 में यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 और धारा 14क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा, इस अधिसूचना के अनुलग्नक के अनुसार विनिर्दिष्ट माल, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों अर्थात् स्पेशल कैमिकल्स, आर्मेनिज्म्स, मैटीरियल्स, इक्विपमेंट्स एवं टेक्नोलोजीज (स्कोमेट) की सूची को अधिसूचित करती है। अनुलग्नक में शामिल स्कोमेट मर्दों का निर्यात, अनुलग्नक में दी गई शर्तों के अनुसार विनियमित होगा। 2010 में यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के अध्याय IVक के प्रावधान अनुलग्नक में यथा उल्लिखित माल, सेवाओं और प्रौद्योगिकी पर लागू होंगे।

2. इस अधिसूचना का अनुलग्नक, निर्यात और आयात मर्दों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण, 2009-2014 की अनुसूची 2 के मौजूदा “परिशिष्ट-3” का स्थान लेगा।

3. अधिसूचना का उद्देश्य.—2010 में विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 का संशोधन किया गया था। इस संशोधन के द्वारा विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 में एक नया अध्याय IVक जोड़ा गया। यह विनिर्दिष्ट माल, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों के निर्यात के नियंत्रण के बारे में है और केन्द्र सरकार को ऐसे माल, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों की सूची को अधिसूचित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिसूचना उन माल सेवाओं और प्रौद्योगिकियों को सूचीबद्ध करता है, जिस पर 2010 में यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 के अध्याय IVक के प्रावधान लागू होंगे। यह सूची निर्यात और आयात मर्दों के आईटीसी (एचएस) वर्गीकरण की अनुसूची 2 के “परिशिष्ट-3”, जिसे सामान्य रूप से स्कोमेट सूची के नाम से जाना जाता है, का स्थान लेगी।

:

[फा. सं. 01/91/171/14/एम-11/एक्स्पोर्ट सैल]

अनुप के. पूजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

अनुलग्नक

परिशिष्ट - 3

स्पेशल कैमिकल्स, आर्गेनिज्म्स, मैटीरियल्स, इक्विपमेंट्स एवं टेक्नॉलोजीज (स्कोमेट) जिनका निर्यात विनियमित है ।

नीचे दी गई सूची में उल्लिखित स्पेशल कैमिकल्स, आर्गेनिज्म्स, मैटीरियल्स, इक्विपमेंट्स एवं टेक्नॉलोजीज (स्कोमेट) का निर्यात केवल इस बारे में जारी निर्यात लाइसेंस के प्रति अनुमत होगा जब तक निर्यात निषिद्ध है अथवा किसी विशिष्ट वर्ग अथवा मद के प्रति/तहत यथा विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हों, की प्रति के प्रति लाइसेंस के बिना अनुमत है ।

2010 में यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के अध्याय IVक के प्रावधान नीचे दी गई सूची में यथानिर्दिष्ट माल, सेवाओं और प्रौद्योगिकियों पर लागू होंगे ।

भारत में पंजीकृत सभी कम्पनियों और उनकी सहायक कम्पनियों तथा भारत में प्रचालित उन सभी व्यवसायिक इकाईयों, जो नीचे सूचीबद्ध स्पेशल कैमिकल्स, आर्गेनिज्म्स, मैटीरियल्स, इक्विपमेंट्स एवं टेक्नॉलोजीज (स्कोमेट) के विनिर्माण, संसाधन और उपयोग में लगी है, के लिए कोई व्यवस्था अथवा समझौता जिसमें सीधे अथवा किसी भारतीय पक्ष अथवा पक्षों के माध्यम से कार्य करते हुए विदेशी सरकारों अथवा विदेशी तृतीय पक्षों द्वारा स्थल के दौरे, स्थल पर जाँच अथवा अभिलेखों/प्रलेखीकरण तक पहुँच सुलभ कराने अथवा करने की जिम्मेवारी शामिल है, करने से पहले केन्द्र सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है । ऐसी अनुमतियों के अनुरोधों पर उसी तरीके से विचार किया जाएगा जिस प्रकार से निर्यात/आयात लाइसेंस के अनुरोधों पर विचार किया जाता है ।

बशर्ते कि जहाँ विदेशी सरकारों अथवा विदेशी तृतीय पक्षों द्वारा स्थल दौरा, स्थल पर जाँच अथवा अभिलेखों/प्रलेखीकरण तक पहुँच कराने से संबंधित जिम्मेवारी किसी द्विपक्षीय समझौते अथवा बहुपक्षीय संधि जिसमें भारत एक पार्टी है के अन्तर्गत ली जाती है, तो संबद्ध समझौते अथवा संधि के प्रावधान लागू होंगे ।

निर्यातकों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर यथा जारी, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में स्कोमेट मदों के निर्यात से संबंधित संगत मार्ग निर्देशों को देखें ।

शब्दावली : स्कोमेट सूची में प्रयुक्त अभिव्यक्तियों का अर्थ निम्नलिखित है :

"परिशुद्धता" को प्रायः अशुद्धता के संबंध में मापा जाता है, अर्थात् एक स्वीकृत मानदण्ड अथवा शुद्ध मूल्य से दिया गया मूल्य सकारात्मक अथवा नकारात्मक अधिकतम कितना विचलित है ।

"एक्टिव फ्लाइट नियंत्रण प्रणाली" ऐसी प्रणाली है जो, मल्टीप्ल सेंसरों से स्वायत्त रूप से संसाधित उत्पादों द्वारा अवांछनीय "विमान" और प्रक्षेपास्त्र गतियों अथवा संरचनात्मक भारों को रोकने के लिए कार्य करती है और इस प्रकार स्वचालित नियंत्रण करने के लिए आवश्यक निवारक नियंत्रण प्रदान करता है ।

"एयर क्राफ्ट" वह हवाई वाहन जिसमें फिक्सड विंग, स्वाइवल विंग, रोटरी विंग (हेलीकाप्टर), ट्रिल रोटर अथवा ट्रिल विंग लगे हों ।

"एंग्यूलर पोजीशन डेविएशन" का तात्पर्य है अपनी शुरूआती पोजीशन से टेबल का वर्क पीस माऊंट निकलने के बाद एंग्यूलर पोजीशन और वास्तविक, काफी वास्तविक पैमाईश एंग्यूलर पोजीशन ।

"कम्पोजिट" का तात्पर्य है "मैट रिक्स" और पाटीकल्स, विस्कर्स, फाइबर्स अथवा विशिष्ट प्रयोजन अथवा प्रयोजनों हेतु उपस्थित उनका कोई संयोजन ।

"कम्पोजिट थ्योरियकल परफार्मांस" ("सीटीपी") कम्पाऊंडिंग एलीमेंट्स (सीई) के समुचय को इस्तेमाल करते हुए संगणित थ्योरिटिकल आपरेशन्स के प्रति सैकेंड मिलियन्स में पैमाईश की गई कम्प्यूटेशनल परफार्मेंस ।

"कनट्यूरिंग कंट्रोल" का तात्पर्य है अनुदेशों के अनुसार कार्यरत दो या उससे अधिक "न्यूमरिकली कंट्रोल्ड" मोशन्स जो अगली आवश्यक स्थिति और उस स्थिति की आवश्यक फीड रेट्स को विनिर्दिष्ट करते हैं ।

"सीटीपी" "कम्पोजिट थ्योरियकल परफार्मांस" के समकक्ष है ।

"डिजाइन किए अथवा संशोधित" उपकरण, पाटर्स अथवा कम्पोनेट्स को बताते हैं जो "विकास" अथवा संशोधन के परिणामस्वरूप विशिष्ट प्राप्टीज से लैस हों जो उन्हें विशेष एप्लीकेशन हेतु उपयुक्त बनाते हैं ।

"डिवेलपमेंट" : "उत्पादन" से पूर्व सभी अवस्थाओं से संबंधित क्रिया जैसे कि डिजाइन, डिजाइन रिसर्च, डिजाइन एनालिसिस, डिजाइन कंसेप्ट्स, एसेम्बली और प्रोटोटाइप्स की टैस्टिंग, पायलर प्राडक्शन स्कीमों, डिजाइन डाटा, उत्पाद में डिजाइन डाटा की रूपांतरण की प्रक्रिया, कंफिग्रेशन डिजाइन, इंटीग्रेशन डिजाइन, ले आऊट।

"डिजिटल कम्प्यूटर" का तात्पर्य है वह उपकरण जो निम्नलिखित एक अथवा उससे अधिक कार्य करता है :-

- क) डाटा स्वीकार करना
- ख) फिक्सड अथवा आल्टरेबल (राइटेबल) स्टोरेज डिवायसेज में अनुदेश अथवा डाटा स्टोर (करना)।
- ग) अनुदेशों की स्टोर की गई प्रणाली के अनुसार डाटा को प्रोसेस करना जो परिवर्तनीय हो; और
- घ) डाटा का आऊटपुट प्रस्तुत करना।

एन.बी : अनुदेशों के स्टोर की प्रणाली के परिवर्तनों में फिक्सड स्टोर डिवायसेज को प्रतिस्थापित करना शामिल है, लेकिन वायरिंग अथवा इंटर कॉन्ट्रोल्स में वास्तविक परिवर्तन के बिना।

"विस्फोटक" ठोस, तरल अथवा गैसीय पदार्थ अथवा उनका मिश्रण जो अपने एप्लीकेशन में प्राथमिक तौर पर बूस्टर अथवा वारहैडस् में प्रमुख हमलों, संहार और अन्य एप्लीकेशंस में विस्फोट हेतु आवश्यक होते हैं।

"फायब्रस अथवा फिलामेंटरी मैटीरियल्स" में निम्न शामिल हैं :-

- क) कंटीन्यूअस् "मोनोफिलामेंट्स";
- ख) कंटीन्यूअस् "यार्न्स" और "रोविंग्स";
- ग) "टेप्स्" फैब्रिक्स रेडम मैट्स और ब्रेडस्स;
- घ) चोप्ड फाइबर्स, स्टेपल फाइबर्स और कोहरेन्ट फाइबर बलेंकेट्स्स्;
- ड.) विस्कर्स, मोनो क्रिस्टलिन अथवा पोलीक्रिस्टलिन, किसी भी लम्बाई के;
- च) एरोमैटिक पोलीमाइड पल्प।

"हाइब्रिड कम्प्यूटर" का तात्पर्य है जो निम्नलिखित सभी कार्य कर सकता है :-

- क) डाटा स्वीकार करना;

- ख) एनालाग और डिजीटल दोनों तरीकों से डाटा को प्रोसेस करें; और
- ग) डाटा का आऊटपुट प्रस्तुत करना ।

"इमेज संवर्धन" का तात्पर्य है एलगोरिद्म्स द्वारा बाह्य प्राप्त सूचना इमेजों को प्रोसेस करे जैसे कि टाइम कंप्रेशन, फिल्टरिंग, एक्सट्रैक्शन, स्लेक्शन, कोरिलेशन, कंवोल्यूशन अथवा डोमेनस्स् (यानी फास्ट फोरियर ट्रांसफार्म अथवा वाल्श ट्रांसफार्म) के बीच ट्रांसफार्मेशन्स् । इसमें एलगोरिद्म्स शामिल नहीं है केवल लाइनयर अथवा सिंगल इमेज का रोटेशनल ट्रांसफार्मेशन इस्तेमाल करना जैसे कि ट्रांसलेशन, फीचर एक्सट्रैक्शन, रजिस्ट्रेशन अथवा फाल्स् कलरेशन ।

"इनफार्मेशन सिक्योरिटी" का तात्पर्य है एक्सेसेबिलिटी, गोपनीयता अथवा जानकारी अथवा संचार की सत्यता जिसमें गलत कार्यप्रणाली से सुरक्षा के इरादे से तरीके व कार्य शामिल नहीं हैं । इसमें क्रिप्टोग्राफी "क्रिप्ट एनालिसिस", कम्प्यूटर सुरक्षा से समझौता के प्रति संरक्षण शामिल हैं ।

एन बी : 'क्रिप्टाएनालिसिस' : क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम के एनालिसिस अथवा क्लीयर टैक्सट समेत गोपनीय है वैरिएबल्स् अथवा संवेदनशील डाटा प्राप्त करने हेतु इसके इनपुट और आऊटपुट ।

"इंसूलेशन" को राकेट मोटर के संघटकों यानी केस नोजल, इनलेट्स्, केस क्लोजर पर इस्तेमाल किया जाता है तथा संसाधित अथवा अध - संसाधित कम्पांजुडेड रबड़ शीट स्टाक जिसमें इंसूलेटिंग अथवा रिफ्रेक्टरी सामग्री शामिल है । इसे स्ट्रैस रिलीफ बूट्स् अथवा फ्लैट्स् के तौर पर भी शामिल किया जा सकता है ।

"इंटीरियर लाइनिंग" सालिड प्रोपेलेट और केस अथवा इंसूलेटिंग लाइनर के बीच बांड इंटरफेस हेतु उपयुक्त है । सामान्यतः रिफ्रेक्टरी अथवा इंसूलेटिंग सामग्रियों यानी कार्बन फिल्ड हाइड्रोक्रिसल टर्मिनेटिड पोली बुटाडाइन (एचटीपीबी) अथवा अन्य पालीमर विद - एडेड क्यूरिंग एजेंट्स् स्प्रेयड अथवा स्क्रीडिड ओवर ए केस इंटीरियर ।

"आइसोलेटिड लाइव कल्वर्स" में स्थिर अवस्था और शुष्कित तैयार सामग्रियों में लाइव कल्वर्स शामिल हैं ।

"आइसोस्टेटिक प्रेसेस" का तात्पर्य है उपकरण जो विभिन्न माध्यमों (गैस, तरल, ठोस पदार्थों आदि) के माध्यम से वर्कपीस अथवा सामग्री पर कैविटी के भीतर सभी दिशाओं में समान दबाव बनाने हेतु कलोजड़ कैविटी पर दबाव बनाने में सक्षम उपकरण ।

"लेजर" : संघटकों की एक असेम्बली जो स्पेशियली और टेम्पोरेली कोहेरेट लाइट जो रेडीएशन के स्टिमूलेटिड एमिशन द्वारा संवर्धित हो ।

"लीनियेरिटि" (सामान्यतः गैर - लीनियेरिटी के अनुसार पैमाइश किए गए) का तात्पर्य है वास्तविक विशेषता (अप्स्केल और डाऊन स्केल रीडिंग्स का औसत), सकारात्मक अथवा नकारात्मक, सीधी लाइन से इस प्रकार स्थापित की अधिकतम अन्तर को बराबर अथवा घटाया जा सके ।

"मैटरिक्स" का तात्पर्य है अधिकतर सतत प्रक्रिया जो पार्टिकल्स, विस्कर्स अथवा फाइबर्स के बीच स्थान को भरता हो ।

"पैमाइश अनिश्चितता" एक विशिष्ट मानदंड है जो विनिर्दिष्ट करता है कि मेजरेबल वेरिएबल्स की सही उत्पाद वैल्यू की किस सीमा तक है जिसका कांफीडेस लेबल 95 प्रतिशत हो । इसमें अनकरेक्टेड सिस्टेमेटिक डेविएशन्स, अनकरेक्टेड बैकलैश और रेडम डेविएशन्स शामिल हों ।

"माइक्रोसर्किट" एक डिवाइस है जिसमें विभिन्न पैसिव और/अथवा एक्टिव एलीमेंट्स स्वतंत्र तौर पर अथवा सतत ढाँचे में सर्कट का कार्य करते हैं । "माइक्रो प्रोग्राम" स्पेशल स्टोरेज में रखी जाने वाली सामान्य अनुदेशों की श्रृंखला, जिसको शुरू करने से पहले सन्दर्भ अनुदेश रजिस्टर में रखा जाता है ।

"मिसाइलें" का तात्पर्य है सम्पूर्ण राकेट प्रणालियाँ और मानवरहित वायूयान प्रणालियाँ ।

"संशोधित" "सॉफ्टवेयर" के सन्दर्भ में साफ्टवेयर द्वारा प्रतिपादित जिस इरादतन बदला गया ताकि इसमें वे विशेषताएँ हो जो इसे विनिर्दिष्ट उद्देश्यों अथवा प्रयोगों हेतु उपयुक्त बनाते हैं । इसकी विशेषताएँ उन उद्देश्यों अथवा प्रयोगों के अलावा भी इसे उपयुक्त बनाते हैं जिनके लिए इन्हें संशोधित किया गया है ।

"मोनोफिलामेंट" अथवा फिलामेंट फाइबर का लघुतम अंश है, व्यास में सामान्यतः कुछेक माइक्रोमीटर।

"मोनोलिथिक इंटेग्रेटेड सर्किट" का आशय है निष्क्रिय अथवा सक्रिया तत्व अथवा दोनों का संयोजन :

क. ये डिफ्यूजन प्रक्रिया, इमप्लांटेशन प्रक्रिया अथवा डिपोजीशन प्रक्रिया में अथवा अकेले सेमी कंडक्टिंग पीस आफ मैटीरियल में, एक कथित 'चिप' ;

ख. अविभाजित सहायक के तौर पर मान्य; और

ग. एक सर्कट के कार्य (कार्यों) को करना ।

एन बी: सर्कट एलीमेंट एलैक्ट्रानिक सर्कट का अकेला सक्रिय अथवा निष्क्रिय कार्यात्मक हिस्सा होता है यथा एक डिओड, एक ट्राजिस्टर, एक रेसिस्टर, एक कैपेस्टर आदि ।

"न्यूरल कम्प्यूटर" का आशय है संगणक यंत्र जो न्यूरान अथवा न्यूरानों के संग्रह के व्यवहार की नकल करने हेतु डिजाइन या संशोधित किया गया हो, यानी एक कम्प्यूटेशल यंत्र जो विगत डाटा पर आधारित कम्प्यूटेशनल कम्पोनेट्स की विविधता के अन्तर संबंधों की संख्या और वजन को मोड्यूलेट करने की अपनी हार्डवेयर क्षमता द्वारा पहचाना जाता है ।

"न्यूमरिकल कंट्रोल" का आशय है एक यंत्र द्वारा निष्पादित प्रक्रिया का स्वतः नियंत्रण जो प्रगति में कार्य के तौर पर सामान्यतः शुरू किए गए न्यूमरिक डाटा का इस्तेमाल करता है ।

"आप्टिकल समायोजित सर्किट" का आशय है "मोनोलिथिक समायोजित सर्कट" अथवा हाइब्रिड समायोजित सर्कट जिसमें फोटोसेसर अथवा फोटोमीटर के तौर पर कार्य करने हेतु एक या उससे अधिक डिजाइन किए गए अथवा आप्टीकल अथवा इलैक्ट्रो - आप्टीकल कार्य करना ।

"प्रिकर्सर्स" : विशेषतः विस्फोटों के विनिर्माण में प्रयुक्त रसायन ।

"प्रेशर ट्रांसड्यूसर्स" वे यंत्र हैं जो प्रेशर पैमाइश को इलैक्ट्रिकल सिग्नल में परिवर्तित करते हैं ।

"उत्पादन" से आशय है सभी उत्पादन अवस्थाओं (यानी उत्पाद इंजीनियरिंग) विनिर्माण, इंटीग्रेशन, असैम्बली (माऊंटिंग) जाँच, गुणवत्ता आश्वासन ।

"उत्पादन उपस्कर" टूलिंग, टेम्प्लेट्स, जिग्स, मेंड्रेल्स, माऊल्ट्स, डाइज, फिक्सचर्य, इलाइनमेंट मैकेनिज्मस, टैस्ट इक्विपमेंट, अन्य मशीनरी और उनके कम्पोनेंट्स, जो उत्पादन की एक अथवा उससे अधिक अवस्थाओं अथवा 'विकास' हेतु विशेषतः डिजाइन किए गए अथवा संशोधित हों ।

"उत्पादन सुविधाएँ" : उपस्कर और उसके लिए विशेष डिजाइन 'साफ्टवेयर' जो 'उत्पादन' की एक या उससे अधिक अवस्थाओं हेतु अथवा 'विकास' हेतु संस्थापनाओं में संयोजित ।

"कार्यक्रम" : एक प्रक्रिया हेतु अनुदेशों की शृंखला, अथवा इलैक्ट्रानिक कम्प्यूटर द्वारा की जाने वाली अवस्था में परिवर्तनीय ।

"प्रोपेलेंट्स" : पदार्थ अथवा मिश्रण जिसका मशीनी कार्य निष्पादन नियंत्रित दरों पर गर्म गैसों के भारी घनत्व को पैदा करने हेतु रसायनिक तौर पर प्रतिक्रिया करता है ।

"पब्लिक डोमेन" का आशय है सूचना के प्रसार पर कोई प्रतिबंध न होना, उस सूचना में बौद्धिक सम्पदा के किन्हीं विधिक अधिकारी के अस्तित्व से 'पब्लिक डोमेन' में सूचना को नहीं हटाता है ।

"रेडिएशन हार्डनड" : का आशय है संघटक अथवा उपकरण जो रेडिएशन स्तरों को बर्दाश्त करने हेतु डिजाइन अथवा रेटिड जोकुलरेडिएशन खुराब की 5×10^3 जी वाई अथवा 5×10^5 रेड्स (एस आई) अथवा उससे अधिक हो ।

"आवश्यक" : चूंकि "तकनालाजी" का आशय है "तकनालाजी" का केवल वह अंश जो नियंत्रित निष्पादन स्तरों, विशेषताओं और क्रियाओं से अधिक अथवा प्राप्त करने हेतु विशेष रूप से जिम्मेवार है। ऐसी 'आवश्यक' 'तकनालाजी' के तहत विभिन्न उत्पाद आएँगे ।

"रिजोलूशन" का आशय है पैमाइश डिवाइस अथवा डिजिटल उपकरणों जो बहुत कम महत्वपूर्ण हों ।

"रोविंग" लगभग समानांतर 'स्ट्रैडस' का (सामान्यतः 12 - 120) गुच्छा है ।

एन बी : स्टैण्ड "मोनोफिलामेट्स" (साधारणतः 200 से अधिक) का लगभग समानांतर व्यवस्थित गुच्छा है ।

"सैटलिंग टाइम" का आशय है कन्वर्टर के किन्हीं दो स्तरों के बीच स्थिर करते समय अंतिम वैल्यू के एकाध बिट के भीतर उत्पादन हेतु आवश्यक समय ।

"सिग्नल प्रोसेसिंग" का आशय है बाह्य तौर पर सूचनात्मक सिग्नलों की प्रक्रिया जो टाइम कम्प्रेशन, फिल्टरिंग, एक्सट्रैक्शन, सलैक्शन, कोरीलेशन, कन्वोलूशन अथवा डोमेनों (यानी फारस्ट फूरियर ट्रांसफार्म अथवा वाल्श ट्रांसफार्मेशन) के बीच ट्रांसफार्मेशन ।

"साफ्टवेयर" अभिव्यक्ति के किसी सशक्त माध्यम से निश्चित एक अथवा उससे अधिक "प्रोग्रामों" अथवा "माइक्रो प्रोग्रामों" का संकलन । तथापि, स्कोमेट सूची पर किसी मद के प्रति जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, सूची वह साफ्टवेयर नियंत्रित नहीं करती जो सार्वजनिक क्षेत्र अथवा निम्नतः जन साधारण को साधारणतया सुलभ हो :-

क. निम्न तरीके द्वारा बिना प्रतिबंध के खुदरा विक्रय केन्द्रों पर स्टाक से बेचा गया है:-

1. काउंटर पर कारोबार;
2. डाक द्वारा कारोबार; अथवा
3. टेलीफोन द्वारा कारोबार; और

ख. आपूर्तिकर्ता द्वारा बिना पर्याप्त समर्थन के प्रयोक्ता द्वारा संस्थापना हेतु डिजाइन किया गया ।

"स्पेस क्वालीफाइड" : 100 कि.मी. अथवा अधिक की ऊँचाई पर काम करने वाले हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट सिस्टमों अथवा उपग्रहों के स्थापना और प्रक्षेपण के प्रयोग हेतु विशेष इलैक्ट्रिकल, मैकेनिकल अथवा पर्यावरण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु डिजाइन, विनिर्मित और परीक्षित उत्पाद ।

"स्टेबिलिटी" का आशय है स्थायी तापमान शर्तों के तहत विशेष पैरामीटर के वैरीएशन से इसके कैलीब्रेटेड वैल्यू के मानक डेवीएशन (1 सिग्मा) इसे समय के एक कार्य के तौर पर अभिव्यक्त किया जा सकता है ।

"विशेषतः डिजाइन्ड" का आशय है उपकरण, पार्ट्स, संघटक अथवा 'साफ्टवेयर' जो 'विकास' के परिणामस्वरूप विशेष विशिष्टताएँ रखता हो जो कतिपय पूर्व निर्धारित प्रयोजनों हेतु स्वयं को अलग दर्शाता है। उदाहरणार्थ, एक उपकरण जो विशेषतः डिजाइन किया गया हो उस पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब वह किसी अन्य कार्य अथवा प्रयोग के लायक न हो। अतः कोई विनिर्माण उपकरण जो कतिपय प्रकार के संघटक उत्पाद हेतु विशेषतः डिजाइन किया गया हो उस पर तभी विचार किया जाएगा जब वह अन्य प्रकार के संघटकों को उत्पादित करने में अक्षम हो।

"टेप" इंटरलेसड् अथवा यूनी डायरेक्शनल, "मोनोफिलामेट्स" 'स्ट्रैड्स्' "रोविंग्स्" "टो" अथवा "यार्न" आदि सामान्यतः प्रीइम्प्रेग्नेटिड विद रसिन से निर्मित सामग्री। एन.बी : "स्ट्रैड्स्" "मोनोफिलामेट्स" (सामान्यतः 200 से अधिक) का बंडल, व्यवस्थित लगभग समानांतर।

"तकनालाजी" का आशय है, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो रक्कोमेट सूची में किसी मद के प्रति, सूचना ('साफ्टवेयर' में निहित सूचना समेत) जो 'पब्लिक डोमेन' की सूचना के अलावा हो, जो निम्न में प्रयोग हेतु सक्षम है :-

क. किसी माल अथवा साफ्टवेयर का विकास, उत्पादन अथवा प्रयोग;

ख. किसी प्रकार की औद्योगिक अथवा वाणिज्यिक गतिविधि अथवा सेवा को उपलब्ध कराना अथवा उसका विकास।

स्पष्टीकरण :- जब तकनालाजी को सम्पूर्णतः अथवा अंशतः (अथवा माल जिससे वह संबंधित हो) को इंगित किया जाएगा इसमें वे सेवाएँ शामिल होंगी जो प्रदान या प्रयोग की जा रही हैं जो ऐसी तकनालाजी अथवा माल के प्रयोग अथवा विकास, उत्पादन में प्रयोग के लिए सक्षम हो।

"टो" "मोनोफिलामेट्स" का बंडल है, सामान्यतः लगभग समानान्तर।

"टोक्रिसन्स" से आशय है जान बूझकर छोड़े गए माल अथवा मिश्रण की शक्ल में टोक्रिसन्स, इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसे कैसे उत्पादित किया गया, पैथोलोजिकल स्पेसीमेंस, फसलें, खाद्य वस्तुएँ अथवा "माइक्रो आग्रेनिज्मस्" के बीज भंडार।

"मानव रहित वायुयान" ("यूएवी") से तात्पर्य है उड़ान शुरू करने और यान में किसी भी मनुष्य की उपस्थिति के बिना उड़ान और चालन को लगातार नियंत्रित करने में सक्षम कोई वायुयान

"में प्रयोज्य" "प्रयोज्य हेतु" "यथा प्रयोज्य" अथवा "हेतु सक्षम" उस विवरण हेतु प्रयोग किया जाता है यथा उपकरण; पार्ट्स, संघटक, मैटीरियल्स अथवा "साफ्टवेयर" जो विशेष प्रयोजन हेतु उपयुक्त है। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि उपकरण, पार्ट्स, संघटकों, तकनालाजी अथवा "साफ्टवेयर" की रचना, संशोधन अथवा विनिर्देश किया जाना चाहिए। ("विशेषतः डिजाइन किए गए के साथ तुलना करें" - ऊपर देखें)

"प्रयोग" में संचालन; संस्थापना (साइट पर संस्थापना); देखरेख; मरम्मत; ओवर हाल, रिफर्बिंशिंग शामिल है।

"वैक्सिन" एक औषध उत्पाद है जो या तो विनिर्माण अथवा प्रयोग करने वाले देश में या फिर विनियमन प्राधिकारियों द्वारा जो विपणन अथवा क्लीनिकल प्रयोग हेतु प्राधिकृत हों, द्वारा फार्मास्यूटिकल नुस्खे हेतु लाइसेंसशुद्धा हों। यह औषध मनुष्यों अथवा जानवरों को बीमारी दूर करने हेतु रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक हो।

"यार्न" टेड़े-मेड़े धागों के गठन को कहा जाता है।

एन.बी. : धागा मोनोफिलामेटों (सामान्यतः 200 से ऊपर) के लगभग समानांतर व्यवस्थित गठन को कहते हैं।

स्कोमेट सूची की मर्दों को निम्नलिखित श्रेणियों में रखा गया है।

श्रेणी 0 परमाणु सामग्रियाँ, परमाणु संबंधी अन्य सामग्रियाँ, उपकरण और प्रौद्योगिकी।

0क निर्धारित पदार्थ

0क1 स्रोत सामग्री

0क2 विशेष विखण्डनीय सामग्री

0क3 अन्य सामग्री

0ख निर्धारित उपकरण

0ग प्रौद्योगिकी

श्रेणी-1 जहरीले रासायनिक कारक और अन्य रसायन
 1क निषिद्ध रसायन
 1ख सिर्फ कैमिकल वेपन्स कन्वेन्शन के सदर्य राज्य को रसायन की अनुमति होगी ।
 1ग जो कैमिकल वेपन्स कन्वेन्शन के सदर्य नहीं हैं उन्हें भी रसायन की अनुमति होगी ।

श्रेणी-2 माइक्रो-आर्गनिज्म, टाक्सिसन्स
 2क बैक्टीरिया
 2ख फन्जाई
 2ग पैरासाइट्स
 2घ वाइरस
 2ड रिकेटसिएल्स.
 2च टाक्सिसन्स
 2छ प्लान्ट पैथोजन्स
 2ज जेनेटिकेली भॉडीफाइड आर्गेनिज्म

श्रेणी-3 सामग्रियाँ, सामग्री संसाधन उपकरण और संबद्ध प्रौद्योगिकी
 3क सामग्री
 3क1 विशेष सामग्री
 3क2 संरचनात्मक सामग्री
 3क3 राकेट प्रौपेलेन्ट्स और संघटक रसायन
 3क4 उच्च विस्फोटक
 3क5 स्टेल्थ सामग्री
 3ख सामग्री संसाधन और उत्पादन उपकरण, संबद्ध प्रौद्योगिकी और विशेष रूप से डिजाइन संघटक और उनके उपरकर (आरक्षित)
 3ग रसायन और जैव-सामग्री विनिर्माण और हैण्डलिंग उपकरण और सुविधाएँ ।

श्रेणी-4 श्रेणी के अन्तर्गत नियंत्रित न होने वाले परमाणु संबंधी अन्य उपकरण और प्रौद्योगिकी ।
 4क उपकरण, एसेम्बलीज, जाँच और उत्पादन उपकरण सहित संघटक

4ख	परमाणु विस्फोट यंत्र के विकास में प्रयुक्त होने वाले उपकरण, एसेम्बली, जाँच और माप के उपकरण सहित संघटक
4ग	प्रौद्योगिकी
श्रेणी-5	उत्पादन और जाँच उपकरण सहित ऐरोस्पेस सिस्टम, उपकरण, संबद्ध प्रौद्योगिकी और विशेष रूप से डिजाइन किए गए उनके संघटक और उपांग ।
5क	राकेट सिस्टम
5क1	सिस्टम्स
5क2	उत्पादन और जाँच उपकरण
5क3	प्रौद्योगिकी
5ख	मानव रहित एरियल वाहन
5ग	एविओनिक्स और नेवीगेशन सिस्टम
5घ	मानवयुक्त एयरक्राफ्ट, एरो-इन्जिन, संबद्ध उपकरण और संघटक ।
5ङ.	माइक्रो-लाइट एयरक्राफ्ट और पार्वड 'हेंग-ग्लाइडर्स'
श्रेणी-6	(आरक्षित)
श्रेणी-7	इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर्स और सूचना सुरक्षा सहित सूचना प्रौद्योगिकी ।
7क	इलेक्ट्रॉनिक्स
7ख	इलेक्ट्रॉनिक जाँच उपकरण
7ग	कम्प्यूटर्स
7घ	सूचना सुरक्षा सहित सूचना प्रौद्योगिकी
7ङ.	(आरक्षित)
श्रेणी-०	परमाणु सामग्री, परमाणु संबंधी अन्य सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी । टिप्पणी :- इन मदों का निर्यात आणविक ऊर्जा अधिनियम, 1962 और आणविक ऊर्जा विभाग द्वारा समय-समय से उसके तहत जारी अधिसूचना/आदेश तथा बनाए गए नियम के द्वारा विनियमित होता है । इस श्रेणी की मदों के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारी आणविक ऊर्जा विभाग है । विनिर्दिष्ट उपकरण अथवा/एक विनिर्दिष्ट सामग्री के निर्यात के लिए लाइसेंस हेतु संयुक्त सचिव, आणविक ऊर्जा विभाग, अणुशक्ति भवन, सी एस एम मार्ग, मुम्बई - 400001 को आवेदन लिख कर करना होगा ।

0क	विनिर्दिष्ट पदार्थ टिप्पणी :- श्रेणी 0क की कोई भी रेडियोएक्टिव सामग्री आणविक ऊर्जा अधिनियम, 1962 के तहत बनाए गए विकिरण संरक्षण नियम, 2004 के प्रावधान तथा आणविक ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा - 16 के प्रावधान भी अतिरिक्त रूप से लागू होंगे ।
0क1	स्रोत सामग्री
0क101	प्रकृति में पाए जाने वाले आइसोटोप्स के मिश्रण वाला यूरेनियम ।
0क102	आइसोटोप 235 में क्षयित यूरेनियम
0क103	थोरियम
0क104	धातु, एलॉय, रासायनिक यौगिक अथवा सांद्रण अथवा किस पदार्थ के रूप में कोई भी पूर्ववर्ती ।
0क105	कोई अन्य सामग्री जिसके एक अथवा अधिक पूर्ववर्ती हो ।
	विनिर्दिष्ट मात्रात्मक सीमाएँ :- जैसा कि नीचे दिया गया है और 12 माह की किसी समयावधि में :- क. यूरेनियम (प्रकृति में आइसोटोप्स के मिश्रण वाले) 100 किलोग्राम से अधिक ख. क्षयित यूरेनियम (प्रकृति में पाए जाने वाले आइसोटोप 235 से नीचे में क्षयित यूरेनियम) 1000 किलोग्राम से अधिक ग. 1000 किलोग्राम से अधिक थोरियम
0क2	विशेष विखण्डनीय सामग्री
0क201	प्लूटोनियम - 239
0क202	यूरेनियम - 233
0क203	आइसोटोप्स 235 अथवा 233 में संवर्धित यूरेनियम
0क204	नेपट्यूनिम
0क205	एक या अधिक पूर्ववर्ती वाली कोई सामग्री
0क206	समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित कोई अन्य विखण्डनीय सामग्री, लेकिन विशेष विखण्डनीय सामग्री शब्दावली में स्रोत सामग्री शामिल नहीं है। टिप्पणी:- विशेष विखण्डनीय सामग्री की कोई भी मात्रा विनिर्दिष्ट पदार्थ है ।

0क3	अन्य सामग्री
	'अन्य सामग्री' का अर्थ है रिएक्टरों के लिए गैर-परमाणु सामग्री, नीचे दी गई परमाणु संबंधी दोहरे-उपयोग की सामग्री तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित सामग्री ।
0क301	ज्यूटीरियम, गुरु जल (ज्यूटीरियम आक्साइड) और कोई भी अन्य ज्यूटीरियम यौगिक, जिसमें ज्यूटीरियम से हाइड्रोजन अणु का अनुपात 1:5000 से अधिक होगा, मात्रा में एक खेप में 5 किलोग्राम ज्यूटीरियम से अधिक अथवा 12 माह की किसी समयावधि में 25 किलोग्राम ज्यूटीरियम ।
0क302	परमाणु ग्रेड के ग्रेफाइट/कार्बन, जो 5 भाग प्रति मिलियन (पीपीएम) बोरोन समतुल्य से अधिक शुद्ध हो और 1.5 ग्राम/सीसी से अधिक घनत्व सहित मात्रा में 12 माह की किसी अवधि में 30 मीट्रिक टन से अधिक हो ।
0क303	धातु, इसके एलाय, यौगिक, उनके विनिर्माण, किसी भी पूर्ववर्ती के अपशिष्ट अथवा स्क्रैप के रूप में भार के आधार पर (अर्थात् 2000 पी पी एम से कम) जिरकोनियम के 500 भाग से 1 भाग से कम हैफनियम अंश सहित जिरकोनियम ।
0क304	बेरीलियम, इसके यौगिक, एलॉय और बेरिल सहित इसके खनिज/सांद्रण लेकिन निम्नलिखित को छोड़कर :- क. एक्स-रे मशीनों और गामा रे डिटेक्टर्स के लिए प्रयुक्त होने वाले बेरीलियम विन्डोज और ख. इमरेल्ड्स अथवा एक्वामेराइन्स के रूप में बेरिल
0क305	लिथियम-6 (6 एल आई) आइसोटोप, इसके प्राकृतिक आइसोटोपिक उपलब्धता से अधिक (अर्थात् 7.5% से अधिक) में संवर्धित लिथियम और लिथियम तत्व, एलॉय, यौगिक, मिश्रण जिसमें लिथियम है उनके विनिर्माण, किसी भी पूर्ववर्ती के अपशिष्ट अथवा स्क्रैप जैसे संवर्धित लिथियम वाले उत्पाद अथवा यंत्र ।
0क306	नियोबियम और टेन्टालम, उनकी धातुएँ, एलाय और कूलम्बाइट तथा टेन्टेलाइट सहित खनिज
0क307	टाइटेनियम एलॉय जिसमें निम्नलिखित दोनों गुण हों :- क. 293 के (200 से) पर 900 एम पी ए अथवा अधिक अल्टीमेट टेन्साइल स्ट्रेच में सक्षम; और ख. 75 मि.मी. से अधिक बाहरी व्यास वाले ट्यूब अथवा बेलनाकार

	<p>ठोस रूप में (फार्जिंग सहित) तकनीकी टिप्पणी :- "सक्षम" पद में टाइटेनियम एलाय हीट ट्रीटमेंट से पूर्व अथवा पश्चात् को शामिल किया गया है ।</p>
0क308	<p>ट्राईटियम, ट्राईटियम यौगिक अथवा मिश्रण जिसमें ट्राईटियम हो जहाँ ट्राईटियम से हाइड्रोजन अणु का अनुपात 1000 में 1 भाग से अधिक हो, आर्गेनिक लेबल्ड यौगिकों, गैस फिल्ड लाइट स्रोतों और रेडियोट्रेसर अध्ययन हेतु ट्रिटिएटेड जल के रूप में ऐसी मात्रा में व ऐसे उद्देश्यों के लिए प्रयोग करने को छोड़कर।</p>
0क309	<p>हैफनियम : (सी ए एस 7440-58-6) हैफनियम धातु, 60% से अधिक भार के हैफनियम वाले एलॉय, 60% से अधिक भार के हैफनियम वाले हैफनियम यौगिक, उनके विनिर्माण और किसी भी पूर्ववर्ती के अपशिष्ट अथवा अवशिष्ट ।</p>
0क310	<p>रेडियम - 226 : रेडियम - 226 (226 आर ए), रेडियम-226 एलॉय, रेडियम-226 यौगिक, रेडियम-226 वाले मिश्रण, उनके विनिर्माण और किसी भी पूर्ववर्ती उत्पाद अथवा यंत्र और मेडिकल अप्लीकेटर्स और उत्पाद अथवा यंत्र जिसमें किसी रूप में आर ए-226 0.37 जी बी क्यू (10 एम सी आई) से कम के उत्पाद अथवा यंत्र को छोड़कर ।</p>
0क311	<p>बोरोन (सी ए एस 7740-42-8) अपनी प्राकृतिक उपलब्धता से अधिक बोरोन-10 (10बी) आइसोटोप में संवर्धित बोरोन निम्नानुसार है : बोरोन तत्व, यौगिक, बोरोन वाले मिश्रण उनके विनिर्माण, किसी भी पूर्ववर्ती के अपशिष्ट अथवा अवशिष्ट ।</p>
0क312	<p>हीलियम - 3 हीलियम - 3 (3एच इ) हीलियम - 3 वाले मिश्रण वे किसी भी पूर्ववर्ती वाले उत्पाद अथवा यंत्र ।</p> <p>टिप्पणी : 1 ग्राम से कम हीलियम - 3 वाले उत्पाद अथवा यंत्र को छोड़ दिया गया है ।</p>

0क313

अल्फा - ईमीटिंग रेडियोन्यूक्लाईड्स :

10 दिन अथवा अधिक लेकिन 200 वर्ष से कम हाल-लाइफ अल्फा वाले अल्फा-ईमीटिंग रेडियोन्यूक्लाईड्स निम्नलिखित रूपों में हैं :

क. तत्त्व

ख. 37 जीबीक्यू प्रति कि.ग्रा. अथवा अधिक से कुल अल्फा एक्टिविटी वाले यौगिक

ग. 37 जीबीक्यू प्रति कि.ग्रा. अथवा अधिक से कुल अल्फा एक्टिविटी वाले मिश्रण

घ. किसी भी पूर्ववर्ती के उत्पाद अथवा यंत्र

इस मद से नियंत्रित अल्फा इमिटर्स में निम्नलिखित शामिल हैं :-

एक्टीनियम - 225	एक्टीनियम - 227	अमेरिसियम - 242एम
कैलीफोर्नियम - 248	कैलीफोर्नियम - 250	कैलीफोर्नियम - 252
कैलीफोर्नियम - 253	कैलीफोर्नियम - 254	क्यूरियम - 240
क्यूरियम - 241	क्यूरियम - 242	क्यूरियम - 243
क्यूरियम - 244	आईस्टीनियम - 252	आईस्टीनियम - 253
आईस्टीनियम - 254	आईस्टीनियम - 255	फर्मियम - 257
गेडोलिनियम - 148	मेन्जीलिवियम - 258	नेप्ट्यूनियम - 235
प्लूटोनियम - 236	प्लूटोनियम - 237	प्लूटोनियम - 238
प्लूटोनियम - 241	पोलोनियम - 209	पोलोनियम - 210
पोलोनियम - 208	रेडियम - 223	थोरियम - 228
थोरियम - 227	यूरेनियम - 230	यूरेनियम - 232

0ख	निर्धारित उपकरण
0ख001	<p>न्यूकिलियर रिएक्टर; सम्बद्ध उपकरण, संघटक और सिस्टम जो विशेष रूप से ऐसे रिक्टरों में प्रयोग में लाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया हो, तैयार अथवा प्रयुक्त या अनुकूलित अथवा इन्टेंडेड हो ।</p> <p>क. पूरे न्यूकिलियर रिएक्टर</p> <p>ख. न्यूकिलियर रिएक्टर वेसल</p> <p>ग. न्यूकिलियर रिएक्टर फ्यूल चार्जिंग और डिस्चार्जिंग मशीनें</p> <p>घ. न्यूकिलियर रिएक्टर कन्ट्रोल राड़िस और उपकरण</p> <p>ड. न्यूकिलियर रिएक्टर प्रेसर ट्यूब्स</p> <p>च. 1:500 अथवा कम के हैफनियम जर्कोनियम अनुपात वाले जर्कोनियम ट्यूब्स और ट्यूब्स की असेम्बलीज</p> <p>छ. प्राइमरी कूलेण्ट पम्पस</p> <p>ज. न्यूकिलियर रिएक्टर इन्टर्नल्स</p> <p>झ. न्यूकिलियर रिएक्टर के प्राइमरी कूलेण्ट सर्किट में प्रयोग हेतु हीट एक्सचेंजर्स (स्टीम जनरेटर्स)</p> <p>ज. न्यूकिलियर रिएक्टर के कोर में न्यूट्रान फ्लाक्स स्तर का पता लगाने के लिए न्यूट्रान जाँच और मापक यंत्र ।</p>
0ख002	<p>संसाधन, उत्पादन, सांद्रण, विनिर्दिष्ट पदार्थ (जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, ड्यूटीरियम, गुरु जल, ट्रीटियम, लिथियम) के परिवर्तन अथवा रिक्वरी के लिए प्लांट; संबद्ध उपकरण, संघटक और विशेष रूप से डिजाइन की गई, तैयार अथवा अनुकूलित अथवा प्रयुक्तया प्रयोग किए जाने की व्यवस्था ऐसे प्लांटों में निम्नलिखित शामिल हैं किन्तु इसी तक सीमित नहीं है :-</p> <p>क. ड्यूटीरियम, गुरु जल के उत्पादन अथवा सांद्रण के लिए प्लांट -</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जल - हाइड्रोजन सल्फाइड इक्सचेंज टार्वर्स 2. हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सर्कुलेशन के लिए ब्लोवर्स और कंप्रेसर्स 3. 1.5 मी. से 2.5 मी. व्यास सहित 35 मी. या अधिक ऊँचाई के अमोनिया - हाइड्रोजन एक्सचेंज टार्वर्स । 4. टॉवर इन्टर्नल्स और स्टेज पंप्स । 5. 3 एमपीए अथवा अधिक के आपरेटिंग प्रेसर्स सहित अमोनिया क्रेकर्स 6. 'आनलाइन' हाइड्रोजन/ड्यूटीरियम रेशियो एनालिसिस में

	<p>सक्षम इन्फ्रारेड एब्जार्बेशन एनालाइजर ।</p> <p>7. संवर्धित ड्यूटीरियम गैस से गुरु जल में परिवर्तन के लिए कैटेलिटिक बर्नर्स</p> <p>8. कंप्लीट हैवी वाटर अपग्रेड सिस्टम्स अथवा उनके कॉलम</p> <p>ख. यूरेनियम के बदलाव हेतु प्लांट</p> <p>ग. प्लूटोनियम के बदलाव हेतु प्लांट</p> <p>घ. ट्रिटियम सुविधाएँ अथवा प्लांट और उनके उपकरण</p> <p>ड. लिथियम आइसोटोप सेपरेशन सुविधाएँ अथवा प्लांट्स् और उनके उपकरण</p>
0ख003	<p>इर्डिएटेड न्यूकिलियर फ्यूल और उपकरण के पुनर्साधन के लिए प्लांट और उपकरण, संघटक और ऐसे प्लांट के लिए विशेष रूप से डिजाइन, तैयार अथवा अनुकूलित अथवा प्रयुक्त अथवा प्रयोग किए जाने की व्यवस्था में निम्नलिखित शामिल हैं किन्तु इसी तक सीमित नहीं है -</p> <p>क. रिमोट आपरेशन हेतु डिजाइन की गई इर्डिएटेड फ्यूल एलिमेंट चॉपिंग मशीनें</p> <p>ख. विदस्टेपिंग हॉट में सक्षम डिजाल्वर्स और इर्डिएटेड न्यूकिलियर फ्यूल के डिजाल्यूशन हेतु अत्यंत कारोजिव लिकिवड और जो रिमोटली लोड की जा सके और मेनटेन की जा सकें ।</p> <p>ग. नाइट्रिक एसिड के कोरोजिव प्रभाव के साल्वेट एक्स्ट्रेक्शन उपकरण रेजिस्टेट और साल्वेट एक्स्ट्रेक्शन उपकरण रेजिस्टेट और साल्वेट इक्स्ट्रेक्टर्स ।</p> <p>घ. नाइट्रिक एसिड के कोरोजिव प्रभाव के केमिकल होल्डिंग अथवा स्टोरेज वेसेल रेजिस्टेट</p> <p>ड. एसेम्बलीज सहित औद्योगिक उपकरण और संघटक निम्नानुसार है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. हाई डेन्सिटी(लीड ग्लास अथवा अन्य)रेडिएशन शील्डिंग विन्डोज 2. रेडिएशन हार्डेन्ड टी.वी. कैमरा अथवा उनके लेन्सेज 3. उच्च विस्फोटक हैण्डल करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए 'रोबोट' अथवा 'इन्ड इफेक्टर्स' ; और उनके कंट्रोल यूनिट्स । 4. रिमोट मैनीपुलेटर्स जिनका प्रयोग रेडियो केमिकल सेपरेशन आपरेशन अथवा हाट सेल्स में रिमोट एक्शन प्रदान करने के लिए हो सकता है ।

0ख004	<p>प्लांट के ट्रीटमेंट, हैण्डलिंग, स्टोरेज और न्यूक्लियर रिएक्टर अथवा खोत सामग्री अथवा विशेष विखण्डनीय सामग्री के संसाधन के प्लांट अथवा न्यूक्लियर पुनर्साधन प्लांट से रेडियोएक्टिव अपशिष्ट का परिवहन; इरेंडिएटेड न्यूक्लियर फ्यूल; विशेष विखण्डनीय सामग्री और विशेष रूप से डिजाइन, तैयार, अनुकूलित अथवा उनके लिए प्रयोग किए जाने हेतु उपकरण ।</p>
0ख 005	<p>सभी सिस्टम, संबद्ध उपकरण, सेपरेशन हेतु संघटक अथवा यूरेनियम, प्लूटोनियम, लिथियम अथवा बोरोन के आइसोटोप्स के इनरिचमेंट, विशेष रूप से डिजाइन, तैयार, अनुकूलित, प्रयुक्त अथवा उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़कर निम्नानुरा होगी :-</p>
क.	<p>गैस सेन्ट्रीफ्यूग और एसेम्बली तथा गैस सेन्ट्रीफ्यूग प्रयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन और तैयार किए संघटक ।</p>
ख.	<p>विशेष रूप से डिजाइन अथवा तैयार एकजलरी ।</p>
ग.	<p>उपकरण और गैस सेन्ट्रीफ्यूग इनरिचमेंट प्लांट के संघटक</p>
घ.	<p>विशेष रूप से डिजाइन अथवा तैयार एसेम्बली और सियस डिफ्यूजन इनरिचमेंट में प्रयोग हेतु संघटक</p>
घ.	<p>विशेष रूप से डिजाइन अथवा तैयार एकजलरी सिस्टम, उपकरण और गैसियस डिफ्यूजन इनरिचमेंट के प्रयोग के लिए संघटक ।</p>
ड.	<p>विशेष रूप से डिजाइन अथवा तैयार सिस्टम्स, उपकरण और एरोडायनमिक इनरिचमेंट प्लांट में प्रयोग हेतु संघटक में प्रयोग हेतु उपकरण ।</p>
च.	<p>विशेष रूप से डिजाइन अथवा तैयार सिस्टम्स, उपकरण और केमिकल एक्सचेंज अथवा आयन एक्सचेंज इनरिचमेंट प्लांट ।</p>
छ.	<p>विशेष रूप से डिजाइन अथवा तैयार सिस्टम्स, उपकरण और लेजर बेर्स्ड इनरिचमेंट प्लांट में प्रयोग हेतु उपकरण ।</p>
ज.	<p>विशेष रूप से डिजाइन अथवा तैयार सिस्टम्स, उपकरण और प्लाज्मा सेपरेशन इनरिचमेंट प्लांट में प्रयोग हेतु उपकरण ।</p>
झ.	<p>विशेष रूप से डिजाइन अथवा तैयार सिस्टम्स, उपकरण और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनरिचमेंट प्लांट में प्रयोग हेतु उपकरण ।</p>

0ख006	<p>न्यूकिलियर रिएक्टर फ्यूल एलिमेंट के फैब्रीकेशन के लिए प्लांट और उनके लिए विशेष सम से डिजाइन अथवा तैयार उपकरण में निम्नलिखित शामिल हैं लेकिन इसी तक सीमित नहीं है :-</p> <p>(क) पूर्णतः स्वचालित पैलेट निरीक्षण स्टेशन जोकि ईंधन पैलेट्स के सतही दोषों और अंतिम आयामों के निरीक्षण के लिए विशेषतः डिजाईन किए गए हों,</p> <p>(ख) स्वचालित वैल्डिंग मशीनें जोकि वैल्डिंग एण्ड कैप्स ऑनटू फ्यूल पिनों (या छड़ों) के लिए विशेषतः डिजाईन किए गए हों</p> <p>(ग) स्वचालित परीक्षण और निरीक्षण स्टेशन जोकि पूरे हो चुके ईंधन पिनों (या छड़ों) की अनन्यता के परीक्षण के लिए विशेषतः डिजाईन किए गए और बनाए गए हों ।</p> <p>मद ग में विशेषतः यह संयंत्र सम्मिलित हैं : 1. पिन (या छड़ों) एण्ड कैप वैल्डज़ का एक्स-रे निरीक्षण 2. पाश्चुराईज्ड पिनों (या छड़ों) से हीलियम लीक डिटैक्टशन और 3. आंतरिक ईंधन पैलेट्स के सही लोडिंग के लिए पिनों (या छड़ों) के परीक्षण के लिए गामा-रे-स्कैनिंग ।</p>
0ख007	100 क्यूरिज (3.7 x 10 12 बैक्यूरेल) से अधिक मात्रा वाले रेडियो आइसोटोप्स के आवागमन, भंडारण, रख-रखाव और उत्पादन के लिए प्लांट या प्रणालियों
0ख008	न्यूट्रॉन जनरेटर्स जिसमें फिसाईल सामग्रियों के उत्पादन के लिए सभी प्रकार के न्यूट्रॉन रिएक्टिंग एसेम्बलीज़ और फ्यूज़न एसेम्बलीज़ शामिल हैं ।
0ग	<p>टैक्नोलॉजी</p> <p>0क और 0ख में विनिर्दिष्ट निर्धारित वस्तुओं या संयंत्रों के प्रयोग उत्पादन या विकास के लिए टैक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर</p>

श्रेणी-1	टॉक्सिक कैमिकल एजेंट्स और अन्य कैमिकल
1 क	निम्नलिखित रासायनों का निर्यात निषिद्ध है (यह रासायनिक हथियार अभिसमय (सी डब्ल्यू सी) की अनुसूची-1 के तहत है)

टिप्पणी : जहाँ डी-एल्कलाईलेटेड कैमिकल्ज के वर्गों तथा पैरेथिसिज में एल्कलाईल वर्गों की सूची का प्रश्न है, सभी संभव मिश्रणों द्वारा सभी संभव रसायन और पैरेथिसिज की सूची में शामिल सभी एल्काई वर्ग निषिद्ध हैं जब तक कि कोई उनमें से विशेष रूप से छूट प्राप्त न हो ।

(1) ओ-एल्की (\leq C10, जिसमें साईक्लोएल्काईल शामिल है) एल्काइन 1 (Me, Et, n-Pr or i-Pr) फास्फोनोफ्लूराइडेट सोमन : ओ-पीनाकोलीन मिथाईल फास्फोनोफ्लूराइडेट

उदाहरणतया:- सारीन: ओ-आइसोप्रोपाइल 1 मिथाईल फास्फोनो-फ्लूओरीडेट
सोमन: इ-पिनाकोलिल मिथाईल फास्फोनोफ्लूओरीडेट

(2) ओ-एल्काईल, (\leq सी 10 साइक्लोएल्काईल समेत) एन-डाइएल्काइल 1 (Me, Et, n-Pr या i-Pr) फास्फोरएमीडोसाईनीडेट्स

उदाहरणतया: टेब्यून: ओ-इथाईल, एन, एन-डाई-मिथाईल फॉस्फोरएमीडोसाईनीडेट

(3) ओ-एल्काइल (एच या \leq C 10 साइक्लोएल्काईल समेत) एस-2-डाईएल्काइल (Me, Et, n-Pr या i-Pr)

एमीनोइथाईल एल्काइल (Me, Et, n-Pr या i-Pr)

फास्फोनोथायोलेट्स एवं साथ लगते एल्काइलेटिड या प्रोटोनेटीड साल्ट्स

उदाहरणतया: वी एक्स: ओ-इथाईल एस-2 डाईआइसोप्रोपाईल अमीनोइथाईल मिथाईल फॉस्फोनोथायोलेट

(4) सल्फर मस्टर्ड्स: 2-क्लोरो एथिल क्लोरो मेथलसल्फाईड

मस्टर्ड गैस: बिस (2-क्लोरोइथाईल) सल्फाइड

बिस (2-क्लोरोइथाईलथायो) मिथेन

सैस्क्यूमस्टर्ड: 1, 2-बीस (2-क्लोरोइथाईलथीयो) इथेन

1,3- बिस (2-क्लोरोइथाईल थीयो) -n- प्रोपेन

1,4- बिस (2-क्लोरोइथाईल थीयो) -n- ब्यूटेन

1,5- बिस (2-क्लोरोइथाईल थीयो) -n- पेटेन

बिस (2-क्लोरोइथाईल थीयो) इथर

ओ-मस्टर्ड : बिस (2-क्लोरो इथाईल थायो मिथाईल) इथर

(5) लेवीसाईट्स

लेवीसाईट 1: 2-क्लोरोविनाईल डाईक्लोरो अरसाईन

लेवीसाईट 2: बीस (2-क्लोरोविनाईल) क्लोरोअरसाईन

लेवीसाईट 3: ट्रीस (2-क्लोरो विनाईल) अरसाईन

(6) नाइट्रोजन मस्टर्ड्स

एच एन 1 : बीस (2-क्लोरोइथाईल) इथाईल-अमाईन

एच एन 2 : बीस (2-क्लोरोइथाईल) क्लोरोअरसाईन

एच एन 3 : ट्रीस (2-क्लोरो इथाईल) अमाईन

(7) सैक्सीटॉक्सिन

(8) राईसीन

(9) एल्काईल (Me, Et, n-Pr or I-Pr)

फॉस्फोनीलिडीफ्लूराईड्स

उदाहरणतया: डी एफ : मिथाईल फॉस्फोनोलिडीफ्लूसाइड

(10) ओ-एल्कोइल (एच या $\leq C 10$ साइक्लो एल्काइल समेत)

ओ-2 डाईएल्काइल (Me, Et, n-Pr or i-Pr)

अमीनो इथाईल एल्काईल (Me, Et, n-Pr or i-Pr)

फॉस्फोनाईट्स एवं साथ लगते एल्काइलेटिड या प्रोटोनेटिडसाल्ट्स

उदाहरणतया: QL -ओ-इथाईल ओ-2-डाईआइसोप्रोपाइल अमीनो इथाईल मिथाईल फॉस्फोनाईट

(11) क्लोरोसारीन ओ-आईसोप्रोपाईल मिथाईल फॉस्फोना क्लोराइडेट

(12) क्लोरोसोमन ओ-पीनाकोलील मिथाईल फॉस्फोनो-क्लोराईडेट

1 ख

निम्नलिखित 1बी में सूचीबद्ध रसायनों का निर्यात केवल स्टेट्स पार्टी को रसायनिक हथियार अभिसमय को अनुमत है ।

(यह रसायनिक हथियार अधिसमय की अनुसूची 2 के संगत है)

निर्यातक के लिए टिप्पणी:

(क) स्टेट्स पार्टीयों की सूची विदेश मंत्रालय के निशस्त्रीकरण और अन्तर्राष्ट्रीय सुरक्षा मामला प्रभाग (कमरा नं० 40जी, साऊथ ब्लॉक, नई दिल्ली) अथवा रसायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन कार्यालय की वेबसाइट www.opcw.org. से प्राप्त की जा सकती है,

(ख) इस श्रेणी के अंतर्गत रसायनों के निर्यात के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए एक सामान्य अनुमति वैध होगी । यह अनुमति इस शर्त के अधीन होगी कि प्रत्येक निर्यात खेप के निर्यातक को निर्यात के 30 दिन के भीतर राष्ट्रीय प्राधिकरण, रसायनिक हथियार अभिसमय, मंत्रीमंडलीय सचिवालय, विदेश मंत्रालय (डी एण्ड आई एस ए), रसायन और पैट्रो-रसायन विभाग तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय को अधिसूचित करना होगा तथा सुपुर्दगी के 30 दिन के भीतर डैर्स्टीनेशन स्टैट पार्टी में बिल ऑफ एन्ट्री की एक प्रति विदेश व्यापार महानिदेशालय में जमा करनी होगी ।

टिप्पणी:- जहाँ डी-एल्कलाईलेटेड कैमिकल्ज के वर्गों तथा पैरेथिसिज में एल्कलाईल वर्गों की सूची का प्रश्न है, सभी संभव मिश्रणों द्वारा सभी संभव रसायन और पैरेथिसिज की सूची में शामिल सभी एल्काईल वर्ग निषिद्ध हैं जब तक कि कोई विशेष रूप से छूट प्राप्त न हो ।

1. अमीटोन ओ, ओ-डाईइथाईल एस-[2-डाईइथाईल-अमीनो(इथाईल)] फॉस्फोरोथायोलेट एवं संलग्नित अल्काईलेटिड या प्रोटोनेटीड साल्ट्स
2. पी.एफ.आई.बी. : 1,1,3,3,3 पेंटाफ्लोरो-2-(द्राईफ्लूरोमिथाईल) 1-प्रोपीन
3. बी. जेड : 3-क्वीन्यूक्लीडीनाईल बैंजीलेट
4. अनुसूची 1 में शामिल रसायनों को छोड़कर जिसमें एक फॉस्फोरस एट्म शामिल होता है एवं जिसमें एक बांडिड मिथाईल, इथाईल या प्रोपाईल (सामान्य या आईसो) समूह जुड़ा होता है परन्तु आगे कोई कार्बन एट्मस नहीं होते - उदाहरणतया:- मिथाईलफॉस्फोनाईल डाईक्लोरोइड डाईमिथाईल मिथाईल फोस्फोनेट

छूटः—फोनोफोसः ओ-इथाईल एस-फिनाईल
इथाईलफोस्फोनोथायोलो थीयोनेट

5. एन, एन-डाईएल्काईल (Me, Et, n-Pr or i-Pr) फॉस्फोरअमीडिक डाईहेलाइड्स
6. डाईएल्काईल (Me, Et, n-Pr or i-Pr) एन-डाईएल्काईल (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-फॉस्फोरअमीडेट्स
7. आर्सेनिक ट्राईक्लोराइड
8. 2,2-डाईफिनाईल-2 हाइड्रोक्सीएसेटिक एसिड
9. क्यून्यूकलीडाईन डाईन-3-ओल
10. एन, एच-डाईएल्काईल (Me, Et, n-Pr or i-Pr) अमीनोइथाईल-2-क्लोराइड्स एवं संगत प्रोटोनेटीड साल्ट्स
11. एन, एन-डाईएलकाईल (Me, Et, n-Pr or i-Pr) अमीनोइथेन-2-ओल्स एवं साथ आने वाले प्रोटोनेटीड साल्ट्स
छूटे : एन, एन-डाईमिथाईल अमीनोइथेनॉल एवं संबंधित प्रोटोनेटीड साल्ट्स.
एन, एन-डाईइथाईल अमीनोइथेनॉल एवं संबंधित प्रोटोनेटीड साल्ट्स
12. एन, एन-डाईएल्काईल (Me, Et, n-Pr or i-Pr) अमीनोइथेन-2-थाइओल्स एवं संबंधित प्रोटोनेटीड साल्ट्स
13. थायोडाइग्लाईकोल : बिस (2-डाइड्रोक्सीइथाईल) सलफाइड
14. पीनाकोलिल एल्कोहल : 3, 3-डाईमिथाईल ब्यूटैन -2- ओल

वाणिज्यिक रूप से महत्पूर्ण सी डब्ल्यू सी की अनुसूची-2 के रसायनों की सूची अधोलिखित है :-

क्रम सं०	रसायन का नाम	अनुसूची में प्रविष्टि	सीएस (रसायन संक्षिप्ति सेवा संख्या)	आई टी सी (एचएस) कोड
1	2-क्लोरो एन, एन-डाई आइसो-प्रोपाईल ईथाइल अमाइन	2ख 10	4261-68-1	29211911
2	डाई ईथाइल अमीनो इथेन ईथोइल	2ख 12	100-38-9	29221910
3	ओ, ओ, डाईमिथाइल मिथाइल फॉस्फोनेट	2ख 04	756-79-6	29209045
4	2-हाइड्रोक्सी एन, एन- डाइआइसो-प्रोपाईल ईथाइल एमाइन	2ख 11	96-80-0	29221111
5	एन, एन-डाइइथाइल अमीनो इथाइल क्लोरोइड हाइड्रो क्लोरोइड	2ख 10	869-24-9	29221112
6	डाई ईथाइल अमीनो इथेन ईथियोल हाइड्रोक्लोरोइड	2ख 12	1942-52-5	29221113
7	डाई मिथाइल अमीनो इथाइल क्लोरोइड हाइडो क्लोरोइड	2ख 10	4584-46-7	29221114
8	डाई-मिथाइल अमीनो इथेन-इथियोल	2ख 12	108-02-1	29221115
9	डाई-मिथाइल अमीनो इथेन-इथियोल हाइड्रो क्लोरोइड	2ख 12	1342-44-9	29221116
10	फास्फोरोथोइक एसिड, एस [2-(डाईइथाइलअमीनो) ईथाइल] ओ,ओ-डाई ईथाइल इस्टर	2क 101	78-53-5	29201910
11	1-प्रोपीन, 1, 1, 3, 3, 3-पेटा फ्लूरो-2 (ट्राईफ्लोरो मिथाइल) (पी. एफ. आई.बी.)	2क 02	382-21-8	29033911

12	बैंजीन एसीटिक एसिड, अल्फाहाइड्रोआक्सी- अल्फाफनाईल, 1-एजाबाई- साइक्लो [2,2,2] ऑक्ट-3 - वाईल ईस्टर	2क 03	6581-06-2	29392050
13	फास्फोनिक एसिड, मिथाईल- कम्पाउंड विद (अमीनो ईमीनो मिथाईल) यूरिया (1:1)	2ख 04	84402-58-4	29209047
14	1-प्रोपेन अमीनियम एन,एन,एन- द्राईमिथाईल-3-[1-ओक्सो-9- आक्टोडीसीनाईल) अमीनो] (जेड) मिथाईल मिथाईलफॉर्स्फोनेट	2ख 04	70055-71-9	29209048
15	फास्फोनिक एसिड, [मिथाईल बीस (5-ईथाईल-2-मिथाईल2-ऑक्सीडो- 1,3,2-डाई-ओक्सफॉर्स्फोरिन-5- वाईल) मिथाईल] ईस्टर	2ख 04	42595-45-9	29209051
16	फास्फोनिक एसिड, [मिथाईल -(5- ईथाईल-2-मिथाईल2-ऑक्सीडो- 1,3,2-डाईआक्सो फास्फोरिन-5- वाईल) मिथाईल] ईस्टर	2ख 04	41203-81-0	29209052
17	फॉस्फोनिक एसिड, प्रोपाइल-डाई- मिथाईल ईस्टर	2ख 04	18755-43-6	29209053
18	फॉस्फोनेस एसिड, मिथाईल-डाई ईथाईल ईस्टर	2ख 04	15715-41-0	29209054
19	फॉस्फोनिक एसिड, ईथाईल	2ख 04	6779-09-5	29209055
20	फॉस्फोनिक एसिड, प्रोपाइल	2ख 04	4672-38-2	29209056
21	फॉस्फोनिक एसिड, मिथाईल	2ख 04	4206-94-4	29209057

22	फॉस्फोनोक्लोरिडीक एसिड, मिथाईल-मिथाईल ईस्टर	2ख 04	1066-52-0	29209058
23	फॉस्फोनोइथिओइक डाई क्लोराइड ईथाईल	2ख 04	993-43-1	29209061
24	फॉस्फोनोईक एसिड मिथाईल	2ख 04	993-13-5	29209062
25	फॉस्फोनोईक एसिड, मिथाईल-डाईमिथाईल ईस्टर	2ख 04	756-79-6	29209063
26	फॉस्फोनोईक डाईक्लोराइड मिथाईल	2ख 04	676-97-1	29209064
27	फास्फोनोस डाईक्लोराइड, मिथाईल	2ख 04	676-83-5	29209065
28	फॉस्फोनोईक एसिड, ईथाईल डाईथाईल ईस्टर	2ख 04	78-38-6	29209066
29	आरसीनस ट्राईक्लोराइड	2ख 07	7784-3-1	28121060
30	बैंजीन एसीटिक एसिड, एल्फा-हाइड्रोक्सी एल्फा-फीनाईल	2ख 08	76-93-7	29181910
31	1-अजाबाईसाइक्लो (2.2.2) आक्टेन-3-ओ एल	2ख 09	1619-34-7	29333930
32	इथेनअमाईन, 2-क्लोरा-एन, एन-डाईमिथाईल	2ख 10	107-99-3	29211914
33	इथेनॉल, 2-[बिस (1-मिथाईल ईथाईल) अमीनो]-	2ख 11	96-80-0	29221920
34	इथेनइथोईल, 2-(डाईइथाईल अमीनो)	2ख 12	100-38-9	29221930
35	इथेनॉल, 2 2' थायोबीस	2ख 13	111-48-8	29309091
36	2-ब्यूटेनॉल, 3,3-डाईमिथाईल	2ख 14	464-07-3	29051910

1 ग

निम्न विशेषोल्लेखित रसायनों का निर्यात सी.डब्ल्यू.सी. की राज्य पार्टीयों को बगैर निर्यात लाइसेंस के किया जा सकता है बशर्ते निर्यातक निर्यात के तीस (30) दिनों के अंदर नेशनल अथारिटी, कैमिकल वीपंस कन्वेशन, कैबिनेट सचिवालय; विदेश मंत्रालय (डी एवं आई एस ए); रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग एवं डी.जी.एफ.टी. को निर्धारित प्रपत्र (आयात-निर्यात फार्म) पर अंतिम प्रयोग प्रमाणपत्र के साथ सूचित करेगा एवं स्टेट पार्टीज में प्रविष्टि बिल की एक प्रति डी.जी.एफ.टी. को सुपुर्दगी के 30 दिनों के अंदर देगा। नीचे विशेषोल्लेखित रसायनों का उन देशों को जो सी.डब्ल्यू.सी. की राज्य पार्टीयाँ नहीं हैं निर्यात प्रतिवंधित रहेगा और सिर्फ निर्यात लाइसेंस के मद्दे अनुमति दी जाएगी और उस स्थिति में भी निर्यातक डी.जी.एफ.टी. को निर्यात के 30 दिनों के अंदर लक्षित राष्ट्र में प्रविष्टि बिल की प्रति उपलब्ध कराएगा।

क्रम सं०	रसायन का नाम	अनुसूची में प्रविष्टि	सीएएस (रसायन संक्षिप्ती सेवा संख्या)	आई टी सी (एचएस) कोड
1	फॉसजीन: (कार्बोनाईल डाईक्लोराइड)	3क 01	75-44-5	28121010
2	सायनोजेन क्लोराइड [(सी एन) सी 1]	3क 02	506-77-4	28530091
3	हाइड्रो सानिक एसिड	3क 03	74-90-8	28111910
4	क्लोरोपिक्रिन: टाइट्रोक्लोरो नाइट्रो मिथेन	3क 04	76-06-2	29049080
5	फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड	3ख 05	10025-87-3	28121030
6	फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड	3ख 06	7719-12-2	28121021
7	फॉस्फोरस पेटाक्लोराइड	3ख 07	10026-13-8	28121022
8	ट्राईमिथाईल फास्फॉर्झेट	3ख 08	121-45-9	29209041
9	ट्राईइथाईल फास्फॉर्झेट	3क 09	122-52-1	29209042
10	डाईमिथाईल फास्फॉर्झेट	3ख 10	868-85-9	29209043
11	डाइइथाईल फास्फॉर्झेट	3ख 11	762-04-9	29209044
12	सल्फर मोनोक्लोराइड	3ख 12	10025-67-9	28121042

13	सल्फर डाईक्लोराईड	3ख 13	10545-99-0	28121043
14	थीयोनाईल क्लोराईड	3ख 14	07719-09-7	28121047
15	इथाईलडाईइथेनोलअमाइन	3ख 15	139-87-7	29221211
16	मिथाईलडाईइथेनोलअमाइन	3ख 16	105-59-9	29221212
17	ट्राईइथेनोलअमाइन	3ख 17	102-71-6	29221300

श्रेणी 2	सूक्ष्म- जीव संरचना, जीव-विष
2क	जीवाणु, चाहे प्राकृतिक, संवर्धित या परिवर्धित, चाहे आइसोलेटेड लाईफ कल्वर के रूप में हों या फिर लीविंग मैटीरियल सहित ऐसे पदार्थ के रूप में जोकि जान-बूझकर निम्नलिखित के लिए ऐसे कल्वर से अप्रभावित अथवा दूषित किए गए हों :
2क 001	बैसिलस एंथ्रासिस
2क 002	बारडीटेला ब्रॉन कॉसपिटेका
2क 003	बूसीला अबोरटस
2क 004	बूसीला मेलीटेनसिस
2क 005	बूसीला सूईस
2क 006	कलामीडिया पिस्टकी
2क 007	क्लोसट्रीडियम बोटूलिनम
2क 008	क्लोसट्रीडियम परफ्रिंगस
2क 009	कोरनीबैक्टीरियम डिपथरी
2क 0010	फ्रांससीला टूलारेनसीस
2क 0011	क्ले बैसीला न्यूमोनी
2क 0012	लीगोनला न्यूमफोलिया
2क 0013	लेप्टोसिपरा इंटरोगंस-सभी सीरो प्रकार भारत में पाए गए हैं
2क 0014	माइको बैक्टीरियम बोविस
2क 0015	माइको बैक्टीरियम ट्यूबरकलोसिस
2क 0016	माइको प्लाज्मा माइकोडिस - वार माइकोडिस
2क 0017	माइको प्लाज्मा माइकोडिस - वार कैपरी
2क 0018	नैसीरिया मैनीनगिटिडिस

2क 0019	पैस्टीयूरेला मल्टीकोडा टाइप बी
2क 0020	श्यूडोमोनस मैली
2क 0021	श्यूडोमोनस श्यूडो मैली
2क 0022	सालमोनेला पारटीफी
2क 0023	शिगेला डायीसेनटेरी
2क 0024	स्टेफलोकोकस अयूरस
2क 0025	स्ट्रेप टोकोकस न्यूमोनी
2क 0026	वाइब्रो कोलेरी एल्टर
2क 0027	वाइब्रीओ कोलेरी 0139
2क 0028	यारसीनिया पेसटीस
2ख	फंजाई, चाहे प्राकृतिक, संवर्धित या परिवर्धित, चाहे आइसोलेटेड लाईफ कल्वर के रूप में हों या फिर लीविंग मैटीरियल सहित ऐसे पदार्थ के रूप में जोकि जान-बूझकर निम्नलिखित के लिए ऐसे कल्वर से अप्रभावित अथवा दूषित किए गए हों :
2ख 001	ब्लास्टोमीसस डरमाटिटिडिस
2ख 002	कोशिशडीयोडस इमीटिस
2ख 003	हिस्टोप्लाज्मा कैप्यूलाटम
2ख 004	नोकार्डिया एसट्रोडिस
2ख 005	पैराकोशिडीयोडिस ब्राजीलीनीसिस
2ग	पैरासाइट, चाहे प्राकृतिक, संवर्धित या परिवर्धित, चाहे आइसोलेटेड लाईफ कल्वर के रूप में हों या फिर लीविंग मैटीरियल सहित ऐसे पदार्थ के रूप में जोकि जान- बूझकर निम्नलिखित के लिए ऐसे कल्वर से अप्रभावित अथवा दूषित किए गए हों:
2ग 001	एनटामोइबा हिस्टोलिटिका
2ग 002	बेबीसिया माइक्रोटी
2ग 003	बेबीसिया डाइवर्जस
2ग 004	बलोसटीडियम कोली
2ग 005	क्रिप्टोस्पोरडियम स्पप
2ग 006	लेश्मेनिया स्पीशिज

2ग 007	नेजीलेरिया आस्ट्रेलियालेनसिस
2ग 008	नेजीलेरिया फाउलेरी
2ग 009	प्लासमोडियम फालसीपरुम
2ग 0010	न्यूमोसिसटिस कारीनी
2ग 0011	सीसटोसोमा मेनासेनी
2ग 0012	सीसटोसोमा जेपोनिकम
2ग 0013	सीसटोसोमा हेमोटोबियम
2ग 0014	टोकसोप्जाल्मा गोन्डी
2ग 0015	ट्राईचिनेला स्पाईरालिस
2ग 0016	ट्राईपेनोसोमा ब्रूयोई
2घ	वायरस, चाहे प्राकृतिक, संवर्धित या परिवर्धित, चाहे आइसोलेटेड लाईफ कल्वर के रूप में हों या फिर लीविंग बैटीरियल सहित ऐसे पदार्थ के रूप में जोकि जान-बूझकर निम्नलिखित के लिए ऐसे कल्वर से अप्रभावित अथवा दूषित किए गए हों:
2घ 001	अफ्रीकन होर्स सिकनस वाइरस
2घ 002	अफ्रीकन स्वाइन फिवर वाइरस
2घ 003	ऐवियन इंफ्यूएंजा वायरस
2घ 004	ब्ल्यू टंग वायरस
2घ 005	केमल पॉक्स वायरस
2घ 006	चिकुनगुनिया वायरस
2घ 007	क्रीमियन-कांगो हेमारेजिक फीवर वायरस
2घ 008	डेंगू वायरस
2घ 009	ईरटर्न इक्यूइन एनसीफ्लाइटिस वायरस
2घ 0010	ईबोला फीवर वायरस
2घ 0011	इनसीप्लोमायो कार्डिटिस वायरस (ई एम सी)
2घ 0012	फुट एण्ड माउथ डीजिज वाइरस (सभी सीरो प्रकार एवं उप प्रकार)
2घ 0013	गायनोरिटो वायरस
2घ 0014	गोटपॉक्स वायरस
2घ 0015	हनटान वायरस

2घ 0016	हरपेस वाइरस सीमेई (मंकी बी वायरस)
2घ 0017	हरपेस इटेलेस, हरपेस साइमीरी
2घ 0018	एच आई बी-1 एवं एच आई बी-2 तथा एच आई बी की अन्य स्ट्रेन्स
2घ 0019	होग कोलरा वायरस
2घ 0020	हयूमेन टी-सैल ल्हयूकेमिया वायरस
2घ 0021	न्यूनिन वायरस
2घ 0022	जापानीज एनसीफलाईटिस वायरस
2घ 0023	क्यासनूर फॉरेस्ट डीजिज वायरस एवं सेट्रल यूरोपियन एनसीफलाईटिस वायरसिज
2घ 0024	कोरियन हेमोरहेजिक फीवर वायरस
2घ 0025	लीम्प्कोसाइटिक कोरियोमेनिनगीटिस वायरस (एल सी एम)
2घ 0026	लासा वायरस
2घ 0027	मारबर्ग वायरस
2घ 0028	मर्सी वेली एनसीफलाईटिस वायरस
2घ 0029	मारक्यूपो वायरस
2घ 0030	मैसन-फाईज़र मंकी वायरस
2घ 0031	मंकी पॉक्स वायरस
2घ 0032	न्यूकांसल डीजिज वायरस
2घ 0033	आमस्क हेमोरहेजिक फीवर वायरस
2घ 0034	पेस्टी डेस पेटीटिस रयूमीनेट वायरस
2घ 0035	पोरसाइन एनटरो वायरस टाईप-1
2घ 0036	पोवासन वायरस
2घ 0037	रेबीज वायरस - सभी विकृतियाँ
2घ 0038	रेसापिरेटरी सिनसाईटियल वायरस
2घ 0039	रिफ्ट वैली फीवर वायरस
2घ 0040	रीडंरपेस्ट वायरस
2घ 0041	सेबिया वायरस
2घ 0042	शीपपॉक्स (फील्ड स्ट्रेन)
2घ 0043	सीन नॉबरी वायरस

2घ 0044	स्मालपॉक्स वायरस
2घ 0045	सेंट लूइस ऐनसीफलाईटिस वायरस
2घ 0046	स्वाइन फीवर वायरस
2घ 0047	टिक-बोर्न ऐनसीफलाईटिस वायरस (रशियन सिंप्रग समर ऐनसीफलाईटिस वायरस)
2घ 0048	शेशन डीजहज वायरस (पोरशन एन्ट्रो वायरस टाइप-1)
2घ 0049	वैरिओला वायरस
2घ 0050	वैनीज्यूलेन ऐनसीफलाईटिस वायरस
2घ 0051	वैसीक्यूलर स्टोमाटिटिस वायरस
2घ 0052	वैस्टर्न ऐनसीफलाईटिस वायरस
2घ 0053	येलो फीवर वायरस, 17 डी वैक्सीन वायरस
2 ड.	रिकटीसियाल, चाहे प्राकृतिक, संवर्धित या परिवर्धित, चाहे आइसोलेटेड लाईफ कल्वर के रूप में हाँ या फिर लीविंग मैटीरियल सहित ऐसे पदार्थ के रूप में जोकि जान-बूझकर निम्नलिखित के लिए ऐसे कल्वर से अप्रभावित अथवा दूषित किए गए हों :
2 ड.001	कोक्सीला बर्ननीटी
2 ड.002	रिकेटीसाई रिकेटीसी
2 ड.003	रिकेटीसाई क्विनटाना
2 ड.004	रिकेटीसाई प्रोवाजीबी
2 च	टाक्सिन्स
2 च 001	अब्रीन्स
2 च 002	एफलाटॉक्सिन्स
2 च 003	अनटोक्सीन्स
2 च 004	बोटूलीनम टॉक्सिन (एस) (क्लोस्ट्रोडियम बोटूलिनम)
2 च 005	बनगारोटॉक्सिन्स
2 च 006	क्लासट्रीडियम परफ्रीनजन्स टॉक्सिन्स
2 च 007	कॉरनीबेक्टीरयम डीपथेरी टॉक्सिन्स
2 च 008	साइनगिनोसिन्स (माइक्रोसिसटिन्स) (माइक्रोसिसटिक एयूजीनोसा)
2 च 009	एनट्रोटॉक्सिन (स्टेफीलोक्सस आयरस)

2 च 010	न्यूरोटॉक्सिन (शीगेला डायसेन्टरी)
2 च 011	रायरीनस
2 च 012	शीगाटॉक्सिन
2 च 013	सेक्सीटॉक्सिन
2 च 014	ट्राईकोथीसीन माइक्रोटॉक्सीनस
2 च 015	टेटानस टॉक्सिन (क्लॉसट्रीडियम टेटानी)
2 च 016	टेट्रोडोटॉक्सीन (सैपरोडीस रयूफ्रीपेस)
2 च 017	वेरीयूकोलोजेन (एम. वेरुकेडिया)
2छ	प्लांट पैथोजनस
2छ 001	बैमीसिया टेबाकी
2छ 002	कैलोटोट्राईशुम कॉफीएन्यूम वर. वर्यूलेस
2छ 003	क्लावाइसेप परप्यूरिया
2छ 004	डोथीस्ट्रोमा पीनी (सिकरहिया पीनी)
2छ 005	एरविनिया एमवाइलोवोरा
2छ 006	फ्रेंकलिनीऐला ऑक्सीडेटालीस
2छ 007	माइक्रोसाईक्लस यूली
2छ 008	पेरोनोसोपारा हीयोसिक्यामी डी बेरी एफ.एस.पी. ट्वेकीना (एडम) रक्गलीकी
2छ 009	फीटोफथोरा इन्फेस्टेस
2छ 0010	प्यूकीनिया ग्रामीनिस
2छ 0011	प्यूकीनिया ऐरीनथी
2छ 0012	प्यूकीनिया स्ट्रीफोरमिस (प्यूकीनिया ग्लूमारम)
2छ 0013	पीराक्यूलेरिया ऑरीजे
2छ 0014	श्यूडोमोनस सोलनएकियारम
2छ 0015	पेरोनोसोपरा हाईस्कामई डी बेरी
2छ 0016	रालरटोनिया सोलन ऐकियारम
2छ 0017	सूगरकेन फीजी डीजिज वायरस
2छ 0018	सेलरोटीनिया सेलरोटायोरम

2छ 0019	टिलेटिया इंडिका
2छ 0020	थ्रीपस पाल्सी
2छ 0021	यूरस्टीलेगो मेडिस
2छ 0022	जेनथोमोनस एलबी लिनएनेस
2छ 0023	जेनथोमोनस कैम्पीस्ट्रीस पी.वी.सीटरी
2छ 0024	जेनथोमोनस कैम्पीस्ट्रीस पी.वी. ओरिजिई

2ज	आनुवांशिक रूप से संबंधित आर्गेनिजम
2ज 001	<p>अनुवांशिकी-संबंधित सूक्ष्म-आर्गेनिजम या आनुवांशिक तत्व जिनमें रोगजनित अनुवांशिकी के साथ संलग्नित न्यूक्लिक एसिड ऋण्खलाएं होती हैं और जिन्हें ऊपर 2क, 2ख, 2ग, 2घ, 2ड. तथा 2च में उद्धृत आर्गेनिजम से बनाया जाता है।</p> <p>आनुवांशिक-संबंधित सूक्ष्म-आर्गेनिजम अथवा आनुवांशिक तत्व जिनमें ऊपर 2च में विनिर्दिष्ट किसी भी टॉक्सिन की न्यूक्लिक एसिड ऋण्खला कोडिंग है।</p>

श्रेणी 3	पदार्थ, पदार्थ संसाधित उपकरण एवं संबंधित तकनीकें
3क	पदार्थ
3क1	विशेष पदार्थ
3क101	जिरकोनियम, बेरीलियम, मैग्नीशियम एवं इनकी मिश्रधातुवीय कणिकाएं 60 माइक्रो मी. के आकार में
3क102	मैराजिंग स्टील किसी भी रूप में जिसमें रेखीय विमाएं 75 एम एम से अधिक हों या शीट, प्लेट अथवा ट्यूबिंग में जिसमें वाल या प्लेट की मोटाई 5 एम एम के बराबर या कम हो
3क103	टंगस्टन (सी.ए.एस 12070-12-1), मोलीबडीनम (सी ए एस 1317-33-5) और उन धातुओं की मिश्रधातुएं जो एकरूपीय गोलाकार अथवा परमाणवीय कण जिनका आकार 500 माइक्रो मी. से कम हो
3क104	जरमेनियम
3क105	गैलियम
3क106	इंडीयम
3क107	टाइटेनियम मिश्रधातुएं जिसमें टाइटेनियम-स्टेबलाइजिड ऊपरलेक्स स्टेनलेस स्टील (टाई-डी.एस.एस.) होता है (0अ307 जैसा कि विशेषकृत है के अलावा)

3क108	किसी भी रूप में एल्यूमीनियम मिश्रधातुएं जो कि एक अंतिम 460 एम पी ए या अधिक की तन्यताजनित ताकत 293k (20 डीग्रिज सी) पर 'प्राप्त करने में सक्षम' होती है नोट- वाक्यांश 'प्राप्त करने में सक्षम' में मिश्र धातुएं गम करने के पहले या बाद में
3क 109	बिसमुथ जिसमें 99.99 प्रतिशत या अधिक की शुद्धता भार के द्वारा होती है एवं जिसमें सिल्वर भार से 10 पी.पी.एम. से कम मिलता है ।
3क110	कैल्शियम जिसमें भार की धात्विक अशुद्धताएं मैग्नीशियम के अलावा 1000 पी पी एम से कम होती हैं तथा जिसमें भार से 10 पी.पी.एम. से कम बोरोन होता है ।
3क111	क्लोरीन ट्राइफ्लोराईड (सी आई एफ 3)
3क112	मैग्नीशियम जिसमें कैल्शियम के अलावा धात्विक अशुद्धियाँ 200 पी पी एम से कम होती हैं तथा जिसमें भार से 10 पी.पी.एम. से कम बोरोन होता है ।
3क113	टंगस्टन, टंगस्टन कार्बाइड तथा मिश्र धातुएं जिनमें 90 प्रतिशत से अधिक टंगस्टन भार के द्वारा ऐसे रूपों में जिनमें खोरवली बेलनाकार समानता (बेलनाकार विरवंड (सैगमैट) समेत) होती है और जिसमें 100 व 300 एम एम का आंतरिक व्यास होता है तथा 20 किग्रा. से अधिक संहति होती है
3क114	(अ) भार के द्वारा 99.0 प्रतिशत या इससे अधिक की शुद्धता वाला तथा $10 \mu\text{m}$ से कम माध्यम कण आकार वाला निकिल पाउडर; (ख) ऊपर वर्णित निकेल पाउडर से व्युत्पन छिद्र युक्त निकिल धातु
3क115	प्राकृतिक बोरोन, बोरोन कार्बाइड अथवा धात्विक बोराइड्स जिनमें 85 प्रतिशत या अधिक की बोरोन शुद्धता हो
3क116	रेशेदार अथवा तंतुदार सामग्रियाँ और प्रैपरेग जो निम्न प्रकार से हैं :- (क) कार्बन या आरमिड रेशेदार या तंतुदार सामग्रियाँ जिनका विशिष्ट मापांक 12.7×10^6 मी. या अधिक हो, अथवा विशिष्ट तन्यता शक्ति 23.5×10^4 मी. या अधिक की हो । (ख) ग्लास फाइब्रस या तंतुदार सामग्रियाँ जिनका विशिष्ट मापांक 3.18×10^6 मी. या अधिक हो, तथा विशिष्ट तन्यता शक्ति 7.62×10^4 मी. या अधिक की हो (ग) उपरोक्त ऊपरवर्णित (क) अथवा (ख) में विनिर्दिष्ट कार्बन या ग्लास फाइब्रस या फिलामेंटरी सामग्रियों से बने थर्मोसेट रेजिन इम्प्रेगनेटेड कन्टीनुअस यार्न्स, रोबिंग्स, टोअज अथवा टेपस 15 मि.मी. अथवा कम (प्रीप्रेग्स) चौड़ाई वाले

3क117	कार्बन-कार्बन संघटक
3 क 2	संरचनात्मक सामग्रियाँ
3 क 201	<p>संरचनात्मक सामग्रियाँ जैसे कि</p> <p>(क) संयुक्त ढांचे, लैमीनेट्स, रेजिन इंमिजनेटिड फाइबर प्रीप्रैग्स और धातु जड़ित फाइबर प्रीफॉर्मस या तो एक जैविक मैट्रिक्स या मैटल मैट्रिक्स जिनमें फाइब्रस या फिलामेंट्री रिइनफोर्समेंट प्रयुक्त हों, और इस प्रकार उनका निर्माण होता हो, उन्हें रॉकेट सिस्टम में प्रयोग करने के लिए विशेष रूप से बनाया जाता है, (इसमें बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम स्पेस लांच विहकल तथा साउंडिंग रॉकेट शामिल हैं) मानवरहित एरिअल विहकल तथा क्रूस मिसाइल तथा इस प्रकार से उप प्रकार भी शामिल हैं</p> <p>(ख) पुनःसंतृप्ति पायेरोलाइज्ड (अर्थात् कार्बन-कार्बन) पदार्थ जिन्हें विशेष रूप से मानव रहित एरियल वाहन तथा क्रूज मिसाइल रॉकेट सिस्टम के लिए डिजाइन किया जाता है (इसमें बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम स्पेस लांच विहकल तथा साउंडिंग रॉकेट शामिल हैं)</p> <p>(ग) फाईन-ग्रेन री-क्रीसटेलाइज्ड बल्क ग्रेफाइट्स एवं पाइरोलिटिक या फाइब्रस रिइनफोर्सड ग्रेफाइट जो राकेट नॉजलस एवं री-एंट्री वेहिकल नोज़ टिप के लिए प्रयुक्ति लायक होती हैं ।</p> <p>(घ) सीरेमिक कम्पोजिट मैटीरियल (डाइइलैक्ट्रिक कांसटेंट जो कि 100 मेगाहर्टज से 100 गीगा हर्टज की फ्रिक्वेंसी पर 6 से कम है) जो मिसाइल रेडोम्स में प्रयुक्त होते हैं ।</p> <p>(ङ.) रेड्यूसल रेडार रिफ्लेक्टिविटी के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ एवं परते</p> <p>(च) बल्क मशीनेबल सिलिकोन कार्बाइड रिइंफोर्सड अनफायरड सिरेमिक जो सि-एंट्री विहकल नोज़ टिप्स में प्रयुक्त कर सकते हैं ।</p>
3 क 3	राकेट नोदक एवं अवयवी रसायन
3 क 301	प्रोपलसिव पदार्थ - हाइड्रोजीन (सी ए एस-302-01) एवं इसके व्यूत्परिकों को

	रॉकेट ईंधन पदार्थों जिसमें मोनोमिथाइल हाइड्रेजिन (एम एम एच) (सी ए एस 60-34), अनसिमिट्रिकल डाईमिथाइल हाइड्रेजिन (यू डी एम एच), सी ए एस 57-14-7) हाईड्रेजिन नाइट्रोट (अरोमेटिक हाइड्रेजिनस एवं उनके साल्ट्स, एडिपिक एसिड डाईहाइड्रेजाइड के अलावा), अमोनियम परक्लोरेट, स्फेरिकल एल्यूमीनियम पाउडर (सी.ए.एस. 7429-90-5) शामिल हैं
3 क 302	धातु ईंधन जिनमें इनमें से कोई भी शामिल हो सकते हैं जिरकोनियम (सी ए एस 7440-67-7), बेरीलियम (सी ए एस 7440-41-7), मैग्नीशियम, टाइटेनियम, टंगस्टन, बोरोन एवं बोरोन मिश्रधातुएं, जिंक तथा मैग्नीशियम की मिश्रधातुएं (सी ए एस 7439-95-4)
3 क 303	बहुलकीय पदार्थ कार्बोक्साइल - टरमिनेटिड पोलीब्यूटार्डीन (सी टी पी बी) हाइड्रॉक्सी - टर्मिनेटेड पॉलिब्यूटार्डीन (एच टी पी बी) रलायसिलाइल एजाइड पॉलिमर (जी ए पी) पॉलिब्यूटार्डीन एक्रिलिक एसिड (पी बी ए ए) पॉलिब्यूटार्डीन एक्रिलोनाइट्राइल (पी बी ए एन)
3 क 304	कम्पोजिट प्रोपैलेन्ट्स और कम्पोजिट मॉडीफाइड डबल बेस प्रोपैलेन्ट्स
3 क 305	हाई एनर्जी डेन्सटी मेटीरियल जैसे बोरोन स्लरी
3 क 306	ऑक्सीडाइज़र्स/फ्यूल्स- परक्लोरेट्स, क्लोरेट्स या क्रोमेट्स जो कि पाऊडर्ड मेटल या अन्य हाई एनर्जी फ्यूल कम्पोनेन्ट्स; डाय नाइट्रोजन ट्रायॉक्साइड, नाइट्रोजन डायाक्साइड/डायनाइट्रोजन टैट्रॉक्साइड, मिक्सड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन (एम ओ एन) डायनाइट्रोजन पैन्टॉक्साइड, इन्हीबिटेड रेड फ्यूर्मिंग नाइट्रिक एसिड (आई आर एफ एन ए) (सी ए एस 8007-58-7), अमोनियम परक्लोरेट (सी ए एस 7790-98-9), अमोनियम डायनाइट्रामाइड (ए डी एन) (सी ए एस 140456-78-6), हाइड्रोजीनियम नाइट्रोफोर्मेट (एच एन एफ), कम्पाऊन्ड जो कि फ्लोराइन और एक और अन्य हेलोजन्स, ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन से बने हों, मिश्रित किए गए हों।
3 क 307	बान्डिंग एजेन्ट्स ट्रिस (1-2(2-मिथाइल) एजाइरीडायनिल फास्फाइन ऑक्साइड (एम ए पी ओ) (सी ए एस 57-39-6), द्रोयमेसासैइल-1-(2-ईथाइल) एजायराइडीन (एच एक्स-868, बी आई टी ए) (सी ए एस 7722-13-8), टेपनॉल (एच एक्स-878) (सी ए एस 68412-46-4), टेपन (एच एक्स-879) रिएक्शन प्रोडक्ट ऑफ टैट्राइथाइलायलीन पैन्टामाइन और एक्रिलोनाइट्राइल

	(सी ए एस 68412-45-3), और पॉलिफक्शनल एजाइरीडाइन एमाइड्स विद आइसोपथालिक, ट्रायमेसिक, आइसोसायान्यूरिक, या ट्रायमिथारलाडिपिक बैकबोन भी जिसमें 2-मिथाइल या 2-इथाइल एजाइरीडाइन ग्रुप हो जिसमें 1,1-आइसोपथालोयल-बिस (2-मिथाइलजायरीडीन) (सी एस 7652-64-4), (एच एक्स-752, एच एक्स-874, और एच एक्स-877) शामिल हो;
3 क 308	क्योरिंग एजेन्ट्स और रिएक्शन कैटालिस्ट्स-ट्रायफिनाइल बिस्मथ (टी पी बी) (सी ए एस 603-33-8) ;
3 क 309	<p>बर्निंग रेट मॉडीफायर्स</p> <p>क. कार्बरिन्स, डेकाबोरेन्स, पेन्टाबोरेन्स और उनके डेरीवेटिव्स ;</p> <p>ख. फैरोसीन डेरीवेटिव्स, निम्नानुसार ;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कैटोसीन (सी ए एस 37206-42-1); 2. इथाइल फैरोसीन ; 3. प्रोपाइल फैरोसीन (सी ए एस 1273-89-8); 4. एन-ब्यूटाइल फैरोसीन (सी ए एस 31904-29-7); 5. पैन्टाइल फैरोसीन (सी ए एस 1274-00-6) 6. डायसाइक्लोपैन्टाइल फैरोसीन (सी ए एस 20773-28-8) 7. डायसाईक्लोहैक्साइल फैरोसीन, 8. डायइथाइल फैरोसीन 9. डायप्रोपाइल फैरोसीन 10. डीब्यूटाइल फैरोसीन (सी ए एस 1274-08-4); 11. डायहैक्साइल फैरोसीन (सी ए एस 93894-59-8); 12. एसेटाइल फैरोसीनस 13. फैरोसीन कार्बोग्जिलिक एसिड्स ; 14. ब्यूटासीन <p>ग. रॉकेट प्रोपेलैन्ट बर्निंग रेट मॉडीफायर्स के रूप में प्रयोग योग्य अन्य फैरोसीन डेरीवेटिव्स</p>
3 क 310	<p>नाइट्रेट ईस्टर्स और नाइट्रेटेड प्लास्टिसाइजर्स निम्नानुसार:</p> <p>क) ट्रायइथाइलीन ग्लायकॉल डायनाइट्रेट (टी ई जी डी एन)</p> <p>ख) ट्रायमिथाइलोलीयथेन ट्रायनाइट्रेट (टी एम ई टी एन) (सी ए एस 3032-55-1)</p> <p>ग) 1,2,4 ब्यूटेनइट्रियोल ट्रायनाइट्रेट(बी टी टी एन) (सी ए एस 6659-60-5);</p> <p>घ) डायइथाइलीन ग्लायकॉल डायनाइट्रेट (डी ई जी डी एन)</p>

3 क 311	स्टैब्लार्ज़स निम्नानुसार : क. 2-नाइट्रोडायफिनायलामाइन (सी ए एस 119-75-5); ख. एन मिथाइल-पी-नाइट्रोएनाइलाइन (सी ए एस 100-15-2)
3 क 4	हाई एक्सप्लोसिव्स
3 क 401	हाई एक्सप्लोसिव्स, और प्रोपैलैन्ट्स या मिक्सचर्स जिनमें निम्नलिखित में से कोई हो; क. साइक्लोटेरामिथाइलेनेटेट्रानाइट्रामाइन (एच एम एक्स); ख. साइक्लोट्रायमिथाइलीनट्राई नाइट्रामाइन (आर डी एक्स); ग. ट्राईअमाइनोट्राइनाइट्रोबेन्जीन (टी ए टी बी) घ. हैक्सानाइट्रोस्टिलबीन (एच एन एस) ‘3क 401क और 3क 401ख पर निर्यात मदों हेतु लाइसेंस आवेदनों को सामान्यतया मना कर दिया जाएगा ।
3 क 5	स्टैब्ल्यू सामग्री
3 क 501	क. रिड्यूसड आवसर्वबल्स जैसे कि रेडार रिफ्लेक्टिविटी, अल्ट्रावॉयलेट/इन्फ्रारेड सिग्नेचर्स और एकांस्टिक सिग्नेचर्स के लिए सामग्री ; ख. डिवाइसेज़, नॉन-स्टैब्ल्यू सामग्री से बनी समेत, रिड्यूसड आवसर्वबल्स के लिए जैसे कि रेडार रिफ्लेक्टिविटी, अल्ट्रावॉयलेट/इन्फ्रारेड सिग्नेचर्स और एकांस्टिक सिग्नेचर्स के लिए;
3 क 502	रिड्यूसड या टेलर्ड रिक्लेक्टिविटी या ईमोसिविटी माइक्रोवेब में, के लिए विशेष रूप से तैयार मेटीरियल्स और कोटिंग्स (पेन्ट्स सहित) कोटिंग्स (पेन्ट्स सहित) को छोड़कर इन्फ्रारेड या एल्ट्रावॉयलेट स्पैक्ट्रा जब सैटेलाइट्स के थर्मल कन्ड्रोल के लिए विशेष रूप से प्रयोग किया जाए ।
3 क 503	3 ए मे मदों के विकास, उत्पादन या प्रयोग से संबंधित तकनीक
3 ख	मेटीरियल्स प्रोसैसिंग और “प्रोडक्शन इक्विपमैन्ट” संबंधित “तकनीक” और उनके विशेष रूप से तैयार कम्पोनैन्ट्स और अनुषंगी ।
3 ख 001	रिमोट मेनिपुलेटर्स जो इलेक्ट्रिकल, हाइड्रॉलिक या मैकेनिकल साधनों द्वारा मानव आपरेटर एक्शन के लिए मैकेनिकल ट्रान्सलेशन प्रदान करते हैं और आप्रेटिंग आर्म और टर्मिनल फिक्सचर जिनका इस्तेमाल रिमोट एक्शन प्रदान करने के लिए किया जा सकता है ।
3 ख 002	वस्त्र मशीनरी को छोड़कर जो कि रॉकेट सिस्टम के लिए परिवर्तित नहीं किया गया, कम्पोजिट स्ट्रक्चर्स फेब्रिकेट करने के लिए वीविंग, इन्टरलेसिंग या ब्रेडिंग

	फाइबर्स के लिए अडाप्टर्स और मॉडीफिकेशन किट्स सहित मल्टी डायरेक्शनल, मल्टीडायमेन्शनल वीविंग और इन्टरलेसिंग मशीनें;
3 ख 003	फाइबर्स या फिलामेन्टरी मेटीरियल के उत्पादन के लिए डिज़ाइन किए गए या संशोधित किए गए उपकरण नामतः कन्वर्टिंग पॉलिमेटिक सब्स्टान्सेज, वेपर डिपोजीशन ऑन हीटेड फिलामेन्टस सब्स्ट्रेट्स: रिफ्रैक्टरी सिरेमिक्स की वेट स्प्रिनिंग
3 ख 004	स्पेशल फाइबर सरफेस ट्रीटमेंट या प्रेपरेग्स और परफार्मस, रोलर्स, टेन्शन स्ट्रेचर्स, कोटिंग इक्विपमैन्ट, कटिंग इक्विपमैन्ट और क्लिकर डायज़ सहित उत्पादित करने के लिए तैयार किए गए और परिवर्तित किए गए इक्विपमैन्ट;
3 ख 005	कार्बन-कार्बन कम्पोजिट्स के डेन्सीफिकेशन के लिए तैयार किए गए और परिवर्तित किए गए केमिकल वेपर डिपोजीशन फरनेसेज़
3 ख 006	पाइरोलिटिक डिपोजीशन और डेन्सीफिकेशन उपकरण जिसमें शामिल हैं :- क. प्रिकर्सर गैसों से मोल्ड, मैन्ड्रल या अन्य सब्स्ट्रेट पर फार्मड पाइरोटिकली मेटीरियल के उत्पादन के लिए टैक्नॉलाजी ख. उपर्युक्त प्रक्रिया के लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए नोजल्स ग. उपकरण और प्रक्रिया नियंत्रण तथा इसके लिए विशेष तौर पर तैयार किए गए सॉफ्टवेयर, संरचनात्मक समेकित रॉकेट नोजल्स और रीऐन्ट्री वैहीकल नोज टिप्स विशेष तौर पर डेन्सीफीकेशन और पॉयरोलाईसिस के लिए तैयार किए गए
3 ख 007	उत्पादन, प्रबंधन, मिश्रण, ठीक करने, कास्टिंग, प्रैसिंग, मशीनिंग या रॉकेट प्रोपैलेन्ट्स या रॉकेट प्रोपैलेन्ट्स संघटकों ठोस या तरल के स्वीकृत परीक्षण के लिए विशेष तौर पर तैयार या संशोधित उत्पादन उपकरण ।
3 ख 008	हाइड्रोजन या हीलियम को -250 डिग्री सेल्सियस (23 के) या उससे कम तक ठंडा करने में सक्षम रेफ्रीजरेशन यूनिटें और उपकरण
3 ख 009	कॉन्टीन्यूअस नाइट्रोजेन
3 ख 010	डीहाईड्रेशन प्रैसेज
3 ख 011	उच्च विस्फोटक बेधन के लिए विशेष तौर पर तैयार किए या संशोधित किए गए स्क्रू एक्सट्रूडर्स
3 ख 012	एक्सट्रूडर प्रोपैलेन्ट को आकार देने के लिए काटने वाली मशीनें

3ख013	1.85 एम या अधिक व्यास वाले और 227 किग्रा. उत्पाद क्षमता वाले स्वीटी बैरलस (टम्बलर्स)
3ख014	वैक्यूम के तहत मिकिंग के लिए प्रोवीजन के साथ कान्टीन्यूअंस मिक्सर्ज और बैच मिक्सर्ज
3ख015	3क3 में मदों में से किसी की भी ग्राइन्डिंग या मिलिंग के लिए प्रयोगयोग्य फ्लूड एनर्जी मिल्ज
3ख016	धातु चूर्णों में स्फैरीसिटी और एक रूप कण के आकार, को प्राप्त करने के लिए उपकरण क. उत्पाद के लिए प्रयोग योग्य धातु चूर्ण उत्पादन उपकरण, नियंत्रित पर्यावरण में, स्फेयरिकल या एटमाइज्ड सामग्री जिसमें शामिल हो; ख. स्पटर्ड या स्फेयरिकल मेटालिक पाउडर के लिए प्रयोग योग्य प्लाज्मा जैनरेटर्स (हाई फ्रीक्वेन्सी आर्क जेट्स) आर्गन-वाटर एन्वायरमैन्ट में प्रोसैस के आर्गनाइजेशन सहित। ग. स्पटर्ड या स्फेयरिकल मेटालिक पाउडर के लिए प्रयोग योग्य प्लाज्मा जैनरेटर्स आर्गन-वाटर इलेक्ट्रोवर्स्ट उपकरण में प्रोसैस के आर्गनाइजेशन सहित।
3ख017	स्पटर आयन पम्प्स
3ख018	ऑटोक्लेव्स और हाइड्रोक्लेव्स जब कम्पोजिट्स और प्रोसैसर्ड कम्पोजिट्स के उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाएं, में ताप, दबाव या वातावरण के विनियमन के लिए तकनीकी डाटा (प्रोसैसिंग शर्तों सहित) और प्रक्रियाएँ
3ख019	3क में उल्लिखित सामग्रियों के उत्पादन और हैन्डलिंग के लिए उपकरण के उपयोग के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए और परिवर्तित किए गए सॉफ्टवेयर
3ग	(आरक्षित)
3घ	रसायन और जैव सामग्री बनाने तथा प्रबंधन करने वाले उपकरण तथा सुविधाएँ :

3घ001

रिएक्शन वैसल्ज, रिएक्टरज या एजीटेटरस, भंडारा टंकियाँ, कंटेनर्स या रिसीवर्स, हीट एक्सचेंजर्स या कंडेनसर्स, डिस्टीलिएशन या एबजोर्बशन कॉलम्स, वाल्व्स दूर से परिचालित किए जाने वाले फिलिंग उपकरण, बहु परतीय पाईपें, बिलोज, डायाफ्राम पंप्स, वैक्यूम पंप्स, पंखे, कम्प्रैसर्स, ब्लोअर्स, गैस (जिसमें हवा भी शामिल है) प्रबंधन या निम्नलिखित से पूर्णतः, आंशिक रूप या किसी एक से बने अन्य तत्व-स्थानांतरण उपकरण:

- (क) निकल या अयस्क जिसमें वजन के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक निकल हो।
- (ख) अयस्क जिसमें वजन के अनुसार 20 प्रतिशत से अधिक निकल और 20 प्रतिशत क्रोमियम हो (उदाहरणार्थः हैसटीलॉय, इलोयम, इनकोनल, इनकलॉय)
- (ग) फ्लूरोपॉलीमर्स
- (घ) शीशा या शीशा लाईन्ड (जिसमें विट्रीफाईड या एन की गई कोटिंग शामिल हो)
- (ङ.) ग्रेफाईट
- (च) टैन्टालम या टैन्टालम एलॉयस
- (छ) टिटैनियम या टिटैनियम अयस्क
- (ज) जिरकोनियम या जिरकोनियम अयस्क
- (झ) सिरामिक्स
- (झ) फैरोसिलीकोन

टिप्पणी: 3घ001 निम्नलिखित मदों को नियंत्रित नहीं करते:

- (क) ग्लास शीट्स (जैसे एक्वैरियम, वाटर टैंक आदि) से बने खुले वैसल्स या कुकवेयर, टेबल वेयर, कलात्मक शीशा या सिरामिक मदें (फूल दान, कलात्मक चीजें इत्यादि)
- (ख) ग्लास-वेयर (चाहे धातु आच्छादित हों या न हों) या ग्लास-लाईन्ड रिएक्शन वैसल्ज या रिएक्टर्स, चाहे एजीटेटर्स से सुसज्जित हो या न हो परन्तु हर वैसल या रिएक्टर का पूरा आंतरिक (ज्यामितिय) आकार 20,000 लीटर (20 एम3) से अधिक हो या 100 लिटर (0.1 एम3) बराबर या उससे कम हो। बाद वाली मद की ग्लास क्षमता या सिरामिक वेयर के उदाहरणों में मानक परीक्षण शाला उपकरण जैसे परखनलियाँ, फ्लास्क, रिटार्टज, क्रूसीबल्स इत्यादि भी शामिल हैं।

3घ002	संवर्ग 1 के अंतर्गत वर्गीकृत इन्सीनरेटर्स जोकि किसी भी रसायन को नष्ट करने के लिए तैयार किए गए हों।
3घ003	<p>1273 के (1000 डिग्री सेंटीग्रेड) से अधिक तापमान वाले कम्बस्टर या पाइरोलाइजर्स जोकि एक हीट जोन (बर्नर) के सक्षम हों और जिसमें निम्नलिखित में से किसी एक से बने या परत चढ़ाए हुए हों और जिसमें कोई भी परत उसके प्रत्यक्ष संपर्क में उसी के बने सामान की हो:-</p> <p>(क) अयस्क जिसमें वजन के अनुसार 25 प्रतिशत से अधिक निकल और 25 प्रतिशत क्रोमियम हो (उदाहरणार्थः हैटेलॉय, इलीयम, इनकोनल, इनकोलॉय)</p> <p>(ख) निकल या अयस्क जिसमें वजन के अनुसार 40 प्रतिशत से अधिक हो, या</p> <p>(ग) टिटैनियम</p> <p>(घ) सिरामिक्स</p>
3घ004	<p>पी3, पी4 सुविधाओं से संबंधित उपकरण जैसे कि प्रोटैक्टिव सूट और श्रेणी 3 सुरक्षा केबिनेट्स।</p> <p>विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू एच ओ) बायो सेफ्टी मैन्यूल में यथाउल्लिखित पी3, पी4 कन्टेनमैन्ट स्तर, पर सम्पूर्ण कन्टेनमैन्ट सुविधाओं के लिए लाइसेंसों की अनुमति नहीं दी जाएगी।</p>
3घ005	3घ में मदों के विकास, उत्पादन और प्रयोग से संबंधित तकनीक

श्रेणी4	न्यूकिलियर संबंधित अन्य उपकरण, असैम्बलीज और कम्पनैन्ट्स; परीक्षण और उत्पादन उपकरण; और संबंधित तकनीक जो श्रेणी 0 के तहत नियन्त्रित न हो।
4क	उपकरण, असैम्बलीज, कम्पनैन्ट्स जिनमें परीक्षण और उत्पादन उपकरण शामिल हो
4क001	फ्लो फोर्मिंग मशीनें, स्पिन फोर्मिंग मशीनें जो कि फ्लो-फोर्मिंग फन्क्शन्स और

	<p>मैन्ड्रेल्स के सक्षम हो, निम्नानुसार,</p> <p>क. फ्लो फोर्मिंग मशीनों के लिए 5क 205 देखें।</p> <p>ख. स्पिन फोर्मिंग मशीनें जिनमें निम्नलिखित दोनों विशेषताएं हों:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. तीन या इससे अधिक रोलर्स (एकिटव या गाइडिंग); और 2. जिनमें 'न्यूमेरिकल कन्ट्रोल' यूनिटें या कम्प्यूटर कन्ट्रोल लगाया जा सकता है। <p>ग. रोटर-फोर्मिंग मैन्ड्रेल्स जो कि बीच का डायामीटर 75 और 400 एमएम के बीच के सिलेंडरिकल रोटर्स बनाने के लिए तैयार किए गए हों।</p> <p>टिप्पणी: मद क001क और 4क001ख में वे मशीनें शामिल हैं जिनमें मेटल प्लस टू ऑक्सीलरी रोलर्स जो कि मैन्ड्रल को सपोर्ट करते हैं, को डिफार्म करने के लिए तैयार किया गया केवल एक सिंगल रोलर है, लेकिन सीधे रूप से डिफार्मेशन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं।</p> <p>4क002 मशीन टूल्स, निम्नानुसार, मैटल हटाने और काटने के लिए, सेरामिक्स, या कम्पोजिट्स, जो कि विनिर्माता के तकनीकी विनिर्देशन के अनुसार दो या इससे अधिक एक्सिज में कन्ट्रॉरिंग कन्ट्रोल के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज के साथ लगाए जा सकते हैं।</p> <p>(क) टर्निंग के लिए मशीन टूल्स जिनमें 35 एमएम से अधिक मशीनिंग डायामीटर के योग्य मशीनों के लिए किसी लीनियर एक्सेस ओवरॉल पोजीशनिंग के साथ $6 \mu\text{m}$ से बेहतर (कम) उपलब्ध सभी कम्पनसेशन्स के साथ पोजीशनिंग एक्युरेसीज़</p> <p>टिप्पणी: मद 4क002क में बार मशीनें नहीं आती, केवल बार फीड के माध्यम से मशीनिंग तक सीमित है, यदि अधिकतम बार डायामीटर बराबर अथवा 42 एमएम से कम है और माऊन्टिंग चक्स की क्षमता नहीं है, मशीनों में 42 एमएम से कम डायामीटर के साथ मशीनिंग पार्ट्स के लिए ड्रिलिंग और/या मिलिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए।</p> <p>(ख) मिलिंग के लिए मशीन टूल्स, जिनमें निम्नलिखित में से कोई एक विशेषता हो:</p> <p>(1) किसी लीनियर एक्सिज (ओवरॉल पोजीशनिंग) के साथ $6 \mu\text{m}$ से</p>
--	--

बेहतर (कम) उपलब्ध सभी कम्पेनसेशन्स के साथ पोजीशनिंग एक्यूरेसीज; या

(2) दो या इससे अधिक कन्टूरिंग रोटरी एक्सिज;

टिप्पणी: निम्नलिखित दोनों विशेषताओं वाली मिलिंग मशीनें 4क002ख के तहत नहीं आती:

(1) 2एम से अधिक एक्स-एक्सिज ट्रेवल; और

(2) 30 μm बदतर (अधिक) एक्स-एक्सिज पर ओवरॉल पोजिशनिंग एक्यूरेसी

(ग) ग्राइंडिंग के लिए मशीन टूल्स, जिनमें निम्नलिखित में से कोई एक विशेषता हो:

(1) किसी लीनियर एक्सिज (ओवरॉल पोजिशनिंग) के साथ 4 μm से बेहतर (कम) उपलब्ध सभी कम्पेनसेशन्स के साथ पोजिशनिंग एक्यूरेसीज

(2) दो या इससे अधिक कन्टूरिंग रोटरी एक्सिज,

टिप्पणी: निम्नलिखित के अनुसार ग्राइन्डिंग मशीनें 4क002ग के तहत नहीं आती,

(1) सिलेण्डरीकल एक्स्टर्नल, इन्टरनल और एक्स्टर्नल-इन्टरनल ग्राइन्डिंग मशीनें जिनमें निम्नलिखित विशेषताएं हों-

(क) सिलेण्डरीकल ग्राइंडिंग तक सीमित

(ख) 150 एमएम के डायामीटर के बाहर या लम्बाई का अधिकतम वर्क-पीस,

(ग) दो एक्सेज से अधिक का न हो जो कि कन्टूरिंग कन्ट्रोल के लिए समन्वित की जा सके, और

(घ) कन्टूरिंग सी-एक्सिज नहीं,

(2) एक्स, वाई, सी और ए तक सीमित एक्सिज के साथ जिग ग्राइन्डर्स और जहाँ सी-एक्सिज का प्रयोग ग्राइंडिंग व्हील को मेनटेन करने के लिए किया जाता है और ए-एक्सिज को ग्राइन्ड वैरेल कैम्स के समनुरूप बनाया जाता है।

(3) टूल्स या कटर्स के विनिर्माण के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए सॉफ्ट वेयर सहित टूल या कटर ग्राइंडिंग मशीनें,

(4) क्रैंकशैफ्ट या कैमशैफ्ट ग्राइंडिंग मशीनें

(घ) नॉन वायर टाइप इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनें (ईडीएम) जिनमें दो या इससे

अधिक कन्टूरिंग रोटरी एक्सिज हैं और जो कि कन्टूरिंग कन्ट्रोल के लिए साथ-साथ समन्वित की जा सकें।

टिप्पणी: आईएसओ 230/2 (1988) या नेशनल इक्वलैन्ट्स के अनुसार किए गए मापों से निम्नलिखित प्रक्रियाओं के तहत लिए गए स्टेटेड पोजीशनिंग एक्युरेसी लेबल्स प्रत्येक मशीन टूल मॉडल के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं यदि प्रदान किए गए हों और व्यक्तिगत मशीन परीक्षणों के बजाय राष्ट्रीय प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत हों।

स्टेटेड पोजीशनिंग एक्युरेसी निम्नानुसार निकाली जाएंगी:

- (1) मूल्यांकन के लिए एक मॉडल की 5 मशीनें चुनें,
- (2) आईएसओ 230/2 (1988) के अनुसार लिनियर एक्सिज एक्युरेसीज मापें,
- (3) प्रत्येक मशीन के प्रत्येक एक्सिज के लिए एक्युरेसी वाल्व्स निर्धारित करें। आईएसओ 230/2 (1988) मानक में एक्युरेसी वैल्व्य निकालने का तरीका है।
- (4) प्रत्येक एक्सिज की औसत एक्युरेसी वैल्व्य निर्धारित करें। यह औसत मूल्य मॉडल के लिए प्रत्येक एक्सिज की स्टेटेड पोजीशनिंग एक्युरेसी बन जाता है ($\hat{A}_x, \hat{A}_y, \dots$);
- (5) चूँकि मद 4क002 प्रत्येक लीनिअर एक्सिज को प्रदर्शित करती है, जितनी लीनिअर एक्सिज होंगी उतनी ही स्टेटेड पोजीशनिंग एक्युरेसी वैल्व्यज होंगी।
- (6) यदि मदों 4क002क, 4क002ख, या 4क002ग के तहत आने वाले मशीन टूल किसी एक्सिज की ग्राइंडिंग मशीनों के लिए 6 μm या बढ़िया (कम) की या मिलिंग या टर्निंग मशीनों के लिए 8 μm या बढ़िया (कम) की स्टेटेड पोजीशनिंग एक्युरेसी, दोनों आईएसओ 230/2 (1988) के अनुसार है, तो निर्माता को प्रत्येक 18 महीने में एक्युरेसी लेबल की पुनः पुष्टि करनी होगी।

तकनीकी टिप्पणियाँ

- (1) एक्सिज नोमेनक्लेचर, अन्तर्राष्ट्रीय मानक आईएसओ 841, न्यूमेरिकल कन्ट्रोल मशीन एक्सिज और मोशन नोमेनक्लेचर के अनुसार होंगी।
- (2) कन्टूरिंग रोटरी एक्सिज की कुल संख्या में जो नहीं गिने गए हैं वे सेकन्डरी पैरलल कन्टूरिंग रोटरी एक्सेज हैं जिनकी केन्द्र लाइन प्राइमरी रोटरी एक्सेज के पैरलल हैं।
- (3) रोटरी एक्सेज को 360 डिग्री से अधिक घूमने की आवश्यकता नहीं है। एक रोटरी एक्सेज लीनिअर डिवाइस द्वारा चलाया जा सकता है जैसे एक स्कू या

	एक रैक और पिनियन।
4क003	<p>डायमेन्शनल इन्स्पेक्शन मशीनें, इन्स्ट्रूमेंट या सिस्टम, निम्नानुसारः</p> <p>(क) कम्प्यूटर कन्ट्रोल्ड या न्यूमेरिकल कन्ट्रोल्ड डायमेन्शनल इन्स्पेक्शन मशीनें जिनमें निम्नलिखित दोनों विशेषताएँ होंगी:</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) दो या अधिक एक्सिज, और (2) वन-डायमेन्शनल लैन्थ मेयरमैंट अनिश्चितता $0.2 \mu\text{m}$ से बेहतर (कम) की परिशुद्धता के परीक्षण से जांच की गई ($1.25 + \text{एल}/1000$) μm से बेहतर (कम) या बराबर (एल मिलीमीटरों में मापी गई लम्बाई है); <p>(ख) 'लिनिअर डिस्प्लेसमैन्ट' मापक संयंत्र, निम्नानुसारः</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) नॉन-कान्टैक्ट टाइप मेयरिंग सिस्टम जिसका विघटन $0.2 \mu\text{m}$ के बराबर अथवा बेहतर (कम) हो 0.2एमएम तक मेयरिंग रेज के भीतर, (2) लिनियर वेरिएबल डिफरेन्शियल ट्रान्सफार्मर (एलवीडीटी) सिस्टम जिनमें निम्नलिखित दोनों गुण होंः <p>(क) लिनियरटी 5 एमएम की मेज़रिंग रेज के भीतर 0.1 प्रतिशत के बराबर या बेहतर (कम); और</p> <p>(ख) ड्रिफ्ट स्टैन्डर्ड एम्बिएन्ट टेस्ट रूम टैम्पेरेचर ± 1 के पर 0.1 प्रतिशत प्रति दिन के बराबर या बेहतर (कम);</p> <p>(3) मेज़रिंग सिस्टम जिनमें निम्नलिखित दोनों विशेषताएँ हों-</p> <p>(क) लेजर निहित हों, और</p> <p>(ख) कम से कम 12 घण्टे, मानक तापमान और मानक दबाव पर ± 1 के तापमान रेज पर रखें</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) $0.1 \mu\text{m}$ या बेहतर के उनके सम्पूर्ण स्केल पर वियोजन (2) माप के साथ अनिश्चितता ($0.2 + \text{एल}/2000$) μm के बराबर या बेहतर (कम) (एल मिलीमीटरों में मापी गई लम्बाई है।) <p>टिप्पणी: मद 4क003ख3 के तहत मेयरिंग इन्टरफेरोमीटर सिस्टम नहीं आते, खुली अथवा बन्द लूप फीडबैक के बिना, मशीन ट्रूल्स के स्लाइड मूवमैंट दोषों</p>

को मापने के लिए लेजर निहित हो, डायमेन्शनल इन्स्पैक्शन मशीनें, या ऐसे ही उपकरण।

तकनीकी टिप्पणी: मद 4क003ख में 'लिनियर डिस्प्लेसमैन्ट' का अर्थ है मेयरिंग प्रोब और मेयरड ऑब्जेक्ट के बीच दूरी का परिवर्तन।

(ग) एन्युलर डिस्प्लेसमैन्ट मेजरिंग इन्स्ट्रुमेन्ट्स जिसमें एन्युलर पोजीशन डेविएशन 0.00025 डिग्री के बराबर अथवा बेहतर (कम)

टिप्पणी: मद 4क003ग आप्टिकल उपकरणों जैसे आटो कोलीमेटर्स को नियंत्रित नहीं करती जिनमें दर्पण के कोणीय विस्थापन की जाँच के लिए कोलीमेटिड लाइट का प्रयोग किया गया है।

घ. हेमी-शैल्स की साथ-साथ लीनियर-एग्युलर जाँच हेतु प्रक्रिया जिसमें निम्नलिखित दोनों विशेषताएँ हैं-

1. $3.5 \mu\text{m}$ प्रति 5 एमएम के बराबर या बेहतर (कम) किसी लीनियर एक्सिस सहित माप अनिश्चितता, और
2. 0.02° के बराबर या कम कोणीय स्थिति विचलन।

टिप्पणी: 1. मद 4क003 में वे मशीन औजार शामिल हैं जिन्हें माप मशीन के रूप में उपयोग किया जा सकता है और यदि वे माप मशीन कार्य हेतु निर्धारित मापदण्ड को पूरा करते हों या उससे बेहतर हों।
2. मद सं. 4क003 में वर्णित मशीनें नियंत्रित हैं यदि वे अपनी प्रचालन क्षमता के भीतर विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक हैं।

तकनीकी टिप्पणी: इस मद में माप मूल्यों के सभी मानदंड जमा/घटा, दर्शाते हैं अर्थात् कुल बैंड नहीं।

4क004	<p>कन्ट्रोल्ड एटमोसफेयर (वैक्यूम या इनर्ट गैस) इन्डक्शन फर्नेसिस, और उसकी विद्युत आपूर्ति निम्नानुसार है:</p> <p>क. भट्टियों में निम्नलिखित सभी विशेषताएँ-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 1123के (850° से.) से अधिक तापमान पर कार्य करने में समर्थ।
-------	---

2. इन्डक्शन कॉयल्स व्यास में 600 मिमी. या कम, और
3. 5 कि.वा. या अधिक विद्युत इनपुट हेतु तैयार

टिप्पणी: सेमिकन्डक्टर वेफर्स के संसाधन हेतु तैयार भट्टियों को मद 4क004क नियंत्रित नहीं करती है।

ख. मद 4क004क में विनिर्दिष्ट भट्टियों हेतु विशेष रूप से तैयार 5 कि.वा. या अधिक की विनिर्दिष्ट आउटपुट पावर सहित विद्युत आपूर्ति।

4क005	<p>'आइसोस्टेटिक प्रेसिस' और सम्बंधित उपस्कर निम्नानुसारः</p> <p>क. 5क208 में यथाविनिर्दिष्ट आइसोस्टेटिक प्रेसिसि,</p> <p>ख. मद 4क005क में विनिर्दिष्ट डाईज, मोल्ड्स और 'आइसोस्टेटिक प्रेसिस' हेतु विशेष रूप से तैयार को नियंत्रित करता है।</p>
-------	--

तकनीकी टिप्पणियाँ-

1. मद 4क005 में 'आइसोस्टेटिक प्रेसिस' का अर्थ विभिन्न माध्यमों (गैस, द्रव्य, ठोस कणों, आदि) के जरिए बन्द केविटी पर दबाव बनाने में समर्थ उपस्कर से है ताकि केविटी के भीतर कार्य सामग्री पर सभी दिशाओं में समान दबाव उत्पन्न कर सके।
2. मद 4क005 में प्रकोष्ठ का आन्तरिक परिमाण उस प्रकोष्ठ का है जिसमें दोनों कार्य तापमान और कार्य दबाव प्राप्त हो जाते हैं और इस में फिक्सर्च शामिल नहीं हैं। उक्त परिमाण या तो दबाव प्रकोष्ठ के आन्तरिक व्यास से या इन्सूलेटिड भट्टी प्रकोष्ठ के आन्तरिक व्यास से छोटा होगा यह इस पर निर्भर करता है कि दोनों प्रकोष्ठों में से वह किसके भीतर स्थित है।

4क006	<p>वाइब्रेशन टेस्ट प्रणाली उपस्कर और संघटक निम्नानुसार हैः</p> <p>क. इलेक्ट्रोडायनामिक वाइब्रेशन टेस्ट प्रणाली जिसमें निम्नलिखित सभी विशेषताएँ हैं-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. फीडबैक या क्लोज्ड लूप तकनीक को काम में लगाना और डिजीटल कन्ट्रोल यूनिट को शामिल करना; 2. 20 और 2000 हर्टज के बीच 10जी आरएमएस पर वाइब्रेशन में समर्थ; 3. 50 केएन या अधिक माप 'वेयर टेवल' प्रदान करने में समर्थ;
-------	--

ख. डिजिटल कन्ट्रोल यूनिटें, वाइब्रेशन जाँच हेतु विशेष रूप से तैयार साफ्ट बेयर सहित 5 कि.हा. से अधिक वास्तविक समय बैंड विड्थ सहित और मद 4क006क में विनिर्दिष्ट प्रणाली हेतु तैयार,

ग. वाइब्रेशन थ्रस्टर्स (शेकर यूनिटें), एसोसिएटिड एम्पलीफार्यर्स सहित या रहित, 50 केएन या अधिक माप के 'बेयर टेबल' प्रदान करने में समर्थ, जिनका मद 4क006क में विनिर्दिष्ट प्रणालियों के लिए प्रयोग किया जाता है।

घ. टेस्ट पीस स्पोर्ट स्ट्रक्चर्स और इलेक्ट्रानिक यूनिटें जिन्हें मल्टीपल शेकर यूनिटें को जोड़कर एक संपूर्ण शेकर प्रणाली बनाने के लिए तैयार किया गया है जो 50 केएन या अधिक, 'माप बेयर टेबल' की प्रभावी संर्योगत बल प्रदान करने में समर्थ है और जिनका मद 4क006क में विनिर्दिष्ट प्रणालीयों के लिए प्रयोग किया सकता है।

तकनीकी टिप्पणी: मद 4क006 में 'बेयर टेबल' का अर्थ एक बल तल या सतह से है फिक्सचर्स या फिटिंग्स रहित।

4क007 वैक्यूम या अन्य नियंत्रित एम्पोस्फेयर मेटालर्जीकल मेल्टिंग और कास्टिंग फर्नेसिस और संबंधित उपस्कर निम्नानुसारः

क. निम्नलिखित दोनों विशेषताओं वाले आर्क री-मेल्ट और कास्टिंग फर्नेसिसः

1. 1000 और 20000 से.मी.3 के बीच क्षमता के उपभोज्य इलेक्ट्रोड, और
2. 1973 के (1700° से.) से अधिक मेल्टिंग तापमान सहित संचालन में सक्षम,

ख. निम्नलिखित दोनों विशेषताओं वाले इलेक्ट्रान बीम मेल्टिंग फर्नेसिस और प्लाजमा एटोमाइजेशन और मेल्टिंग फर्नेसिस,

1. 50 के डब्ल्यू या अधिक की पावर और
2. 1473 के (1200° से.) से अधिक मेल्टिंग तापमान सहित प्रचालन में सक्षम,

ग. मद 4क007क या 4क007ख में विनिर्दिष्ट किसी भी फर्नेस हेतु विशेष रूप से समनुरूप कार्ग्यूटर नियंत्रण और निगरानी प्रणालियों।

4क008	<p>निम्नानुसार लिक्विड एस्टीनाइड मेटल्स के लिए प्रतिरोधी सामग्री से बने क्रूसीबल्स:</p> <p>क. निम्नलिखित दोनों विशेषताओं वाले क्रूसीबल्स:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 150 से.मी.3 (150 एमएल) और 8000 से.मी.3 (8ली.) के बीच वाल्यूम, और 2. भार में 98 प्रतिशत या अधिक शुद्धता वाले निम्नलिखित किसी सामग्रियों से कोटिड या बने: <p>क. कैल्सियम फ्लोराइड (सीएएफ2);</p> <p>ख. कैल्सियम जिरकोनेट (मेटाजी स्कोनेट) (सीएजेडआरओ3);</p> <p>ग. सीरियम सल्फाइड (सीई2एस3);</p> <p>घ. एरबियम आक्साइड (एरबिया) (ई आर 2 ओ 3);</p> <p>ड. हेफ्नीयम आक्साइड (हेफ्निया) (एच एफ ओ 2);</p> <p>च. मैग्नीशियम आक्साइड (एमजीओ);</p> <p>छ. नाइट्राइडेड निओबियम-टाईटेनियम-टंगस्टन अलॉय (लगभग 50 प्रतिशत एनबी, 30 प्रतिशत टीआई, 20 प्रतिशत डब्ल्यू);</p> <p>ज. यत्रीयम आक्साइड (यत्रीया) (वाई 2 ओ 3); या</p> <p>झ. जिरकोनियम आक्साइड (जिरकोनिया) (जेड आर ओ 2);</p> <p>ख. निम्नलिखित दोनों विशेषताओं वाले क्रूसीबल्स</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 50 से.मी.3 (50 एमएल) और 2000 से.मी.3 (2 ली.) के बीच वाल्यूम, और 2. भार में 99.9 प्रतिशत या अधिक शुद्धता वाले निम्नलिखित किसी सामग्रियों से कोटिड या बने: <p>ग. निम्नलिखित सभी विशेषताओं वाले क्रूसीबल्स</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 50 से.मी.3 (50 एमएल) और 2000 से.मी.3 (2 ली.) के बीच वाल्यूम, और 2. भार में 98 प्रतिशत या अधिक शुद्धता वाले निम्नलिखित किसी सामग्रियों से कोटिड या बने, 3. टेन्टेलम कार्बाइड, नाइट्राइड, बोराइड से कोटिड या उनका कोई संयोजन।
-------	---

4क009	<p>हैवी वाटर से ट्रीटियम की वसूली या हैवी वाटर के उत्पाद हेतु हाइड्रोजन और वाटर के बीच हाइड्रोजन आइसोटोप एक्सचेंज को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से बनाए गए या तैयार प्लेटीनाइज्ड कैटालिस्ट ।</p>
4क010	<p>निम्नलिखित दोनों विशेषताओं वाले ट्यूब के रूप में कम्पोजिट संरचनाएँ- क. 75 और 400 एमएम के बीच आन्तरिक व्यास के, और ख. मद 3क116 में विनिर्दिष्ट किसी भी सामग्री से बने।</p>
4क011	<p>निम्नलिखित सभी विशेषताओं वाले फ्रीक्वेन्सी चेंजर्स या जनरेटर्सः</p> <p>क. 40 वा. या अधिक की पावर उपलब्ध कराने में सक्षम मल्टीफेस आउटपुट, ख. 600 और 2000 फ्रीक्वेन्सी के बीच प्रचालन में सक्षम, ग. 10 प्रतिशत से अधिक (कम) टोटल हारमोनिक डिस्टोर्शन, और घ. 0.1 प्रतिशत से अधिक (कम) फ्रीक्वेन्सी कन्ट्रोल।</p> <p>टिप्पणी: गैस सेन्ट्रीफ्यूज प्रोसेस हेतु विशेष रूप से डिजाइन या तैयार फ्रीक्वेन्सी चेंजर्स और जनरेटर्स निर्धारित उपस्कर (0ख श्रेणी) के तहत नियंत्रित होते हैं।</p> <p>तकनीकी टिप्पणी: मद 4क011 में फ्रीक्वेन्सी चेंजर्स कन्वर्टर्स या इन्वर्टर्स से भी जाने जाते हैं।</p>
4क012	<p>निम्नलिखित लेजर्स, लेजर एम्पलीफायर्स और ओसीलेटर्सः</p> <p>क. निम्नलिखित दोनों विशेषताओं वाले कापर वेपर लेजर्सः</p> <ol style="list-style-type: none"> 500 और 600 एन.एम. वेवलैन्थ के बीच चलने वाले, और 40 वाट के समकक्ष या अधिक औसत आउटपुट पावर, <p>ख. निम्नलिखित दोनों विशेषताओं वाले एरगान ऑयन लेजर्सः</p> <ol style="list-style-type: none"> 400 और 515 एन.एम. वेवलैन्थ के बीच चलने वाले, और 40 वाट के समकक्ष या अधिक औसत आउटपुट पावर, <p>ग. निम्नलिखित में से एक 1000 और 1100 एन.एम. के बीच आउटपुट वेवलैन्थ सहित निओडाइमियम-डोप्ल (ग्लास के अलावा) लेजर्सः</p>

1. निम्नलिखित में से एक और 1 एनएस के समान या अधिक पल्स ऊरुरेशन के साथ पल्स-एक्साइटेड और क्यू- स्विच्ड:
 - क. 40 वाट से अधिक औसत आउटपुट पावर सहित एक सिंगल ट्रान्सवर्स मोड आउटपुट, या
 - ख. 50 वाट से अधिक औसत आउटपुट पावर सहित एक मल्टीपल-ट्रान्सवर्स,
 - या
2. 40 वाट से अधिक औसत आउटपुट पावर सहित 500 और 550 एन एम के बीच आउटपुट वेवलैंग्थ देने के लिए फ्रीक्वेंसी दोगुनी करने के लिए,
- घ. निम्नलिखित सभी विशेषताओं वाले ट्यूनेबल पल्सड सिंगल मोड डाइलेजर ओसीलेटर्स:
 1. 300 और 800 एनएम वेवलैंग्थ के बीच प्रचालित,
 2. 1 वाट से अधिक औसत आउटपुट पावर,
 3. 1 कि.हा. से अधिक रेपेटीशन रेट, और
 4. 100 एनएस से कम पल्स विड्थ,
- ड. निम्नलिखित सभी विशेषताओं वाले ट्यूनेबल पल्सड डाइलेजर एम्प्लीफार्यर्स और ओसीलेटर्स:
 1. 300 और 800 एनएम वेवलैंग्थ के बीच प्रचालित,
 2. 1 वाट से अधिक औसत आउटपुट पावर,
 3. 1 कि.हा. से अधिक रेपेटीशन रेट, और
 4. 100 एनएस से कम पल्स विड्थ,

टिप्पणी: मद 4क012ड. सिंगल मोड ओसीलेटर्स को नियंत्रित नहीं करती है।

च. निम्नलिखित सभी विशेषताओं वाले अलेक्जेन्ड्राइट लेजर्स:

1. 720 और 800 एनएम के बीच वेवलैंग्थ पर प्रचालित,
2. 0.005 एनएम या कम बैंडविड्थ,
3. 125 हर्टज़ से अधिक रेपेटीशन रेट, और
4. 30 वाट से अधिक औसत आउटपुट पावर,

छ. निम्नलिखित सभी विशेषताओं वाले पल्सड कार्बन डाईआक्साइड लेजर्स:-

1. 9000 और 11000 एनएम वेवलैंग्थ पर प्रचालित,

2. 250 हर्ट्ज से अधिक रेपेटीशन रेट,
 3. 500 वाट से अधिक औसत आउटपुट पावर, और
 4. 200 एनएस से कम पल्स विड्थ।

टिप्पणी: मद 4क012छ कटिंग और वेल्डिंग उपयोग हुए अधिक पावर (विशेष रूप से 1 से 5 कि. वाट) औद्योगिक सीओ2 लेजर्स क्योंकि यह लेटर लेजर्स या तो कन्टीन्यूअस वेव है या 200 एनएस से अधिक पल्स विड्थ के साथ पल्स किए हुए हैं।

ज. निम्नलिखित सभी विशेषताओं वाले पल्सड एक्जाइमर लेजर्स (एक्सईएफ, एक्सईसीआई, केआरएफ):

1. 240 और 360 एनएम वेवलैंथ पर प्रचालित,
2. 250 हर्ट्ज से अधिक रेपेटीशन रेट, और
3. 500 वाट से अधिक औसत आउटपुट पावर;

झ. पैरा-हाइड्रोजन रमन शिफ्टर्स जिन्हें 16एनएम आउटपुट वेवलैंथ पर और 250 हर्ट्ज से अधिक रेपेटीशन रेट पर चलने के लिए डिजाइन किया गया है।

4क013	<p>निम्नलिखित सभी विशेषताओं वाले वाल्व</p> <p>क. 5 मी.मी. या अधिक आकार के।</p> <p>ख. वेलोसील वाले, और</p> <p>ग. भार में 60 प्रतिशत से अधिक के निकल से पूर्णरूप से बने या एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम अलाय, निकल या निकल अलाय की लाइन के साथ।</p>
4क014	<p>तकनीकी टिप्पणी: भिन्न इन्लेट और आउटलेट व्यास में वाल्व के लिए मद 4क013क में नामिक आकार मानदण्ड छोटे से छोटे व्यास से सन्दर्भित है।</p>

4क014	<p>निम्नलिखित सभी विशेषताओं वाले सूपरकन्डकिंग सोलेनोइडल इलेक्ट्रोमेग्नेट्स:</p> <p>क. 2 टी से अधिक मेरेनेटिक फील्ड्स उत्पन्न करने में सक्षम,</p> <p>ख. आन्तरिक व्यास की लम्बाई का औसत 2 से अधिक,</p>
-------	--

ग. आन्तरिक व्यास 300 मि.मी. से अधिक, और
 घ. आन्तरिक वाल्यूम के केन्द्रीय 50 प्रतिशत से अधिक 1 प्रतिशत बेहतर
 मेग्नेटिक फील्ड यूनीफार्म।

टिप्पणी: मद 4क014 उन मैग्नेट्स को नियन्त्रित नहीं करती है जिन्हें विशेष रूप से डिजाइन किया गया है और मेडीकल न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेन्स (एनएमआर) इमेजिंग सिस्टम्स के भाग के रूप में निर्यात किया गया है ('उसके भाग का रूप' का अर्थ आवश्यक रूप से नहीं है कि समान पोतलदान में वास्तविक भाग 1 विभिन्न स्रोतों से अलग-अलग पोतलदान अनुमत हैं बशर्ते कि सम्बन्धित निर्यात दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से 'के भाग के रूप में' संबंध का उल्लेख हो)।

4क015	<p>निम्नलिखित दोनों विशेषताओं वाली हाई-वोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट पावर आपूर्तियों-</p> <p>क. 8 घंटों की समयावधि से ज्यादा में 500क या अधिक की करेन्ट आउटपुट के साथ, 100 वोल्ट या अधिक, सतत उत्पादन में समर्थ, और ख. 8 घंटों की समयावधि से ज्यादा में 0.1 प्रतिशत से बेहतर करेन्ट या वोल्टेज स्थापित्व।</p>
4क016	<p>निम्नलिखित दोनों विशेषताओं वाली हाई-वोल्टेज डाइरेक्ट करेन्ट पावर आपूर्तियों-</p> <p>क. 8 घंटों की समयावधि से ज्यादा में 1 ए या अधिक के करेन्ट आउटपुट के साथ, 20 केवी या अधिक, सतत उत्पादन में समर्थ, और ख. 8 घंटों की समयावधि से ज्यादा में 0.1 प्रतिशत से बेहतर करेन्ट या वोल्टेज स्थायित्व।</p>
4क017	<p>किसी भी समय 0 से 13 केपीए की रेज में पूर्ण दबाव को मापने में सक्षम और निम्नलिखित दोनों विशेषताओं वाले प्रेशर ट्रान्सडयूसर्सः</p> <p>क. भार में 60 प्रतिशत से अधिक निकल वाले एल्यूमीनियम, एल्यूमीनियम अलॉय, निकल या निकल अलॉय से बने या संरक्षित प्रेशर सेन्सिंग एलिमेन्ट्स; और</p>

ख. निम्नलिखित किसी एक विशेषता वाले:

1. 13 केपीए से कम का फुल स्केल और फुल स्केल के 1 प्रतिशत से \pm की बेहतर एक्यूरेसी वाले, या
2. 13 केपीए या अधिक का फुल स्केल और 130 पीए \pm की बेहतर एक्यूरेसी वाले।

तकनीकी टिप्पणियाँ-

1. मद 4क017 में प्रेशर ट्रान्सडयूसर्स वेयन्ज हैं जो प्रेशर मैजरमेन्ट को इलेक्ट्रीकल सिगनल में बदलते हैं।
2. मद 4क017 में एक्यूरेसी में शामिल है एम्बीयन्ट तापमान पर नानलीनियरिटी, हिस्टोरेसिस और रिपीटेबिलीटी।

4क018

निम्नलिखित सभी विशेषताओं वाले वैक्यूम पम्प्स:

- क. 380 मि.मी. के समक्ष या अधिक आकार के इनपुट थ्रोट,
- ख. 15 एम3/एस, के समक्ष या अधिक की पम्पिंग स्पीड, और
- ग. 13.3 एमपीए से अधिक अल्टीमेट वैक्यूम पैदा करने में सक्षम।

तकनीकी टिप्पणियाँ-

1. नाइट्रोजन गैस या वायु के साथ मैजरमेन्ट प्वाइन्ट पर पम्पिंग स्पीड निर्धारित की जाती है।
2. पम्प ब्लाकड आफ के इनपुट के साथ पम्प के इनपुट पर अल्टीमेट वैक्यूम निर्धारित किया जाता है।

4क019

प्रतिधंटा 250 ग्रा. फ्लोरीन से अधिक आउटपुट क्षमता सहित फ्लोरीन उत्पादन हेतु इलेक्ट्रोलीटिक सेल्स।

4क020

निम्नानुसार रोटर फेब्रीकेशन या असेम्बली इक्विपमेन्ट, रोटर स्ट्रेटनिंग इक्विपमेट, बेलोज-फोर्मिंग मेन्डेल्स और डाईज़:

- क. गैस सेन्ट्रीफ्यूज रोटर ट्यूब सेक्शन्स, बेफल्स और एण्ड कैप्स की असेम्बली के लिए रोटर असेम्बली इक्विपमेन्ट।

टिप्पणी: मद 4क020क में शामिल हैं प्रसीजन मेन्ड्रल्स, क्लैम्पस और श्रिन्क फिट मशीन्स।

ख. कामन एक्सिस के लिए गैस सेन्ट्रीफ्यूज रोटर ट्यूब सेक्शन्स की एलाइनमेन्ट हेतु रोटर स्ट्रेटनिंग इक्विपमेन्ट,

तकनीकी टिप्पणी: मद 4क020ख में ऐसे उपस्कर में सामान्य रूप से प्रसीजन मैजरिंग प्रोब्स आते हों जो कम्प्यूटर से जुड़े होते हैं और बाद में उसके एक्शन को नियंत्रित करते हैं, उदाहरणार्थ रोटर ट्यूब सेक्शन्स को एलाइन करने के लिए उपयोग होने वाले न्यूमेटिक रैम्स।

ग. बेलोज-फोर्मिंग मेन्ड्रेल्स और सिंगल-कन्वोल्यूशन वेलोज के उत्पादन के लिए डाइज।

तकनीकी टिप्पणी: मद 4क020ग में सन्दर्भित बेलोज में निम्नलिखित सभी विशेषताएं हैं-

1. आन्तरिक व्यास 75 और 400 मि.मी. के बीच;
2. लम्बाई 12.7 मि.मी. के बराबर या अधिक;
3. सिंगल कन्वोल्यूशन डेथ 2 मि.मी. से अधिक; और
4. आई स्ट्रेंगथ एल्यूमीनियम अलॉयज़, मरांजिंग स्टील, या हाई स्ट्रेंगथ फाइब्रस या फिलामेन्टरी मैटीरियल।

4क021	<p>निम्नानुसार सेन्ट्रीफ्यूगल मल्टी-प्लेन बैलेन्सिंग मशीन्स, फिक्सड या पोर्टेबल, होरीजोन्टल या वर्टिकल;</p> <p>क. 600 मि.मी. या अधिक की लम्बाई और निम्नलिखित सभी विशेषताओं वाले बैलेन्सिंग फ्लेक्सिबल रोटर्स के लिए डिजाइन की गई सेन्ट्रीफ्यूगल बैलेन्सिंग मशीन्स:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. स्विंग या जर्नल व्यास 75 मि.मी. से अधिक; 2. 0.9 से 23 किग्रा. की मास केपाबिलीटी; और 3. 5000 आरपीएम से अधिक रेवोल्यूशन की बैलेन्सिंग स्पीड की क्षमता।
-------	--

	<p>ख. हौलो सीलिन्ड्रिकल रोटर संघटकों के बैलेन्स के लिए डिजाइन की गई और निम्नलिखित सभी विशेषताओं वाली सेन्ट्रीफ्यूगल बैलेन्सिंग मशीन:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जरनल व्यास 75 मि.मी. से अधिक; 2. मास क्षमता 0.9 से 23 किग्रा.; 3. प्रति प्लेन 0.010 किग्रा. X मिमी./किग्रा. के बराबर या कम रेजीडयूअल इनबैलेन्स को बैलेन्स करने में समर्थ; और 4. बेल्ट ड्राइव टाइप।
4क022	<p>निम्नलिखित अनुसार फिलामेन्ट वाइन्डिंग मशीन और सम्बन्धित उपस्कर:</p> <p>क. 5क 206 में यथा विनिर्दिष्ट फिलामेंट वाइन्डिंग मशीन।</p> <p>ख. मद 4क022क में विनिर्दिष्ट फिलामेंट वाइन्डिंग मशीनों कोआडिनेटिंग और प्रोग्रामिंग कन्ट्रोल;</p> <p>ग. मद 4क022क में विनिर्दिष्ट फिलामेन्ट वाइन्डिंग मशीन के प्रेसीजन मेन्ड्रेल्स।</p>
4क023	<p>50 एम ए या अधिक टोटल आयन बीम करेन्ट उपलब्ध कराने के लिए सिंगल या मल्टीपल आयन सोर्सिस से सज्जित, के लिए डिजाइन इलेक्ट्रोमेनेटिक आइसोटोप सेपरेटर्स।</p> <p>टिप्पणियाँ-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मद 4क023 में शामिल हैं स्टेबल आइसोटोप्स के साथ-साथ यूरेनियम एनरिचिंग में सक्षम सेपरेटर्स। 2. एक सेपरेटर जो एक मास यूनिट अन्तर के साथ लेड के आइसोटोप्स को अलग करने में सक्षम है वह थ्री यूनिट मास अन्तर के साथ यूरेनियम के आइसोटोप्स एनरिच करने में सक्षम है। 3. मद 4क023 में आयन सोर्सिस सहित सेपरेटर्स और कलेक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड और कोन्फीगुरेशन्स में आने वाले दोनों शामिल हैं जिनमें वे फील्ड के लिए बाहरी हैं। <p>तकनीकी टिप्पणी: एक सिंगल 50 एमए आयन सोर्स नैचुरल एबनडेन्स फीड से प्रति वर्ष 3 ग्रा. से अधिक सेपारेटिड हाइली एनरिच्ड यूरेनियम (एचईयू) का</p>

	उत्पादन नहीं कर सकता।
4क024	<p>230 एटोमिक मास यूनिट्स या अधिक के आयन्स को मापने में सक्षम मास स्पेक्ट्रोमीटर्स और 230 में 2 भागों से अधिक रेजोल्यूशन वाले, निम्नानुसार, और उसके आयन सोर्सिसः</p> <p>क. इंडिकेटरली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमीटर्स (आईसीपी/एमएस);</p> <p>ख. ग्लो डिस्चार्ज मास स्पेक्ट्रोमीटर्स (जीडीएमएस);</p> <p>ग. थर्मल आयनाइजेशन मास स्पेक्ट्रोमीटर्स (टीआईएमएस);</p> <p>घ. इलेक्ट्रान बाम्बार्डमेट मास स्पेक्ट्रोमीटर्स जिनमें एक स्रोत चैम्बर होता है जो ऐसे पदार्थों से, जो कि यूएफ6 का प्रतिरोधी हैं बने होते हैं पंक्तिबद्ध या प्लेटिड हैं;</p> <p>ड.. मोल्यूकूलर बीम मास स्पेक्ट्रोमीटर्स जिनमें निम्न में से एक विशेषता हो-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. एक स्रोत चैम्बर जोकि स्टेनलेस स्टील या मोलीबडीनम से बना होता है, पंक्तिबद्ध होता है या प्लेटिड होता है व एक कोल्ड ट्रैप से लैस हो जो कि 193के (-80° सी.) या कम तापक्रम पर ठंडा हो सके, अथवा 2. एक स्रोत चैम्बर जोकि ऐसे पदार्थों जो कि यूएफ6 के प्रतिरोधी होते हैं से बना है, पंक्तिबद्ध होता है या प्लेटिड होता है। <p>च. मास स्पेक्ट्रोमीटर्स जो कि माइक्रो-प्लूरोनेशन ऑयन स्रोत से सुसज्जित होते हैं जिन्हें एकटीनाईड्स या एकटीनाईड फ्लूराइड्स के लिए बनाया जाता है।</p> <p>टिप्पणी- मास स्पेक्ट्रोमीटर्स जो कि विशेष रूप से यूरेनियम के ऑन-लाइन सैंपल्स के निर्धारित उपकरणों से हैक्साप्लॉराइड नियंत्रित करते हैं (0 ख वर्ग)</p>
4क025	<p>विशेषीकृत पैकिंग जो कि गुरुजल को साधारण जल से अलग करने के काम में आती है जिसमें ये दोनों गुण हो :-</p> <p>क. वेटेबिलिटी को सुधारने के लिए यह कैमिकली ट्रिटीड फॉस्फर ब्रांज मैश</p>

से बना है और
ख. वैक्यूम डिस्ट्रिलेशन टॉवर्स में प्रयोग करने के लिए डिजाईन की जाती है।

4क026	<p>उत्प्रेरकों के मध्य तरल अमोनिया (केएनएच2/एनएच3) में पम्प जो कि कंसंट्रेटिड या डायल्यूट पोटाशियम में घोलों को फैला सकते हों, में निम्न सभी विशेषताएं होनी चाहिए-</p> <p>क. एयरटाइट (अर्थात् वायुरुक्ष्म हों)</p> <p>ख. 8.5 मी3/एच से अधिक की क्षमता हो और</p> <p>ग. इनमें से कोई एक विशेषता हो;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. घोलों में कंसंट्रेटिड पोटाशियम के लिए (1 प्रतिशत या अधिक), 1.5 से 60 एमपीए का कार्यकारी दबाव, या 2. घोलों में डायल्यूट पोटाशियम के लिए (1 प्रतिशत से कम), 20 ये 60 एमपीए का कार्यकारी दबाव।
4क027	<p>टर्बो-एक्सपेंडर्स या टर्बो-एक्सपेंडर-कम्प्रेसर सैट्स में इनमें से दोनों विशेषताएं हों-</p> <p>क. 35के (-238° सी.) या कम बाहरी तापक्रम के लिए कार्य करने हेतु निर्मित, और</p> <p>ख. 1000 किग्रा./घंटा या अधिक के हाइड्रोजन गैस के थ्रूपुट के लिए निर्मित</p>
4क028	<p>वाटर हाइड्रोजन सल्फाईड एक्सचेंज ट्रे कालम्स और इन्टरनल कान्ट्रैक्टर्स, निम्नवत हैं-</p> <p>क. निम्नलिखित सभी लक्षणों वाले वाटर हाइड्रोजन सल्फाईड एक्सचेंज ट्रे कालम्स:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2 एमपीए या अधिक दबाव पर संचालित किए जा सकते हैं, 2. कार्बन स्टील से विनिर्मित जिसमें 5 या अधिक ग्रेन साईज नम्बर के आस्टेनिटिक एएसटीएम (अथवा समान मानक) है, और 3. 1.8 मी. या अधिक व्यास का। <p>ख. मद 4क028क में विनिर्दिष्ट वाटर-हाइड्रोजन सल्फाईड एक्सचेंज ट्रे कालम्स हेतु इन्टरनल कान्ट्रैक्टर्स।</p> <p>टिप्पणी: उन कालम्स के लिए जो हैवी वाटर के उत्पादन के लिए विशेष रूप</p>

से बनाए या तैयार किए गये हैं, निर्धारित उपकरण (0ख002) देखें।

तकनीकी टिप्पणी: कालम्स के इन्टरनल कान्टैक्टर्स सेगमेंटेड ट्रेज हैं जिनका प्रभावी एसेम्बल्ड व्यास 1.8 मी. या अधिक है, काउण्टर करेन्ट कान्टैक्टिंग की सुविधा देने के लिए बनाया गया है और 0.03 प्रतिशत या कम कार्बन अंश वाले स्टेनलेस स्टील से विनिर्मित हैं। ये सीवट्रेज, वाल्वट्रेज, बबल कैप ट्रेज या टर्बो ग्रिड ट्रेज हो सकती हैं।

4क029	<p>हाइड्रोजन-क्रायोजेनिक डिस्टलेशन कालम्स, जिनमें निम्नलिखित सभी लक्षण हैं-</p> <p>क. 35के (-238° सी) या कम आन्तरिक तापमान पर संचालन के लिए बनाए गये,</p> <p>ख. 0.5 से 5 एमपीए के आन्तरिक दबाव पर संचालन के लिए बनाए गये,</p> <p>ग. निम्नलिखित में से किसी एक से विनिर्मित:</p> <ol style="list-style-type: none"> कम सत्फर अंश वाले 300 शृंखला के स्टेनलेस स्टील और 5 या अधिक ग्रेन साईज नम्बर के आस्टेनिटिक एएसटीएम (या समान मानक) के साथ, अथवा समान वस्तुएं जो क्रायोजेनिक और एच2 संगत दोनों हैं और घ. 1 मी. या अधिक के आन्तरिक व्यास और 5 मी. या अधिक के प्रभावी लम्बाई के।
4क030	अमोनिया सिंथेसिस कनवर्टर्स अथवा सिंथेसिस यूनिटें जिसमें अमोनिया/हाइड्रोजन उच्च दबाव एक्वेज कालम से सिंथेसिस गैस (नाईट्रोजन और हाइड्रोजन) वापस ली गई है और सिंथेसाइज्ड अमोनिया उक्त कालम को वापस की गई है।
4ख	न्यूक्लीयर एक्सप्लोसिव प्रणाली के विकास में प्रयुक्त जाँच और माप उपकरण सहित उपकरण, एसेम्बली और संघटक।
4ख001	<p>फोटोमल्टीप्लायर ट्यूब्स जिसमें निम्नलिखित दोनों लक्षण शामिल हैं-</p> <p>क. 20 वर्ग सेमी. से अधिक क्षेत्रफल के फोटोकैथोड और</p>

ख. 1 एनएस से कम एनोडपल्स राइज टाईम।

4ख002 फ्लैश एक्स-रे जनरेटर्स अथवा पल्स्ड इलेक्ट्रान एक्सीलरेटर्स जिनमें निम्नलिखित समूह लक्षण मौजूद हैं-

क. 500 केर्ड्वी या अधिक किन्तु 25 एमईवी से कम के एक्सीलरेटर पीक इलेक्ट्रान एनर्जी, और

ख. 0.25 या अधिक के मेरिट (के) आँकड़े के साथ अथवा

क. 25 एमईवी या अधिक के एक्सीलरेटर पीक इलेक्ट्रान एनर्जी और

ख. 50 एम डब्ल्यू से अधिक पीक पावर।

टिप्पणी: मद 4ख002 उन एक्सीलरेटर्स को नियन्त्रित नहीं करता जो इलेक्ट्रान बीम या एक्स-रे रेडिएशन (इलेक्ट्रान माइक्रोस्कापी, उदाहरणार्थ) से अलग प्रयोजन के लिए तैयार प्रणाली के संघटक भाग हैं और जो चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए भी नहीं तैयार किए गये हैं।

तकनीकी टिप्पिणियां-

- मेरिट के का आँकड़ा के $= 1.7 \times 10^3$ वी2. 65 क्यू पारिभाषित है। वी मिलियन इलेक्ट्रान वोल्ट्स में पीक इलेक्ट्रान एनर्जी है। यदि एक्सीलरेटर बीम पल्स ड्यूरेशन 1 माइक्रो सेकेण्ड के बराबर या उससे कम है, तो क्यू कुल एक्सीलरेटेड आवेश है कूलम्ब में। यदि एक्सीलरेटर बीम पल्स ड्यूरेशन 1 माइक्रोसेकेण्ड से अधिक है तो क्यू अधिकतम एक्सीलरेटर आवेश 1 माइक्रोसेकेण्ड में है क्यू बराबर है। 1 माइक्रोसेकेण्ड से कम पर टी के सापेक्ष में आई का समाकलन अथवा बीम पल्स का टाईम ड्यूरेशन (क्यू = आईडीटी) जहाँ आई एम्पीयर्स में बीम करेन्ट और टी सेकण्ड्स में समय है।
- पीक पावर = (वोल्ट्स में पीक पोटेंशियल) \times (एम्पीयर्स में पीक बीम करेन्ट)
- माइक्रोवेव एक्सीलरेटिंग कैविटीज पर आधारित मशीनों में बीम पल्स का टाइम ड्यूरेशन, 1 माइक्रोसेकेण्ड या एक माइक्रोवेव माइलेटर पल्स के परिणामतः बन्द बीम पैकेट के ड्यूरेशन में से कम वाला है।
- माइक्रोवेव एक्सीलरेटिंग कैविटीज पर आधारित मशानों में, पीक बीम

	करेन्ट बन्ड बीम पैकेट के टाईम ड्यूरेशन में औसत करेन्ट है।
4ख003	प्रक्षेपास्त्रों को 2 किमी/सेकण्ड या अधिक का त्वरण देने में समर्थ मल्टीस्टेज लाईट गैस गन्स अथवा अन्य उच्चवेग गन प्रणाली (कॉयल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और इलेक्ट्रोथर्मल प्रकार के और अन्य अग्रवर्ती प्रणालियाँ)
4ख004	<p>निम्नवत मेकेनिकल रोटेटिंग मिरर कैमरे और उनके विशेष तौर पर तैयार संघटक:-</p> <p>क. 225000 फ्रेम्स प्रति सेकण्ड से ज्यादा रिकार्डिंग दर के फ्रेमिंग कैमरे, ख. 0.5 मिमी./माइक्रोसेकण्ड से ज्यादा राइटिंग स्पीड के स्ट्रीक कैमरे।</p> <p>टिप्पणी: मद 4ख004 में इन कैमरों के संघटकों में उनके सिंक्रोनाइजिंग इलेक्ट्रानिक्स यूनिटें और रोटर एसेम्बलीज शामिल हैं जो टर्बाइन्स, मिरर्स और बीयरिंग्स से बनी हैं।</p>
4ख005	<p>इलेक्ट्रानिक स्ट्रीक कैमरे, इलेक्ट्रानिक फ्रेमिंग कैमरे, ट्यूब्स और डिवाइसेज निम्नानुसार हैं-</p> <p>क. 50 एनएस या कम टाइम रिजोल्यूसन के योग्य इलेक्ट्रानिक स्ट्रीक कैमरे। ख. मद 4ख005क में विनिर्दिष्ट कैमरों हेतु स्ट्रीक ट्यूब्स, ग. 50 एनएस या कम फ्रेम एक्सपोजर टाईम के योग्य इलेक्ट्रानिक (या इलेक्ट्रानिकली शार्ट्ड) फ्रेमिंग कैमरे। घ. मद 4ख005ग में विनिर्दिष्ट कैमरों के साथ प्रयोग के लिए फ्रेमिंग ट्यूब्स और सालिड स्टेट इमेजिंग डिवाइसेज, निम्नानुसार:-</p> <ol style="list-style-type: none"> प्राक्सीमिटी फोकरड इमेज इन्टेन्सीफायर ट्यूब्स जिसमें फोटो कैथोड रेसिस्टैन्स कम करने के लिए द्रान्सपेरेण्ट कंडक्टिव कोटिंग पर फोटोकैथोड का लेप किया गया है। गेट सिलिकान इंटेन्सीफायर टार्गेट (एसआईटी) विडिकान ट्यूब्स जहाँ तीव्र प्रणाली फोटो कैथोड से फोटोइलेक्ट्रान का गैटिंग अनुमत करती है, इससे पहले कि एसआईटी प्लेट पर ये अतिक्रमण करती हों। केर अथवा पाकेल्स सेल इलेक्ट्रो-आप्टिकल शटरिंग, अन्य फ्रेमिंग ट्यूब्स और सालिड स्टेट इमेजिंग डिवाइसेज जिनका

	50 एन एस से कम फास्ट इमेज गैटिंग टाईम है और मद 4ख005ग में विनिर्दिष्ट कैमरों हेतु विशेष तौर पर बनाए गये हैं।
4ख006	<p>हाइड्रोडायनामिक प्रयोगों हेतु स्पेशलाइज्ड इन्स्ट्रुमेन्टेशन निम्नानुसार है-</p> <p>क. 10 माइक्रोसेकण्ड से कम समयान्तर के दौरान 1 किमी/सेकण्ड से ज्यादा वेग के माप हेतु वेलासिटी इण्टर फेरोमीटर्स,</p> <p>ख. 10 जी पास्कल से अधिक दबाव हेतु मैंजानिन गेजेज,</p> <p>ग. 10 जी पास्कल से अधिक दबाव हेतु क्वार्ट्ज प्रेशर ट्रान्सड्यूसर्स।</p> <p>टिप्पणी: मद 4ख006क में विसार्स (किसी भी रिफ्लेक्टर के लिए वेलासिटी इन्टरफेरोमीटर प्रणाली) और डीएलआई (डाप्लर लेजर इण्टरफेरोमीटर्स) जैसे वेलासिटी इण्टरफेरोमीटर्स शामिल हैं।</p>
4ख007	<p>हाई स्पीड पल्स जनरेटर्स जिसमें निम्नलिखित दोनों लक्षण हैं-</p> <p>क. 55 ओम् से कम रेसिस्टिव लोड में 6 वोल्ट से अधिक आउटपुट वोल्टेज।</p> <p>ख. 500 पीएस से कम 'पल्स ट्रांजिशन टाईम'।</p> <p>तकनीकी टिप्पणी: मद 4ख007ख में 'पल्स ट्रांजिशन टाईम' 10 प्रतिशत और 90 प्रतिशत वोल्टेज एम्पिलीट्यूड के बीच समयान्तर के रूप से पारिभाषित किया गया है।</p>
4ख008	<p>डिटोनेटर्स और मल्टी प्वाइट इनिसिएशन सिस्टम, निम्नानुसार:-</p> <p>क. इलेक्ट्रिकली ड्रिवेन एक्सप्लोसिव डिटोनेटर्स निम्नानुसार:</p> <ol style="list-style-type: none"> एक्सप्लोडिंग ब्रिज (ईबी) एक्सप्लोडिंग ब्रिज वायर (ईबीडब्ल्यू) स्लैपर एक्सप्लोडिंग फायल इनिसियेटर्स (ईएफआई) <p>ख. 2.5 माइक्रोसेकण्ड से कम की सतह पर फैली इनिसिएशन टाइमिंग से सिंगल फायरिंग सिग्नल से 5000 वर्ग मिमी. से अधिक क्षेत्रफल में फैले</p>

लगभग एक साथ विस्फोटक सतह को इनिसिएट करने के लिए तैयार सिंगल अथवा मल्टीपल डिटोनेटर्स की व्यवस्था।

टिप्पणी: मद ख008 केवल प्राथमिक विस्फोटकों जैसे लेड एजाईड को नियंत्रित नहीं करता है।

तकनीकी टिप्पणी: मद 4ख008 में संबंधित डेटोनेटर्स एक छोटे इलेक्ट्रिकल कंडक्टर (ब्रिज, ब्रिज वायर अथवा फायल) का प्रयोग करेगा जो इसमें से तेज हाई करेन्ट इलेक्ट्रिकल पल्स गुजारने पर विस्फोटक रूप में वाष्पीकृत हो जाता है। नान स्लैपर किस्म में एक्सप्लोडिंग कंडक्टर पीईटीएन (पेन्टा इरिथ्रिटालट्रेनिंग्रेट) जैसे कान्टैक्टिंग हाई एक्सप्लोसिव मैटेरियल में रसायनिक डेटोनेशन शुरू कर देता है। स्लैपर डेटोनेटर्स में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का विस्फोटक वाष्पीकरण अन्तराल के सिरे पर एक फ्लायर या स्लैपर पैदा करता है और विस्फोटक पर स्लैपर का प्रभाव रसायनिक डेटोनेशन की शुरूआत कर देता है। कुछ डिजाइन्स में स्लैपर चुम्बकीय बल से प्रभावित होता है। एक्सप्लोडिंग फायल डेटोनेटर या तो एक ईबी अथवा एक स्लैपर टाईप डेटोनेटर का उल्लेख करता है। इनिसियेटर शब्द कभी-कभी डेटोनेटर शब्द के स्थान पर भी प्रयोग होता है।

4ख009 फायरिंग सेट्स और समान हाई करेन्ट पल्स जनरेटर निम्नानुसार हैं-

- क. एक्सप्लोसिव डेटोनेटर फायरिंग सेट जो उपर्युक्त मद 4ख008 द्वारा विनिर्दिष्ट मल्टीपल कन्ट्रोल्ड डेटोनेटर्स को चलाने के लिए बनाया गया है।
- ख. माडुलर इलेक्ट्रिकल पल्स जनरेटर्स(पल्सर्स) जिसमें निम्नलिखित सभी लक्षण मौजूद हैं-
 1. पोर्टबल, मोबाईल अथवा रगेडाईज्ड-प्रयोग हेतु बनाया हुआ।
 2. डस्ट टाईट इनक्लोजर में बन्द
 3. 15 माइक्रोसेकण्ड से कम में उनकी ऊर्जा प्रदान करने के योग्य,
 4. 100 ए से अधिक आउटपुट वाले,
 5. 40 ओम से कम लोड में 10 माइक्रो सेकण्ड से कम 'राइज

टाइम' वाले,

6. 25.4 सेमी. से अधिक कोई माप नहीं,
7. 25 किग्रा. से कम भार, और
8. 223° से 373° के (-50° सी से 100° सी) के विस्तारित ताप सीमा पर संचालन के लिए विनिर्दिष्ट अथवा ऐरोस्पेस इस्तेमाल हेतु यथोचित विनिर्दिष्ट।

टिप्पणी: मद4ख009ख में जिनान फ्लैशलैम्प ड्राइवर सहित।

तकनीकी टिप्पणी: 4ख009ख5 मद में 'राइज टाइम' को 10 प्रतिशत से 90 प्रतिशत की करंट एम्पलीट्यूड के मय अन्तराल के रूप में पारिभाषित किया गया है जिस्टिव लोड ड्राइव हो रहा हो।

4ख010 स्विचिंग यंत्र निम्नानुसार हैं-

क. कोल्ड केथोड ट्यूब्स, चाहे गैस भरी हो अथवा नहीं, स्पार्क गैस की तरह संचालित, जिसमें निम्नलिखित गुण होः

1. तीन या अधिक इलेक्ट्रोड्स हों,
2. 2.5 कि. वोल्ट अथवा अधिक की एनोड पीक वोल्टेज रेटिंग,
3. 100ए अथवा अधिक की एनोड पीक करंट रेटिंग, और
4. 10 माइक्रो सेकेण्ड अथवा कम एनोड डिले टाइम,

टिप्पणी: गैस क्रिट्रोन ट्यूब्स और वैक्यूम स्प्राइट्रान ट्यूब्स सहित मद 4ख010क

ख. ट्रिगर्ड स्पार्क-गैप्स जिसमें दोनों निम्नलिखित गुण हों-

1. 15 माइक्रो सेकेण्ड अथवा कम का एनोड डिले टाइम,

2. 500ए अथवा अधिक के पीक करंट के लिए रेटेड,

ग. फास्ट स्विचिंग क्रिया के साथ माउंच्यूल्स अथवा असेम्बलीज जिसमें सभी निम्नलिखित गुण हों-

1. 2 कि. वोल्ट से अधिक एनोड पीक वोल्टेज रेटिंग,

2. 500ए या अधिक एनोड पीक करंट रेटिंग, और

	3. 1 माइक्रो सेकेण्ड या कम का टर्न-आन टाइम।
4ख011	<p>पल्स डिस्चार्ज कैपेसिटर जिसमें निम्नलिखित में कोई एक गुणों का सेट हो:</p> <p>क. 1. 1.4 कि.वोल्ट से अधिक वोल्टेज रेटिंग, 2. 10 जूल से अधिक ऊर्जा स्टोरेज, 3. 0.5 माइक्रो एफ से अधिक कैपेसिटेस, और 4. 50 एनएच से कम सीरीज इंडक्टेस, अथवा</p> <p>ख. 1. 750 वोल्ट से अधिक वोल्टेज रेटिंग, 2. 0.25 माइक्रो एफ से अधिक कैपेसिटेस, और 3. 10 एनएच से कम सीरीज इंडक्टेस।</p>
4ख012	<p>न्यूट्रान जनरेटर सिस्टम, ट्यूबस सहित, जिसमें निम्नलिखित दोनों गुण हों-</p> <p>क. बिना एक्सटर्नल वैक्यूम सिस्टम के बिना आपरेशन के लिए डिजाइन किया हुआ, और</p> <p>ख. ट्रिटियम-ज्यूटीरियम न्यूक्लियर रिएक्शन को प्रेरित करने हेतु इलेक्ट्रोस्टेटिक एक्सीलरेशन को प्रयोग करना।</p>
4ग.	<p>प्रौद्योगिकी</p> <p>4क और 4ख की मदों के विकास, उत्पादन अथवा प्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी।</p>

श्रेणी 5	एरोस्पेस सिस्टम्स, उत्पादन और टेस्ट इक्विपमेंट सहित इक्विपमेंट, संबद्ध प्रौद्योगिकी और विशेष रूप से डिजाइन किए गए उनके संघटक और अनुषंगी।
5क.	राकेट सिस्टम (बैलिस्टिक मिसाइल, स्पेस लॉच वेहिकल और साउण्डिंग राकेट सहित)
5क1	सिस्टम्स
5क101	<p>मिसाइलों और राकेटों के लिए सिस्टम, जिसमें शामिल हैं:-</p> <p>क. सम्पूर्ण राकेट सिस्टम (बैलिस्टिक मिसाइल, स्पेस लॉच वेहिकल और साउण्डिंग राकेट सहित)</p> <p>ख. इंजिन सहित संपूर्ण राकेट स्टेज</p>

ग. सेटेलाइट के लिए डिजाइन की गई या संशोधित की गई लिक्विड प्रोपेलेन्ट एपोजी सहित सॉलिड या लिक्विड फ्यूल राकेट इंजिन और उनके कंट्रोल सिस्टम।

टिप्पणी: 5क101 प्लेयर के लिए जेएटीओ ईकाइयों, प्रोपल्शन यूनिटों को, डिस्प्ले फायरवर्क के लिए इंजेक्शन सीटों, इमर्जेन्सी इस्केप इकिविपमेंट और राकेटों को नियंत्रित नहीं करती।

5क102 मिसाइलों और राकेटों में प्रयोग होने वाले सब-सिस्टमों और संघटकों में शामिल हैं:

- क. राकेट मोटर केसेस, इण्टीरियर लाइनिंग, इन्सुलेशन और नोजल्स,
- ख. राकेट स्टेजिंग मैकेनिज्म्स, सेपरेशन मैकेनिज्म और इण्टर-स्टेजेज,
- ग. लिक्विड और स्लरी प्रोपेलेन्ट (आक्सीडाइजर सहित), कंट्रोल सिस्टम, और उनके संघटक, वाइब्रेशन से रेजिस्टेस के लिए विशेष रूप से डिजाइन अथवा संशोधित,
- घ. री-इन्ट्री वेहकिल्स और उपकरण जिसमें शामिल हैं-
 1. हीट-शील्ड और उनके संघटक, मिट्टी से निर्मित या अपादामी पदार्थ,
 2. हीट-सिंक्स और उनके संघटक, हल्के वजन से निर्मित, उच्च हीट क्षमता-युक्त पदार्थ
 3. री-एंट्री वाहनों के लिए विशेष रूप से निर्मित इलैक्ट्रॉनिक उपकरण।
- ड. गाइडेंस सिस्टम और जायरो और इनर्सियल रेफरेन्स यूनिटों जैसे उनके संघटक,
- च. फ्लेक्सिबल नोजल जैसे थ्रस्ट वेक्टर कन्ट्रोल प्राप्त करने की विधि सहित थ्रस्ट-वेक्टर कन्ट्रोल सब सिस्टम्स, द्रव या सेकेण्डरी गैस इंजेक्शन, मूवेबल इंजिन या नोजल, इक्जास्ट गैस रस्ट्रीम (जेट वेन्स् या प्रोब्स) और थ्रस्ट टैब्स का प्रयोग,
- छ. हाइब्रिड राकेट मोटर्स और उनके संघटक,
- ज. अस्त्र-शस्त्र और वारहेड के लिए सैफिंग, आर्मिंग, फ्यूजिंग और फायरिंग प्रणाली।
- झ. राडार रेफ्लेक्टिविटी, अल्ट्रावायलेट/इन्फ्रारेड सिग्नेचर्स और एकाउस्टिंग सिग्नेचर्स जैसे रीड्यूस्ड आब्जर्वेबल्स हेतु विशेष रूप

	से बनाए गये साफ्टवेयर।
5क2	प्रोडक्सन और जॉच उपकरण,
5क201	द्रान्सोनिक, सुपरसोनिक, हाईपरसोनिक विण्ड टनल्स, गन टनल्स, ऐरोबैलिस्टिक रेन्जेस।
5क202	5क1 में प्रणालियों के संचालन हेतु बनाया गया जॉच और उत्पादन उपकरण और सुविधाएं।
5क203	पूरी राकेट प्रणाली और उपप्रणाली के लिए प्रयोग होने वाली टेस्ट बैन्चेज/स्टैण्ड्स (बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली, स्पेस लॉच वेहिकल और साउण्डिंग राकेट सहित) जिसमें सालिड या लिकिंड प्रापलेट राकेट्स, मोर्टर्स या इंजिन्स के संचालन की क्षमता है अथवा जो तीन एक्सीयल थ्रस्ट संघटकों को एक साथ मापने में समर्थ है।
5क204	डिजिटल कन्ट्रोल टेक्नीक्स और फीड बैक अथवा क्लोज्ड लूपटेस्ट उपकरण और उनके साफ्टवेयर (4क006 का संदर्भ लें) का प्रयोग करते हुए वाईब्रेशन जॉच उपकरण (वाईब्रेशन जॉच प्रणाली और वाईब्रेशन थ्रस्टर्स) और संघटक।
5क205	<p>फ्लो-फोर्मिंग मशीन्स और उनके विशेष तौर से तैयार संघटक जो विनिर्माता तकनीकी विशिष्टीकरण के अनुसार:-</p> <ol style="list-style-type: none"> सुपुर्दगी पर ऐसी यूनिटों से सुसज्जित न होने पर भी न्यूमेरिकल कन्ट्रोल यूनिट्स या कम्प्यूटर कन्ट्रोल के साथ सुसज्जित की जा सकती है और दो अक्षों से अधिक हैं जो कन्ट्रूरिंग कन्ट्रोल के लिए एक साथ समन्वित की जा सकती है। <p>टिप्पणी: मद 5क205 में वे मशीनें शामिल हैं जो मेटल और दो सहायक, रोलर्स को डीफार्म करने के लिए बनाए गये केवल सिंगल रोलर्स हैं। ये रोलर्स मैंड्रेक को सपोर्ट करते हैं किन्तु सीधे डीफार्मेशन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं।</p>
5क206	फिलामेंट वाइडिंग मशीन्स जिसके लिए पोजीशनिंग रैपिंग और वाइडिंग फाइबर्स को दो या अधिक अक्षों, उनके प्रेसीसन मैन्ड्रेलेस और कोआर्डिनेटिंग और प्रोग्रामिंग कन्ट्रोल्स में समन्वित और प्रोग्राम की जा सके।
5क207	टेपलेइंग मशीन्स जिनमें पोजीशनिंग और लेइंग टेप और शीट्स के लिए दो या अधिक अक्षों में गति का समन्वय और प्रोग्रामिंग की जा सके।

5क208	69 एमपीए से अधिक या उसके बराबर और ज्यादा अधिकतम वर्किंग प्रेशर के सभी लक्षणों वाले आइसो स्टैटिक प्रेसेस, जिसे 600° सी या अधिक नियन्त्रित थर्मल तापमान प्राप्त करने और कायम रखने के लिए बनाया गया है और 152 मिमी. या अधिक आन्तरिक व्यास के साथ चैम्बर कैविटी विद्यमान है।
5क209	15 किमी. से अधिक या बराबर ऊँचाई या- 50° और $+125^{\circ}$ से. के बीच तापमान सीमा के साथ इनवायरनमेन्टल चैम्बर्स सिमुलेटिंग वाइब्रेशन इन वायरनमेन्ट्स।
5क210	15 किमी. से अधिक या बराबर ऊँचाई या- 50° और $+125^{\circ}$ से. तापमान सीमा के साथ इनवायरनमेन्टल चैम्बर्स सिमुलेटिंग एकाउस्टिक प्रेशर लेवेल 140 डीबी अथवा अधिक या रेटेड एकाउस्टिक पावर आउटपुट 4 कि.वाट या अधिक।
5क211	एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रान्स से ब्रेस्ट्राहलग द्वारा उत्पादित एक्सीलरेटर्स डीलीवरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
5क212	पल्स्ड इलेक्ट्रान एक्सीलरेटर्स
5क213	आईएसओ 492 टालरेन्स क्लास2 अथवा उससे बेहतर के अनुसार विनिर्दिष्ट सभी टालरेन्सेज के साथ रेडियल बाल बीयरिंग्स तथा निम्नलिखित सभी लक्षणों वाले:- क. 12 और 50 मिमी. के बीच आन्तरिक रिंग बोर व्यास, ख. 25 और 100 मिमी. के बीच बाह्य रिंग व्यास, और ग. 10 और 20 मिमी. के बीच चौड़ाई।
5क214	मद 3ए3 में नियन्त्रित प्रोपेलेट्स के लिए विशेष रूप से बनाए गये लिक्विड प्रोपेलेन्ट टैंक अथवा 5क और 5ख में विनिर्दिष्ट प्रणाली प्रयुक्त होने वाले अन्य लिक्विड प्रोपेलेट।
5क215	5क101 और 5क102 हेतु उपकरण या वस्तुओं के लिए विशेष रूप से तैयार उत्पादन सुविधाएं और उत्पादन उपकरण।
5क216	3क3 में यथा सन्दर्भित लिक्विड प्रोपेलेट्स या प्रोपेलेट कान्स्चुएन्ट के उत्पादन, संचालन अथवा मंजूरी जाँच हेतु जाँच उपकरण और उसके विशेष तौर पर बनाए गये संघटक।
5क217	राकेट प्रणाली (बैलिस्टिक मिसाईल प्रणाली, स्पेस लांच वाहन और साउण्डिंग राकेट्स सहित), अनमैन्ड एअरबोर्न प्रणाली और क्रूज मिसाईल में प्रयोग होने

वाले लांच और ग्राउण्ड सहायक उपकरण और सुविधाएं जो निम्नवत हैं:-

क. परिवहन, हैण्डलिंग, कन्ट्रोल, एकिटेवेशन और प्रणाली की लॉचिंग के लिए बनाए गए रूपान्तरित उपकरण, डिवाइसेज और वेहिकल्स।

ख. ग्रेविटी मीटर्स (ग्रेवी मीटर्स), ग्रेविटी, ग्रेडियोमीटर्स और उनके विशेष रूप से तैयार संघटक, पूरे रॉकेट प्रणाली हेतु प्रयोग में आने वाली समुद्री या एअरबोर्न हेतु तथा पूरे अनमैन्ड एरियल वेहिकल प्रणाली (क्रूज मिसाइल सिस्टम टार्गेट ड्रोन्स और रेकनायसैन्स ड्रोन्स सहित) के लिए परिकल्पित या रूपान्तरित।

ग. कम्पलीट रॉकेट सिस्टम्स और कम्पलीट मानव रहित एरियल वाहन सिस्टम्स और क्रूस मिसाइलों के लिए डिजाईन्ड या मोडिफाइड ग्राउंड इकिवपमेंट सहित टेलीमेट्री और टेली-कमांड उपकरण इसमें मेन्ड एअरक्राफ्ट या सैटेलाईटों के लिए डिजाइन्ड या मोडिफाइड कंट्रोल इकिवपमेंट, टेरिस्ट्रियल या मेरिन एप्लिकेशन के लिए डिजाइन्ड या मोडिफाइड कंट्रोल ग्राउंड बेस्ड इकिवपमेंट और वाणिज्यिक, सिविल या 'जीवन सुरक्षा' (उदाहणार्थ डाटा इन्टेरिटी, उड़ान सुरक्षा) जीएनएसएस सेवाओं के लिए कंट्रोल इकिवपमेंट शामिल नहीं हैं।

घ. न्यूकलीयर प्रभाव के विरुद्ध रॉकेट सिस्टम्स, मानवरहित एरियल वाहन और क्रूस मिसाइलों की सुरक्षा में संयुक्त थर्मल और प्रेशर शॉक को रोकने के लिए बने राडोम्स (उदाहरणार्थ इलेक्ट्रो-मेनेटिक पल्स (ईएमपी), एक्स-रे, संयुक्त ब्लास्ट और थर्मल प्रभाव)।

ड. अपने उड़ान मार्ग दोरान वाहन की स्थिति का पता लगाने के लिए पोस्ट-फ्लाइट, रिकार्ड डाटा को प्रोसेस करने वाला साफ्टवेयर।

5क218	रॉकेट सिस्टम्स (बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स, स्पेस लांच ल्हीकल्स और साउंडिंग रॉकेट्स सहित), मानवरहित एअरबोर्न सिस्टम और क्रूस मिसाइल्स और इनके सब सिस्टम्स के लिए रेडार क्रास सेक्शन मेजरमेंट हेतु विशेष रूप से निर्मित सिस्टम्स।
5क3	प्रौद्योगिकी

5क301	विकास, उत्पादन, परीक्षण और 5क1 और 5क2 में मदों के प्रयोग से संबंधित प्रौद्योगिकी।
5क302	विकास, उत्पादन, परीक्षण और 5क1 और 5क2 में मदों के प्रयोग से संबंधित प्रौद्योगिकी के लिए साफ्टवेयर।
5क303	5क1 और 5क2 में निर्दिष्ट सिस्टम्स में प्रयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित एक से अधिक सब सिस्टम के कार्य को समन्वित करने वाला साफ्टवेयर।
5ख	<p>क्रूस मिसाइलों, टार्गेट ड्रोन्स और रिकोनसेन्स ड्रोन्स और इससे संबंधित इक्विपमेंट और विशेष रूप से निर्मित कम्पोनेटों सहित मानवरहित एरियल वाहन:</p> <p>क. रिमोट चालित एअर वाहनों (आरपीवी) और ऑटोनोमस प्रोग्रामेबल वाहनों सहित मानव रहित एरियल वाहन:</p> <p>ख. एसोसिएटेड लांचर्स और ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट:</p> <p>ग. कमांड और कंट्रोल के लिए सम्बद्ध इक्विपमेंट:</p> <p>घ. पूर्ण मानव रहित एरियल वाहन सिस्टम (क्रूस मिसाइल सिस्टम्स, टार्गेट ड्रोन्स और रिकोनसेन्स ड्रोन्स:</p> <p>ड. लाइट वेट टुर्बोजेट और टुर्बोफेन इंजन्स (टुर्बो कम्पाउंड इंजन्स);</p> <p>च. कम्बसटन और विशेष रूप से निर्मित कम्पोनेन्ट्स को विनियन्त्रित करने वाले उपकरणों सहित रामजेट/स्क्रामजेट/पल्स जेट/कम्बाइन्ड साइकिल इन्जन्स।</p> <p>छ. ऑटोनोमस फ्लाइट कंट्रोल और नेविगेशन क्षमता या मानव चालित डायरेक्ट विजन रैंज से नियंत्रित उड़ान क्षमता वाला पूर्ण मानवरहित एरियल वाहन सिस्टम, एरोसल डिस्पेन्सेशन को समाविष्ट करने के लिए निर्मित या विकसित तन्त्र या ऐसे वाहनों के ईंधन कम्पोनेन्ट्स के अलावा पार्टीकुलेट या तरल रूप में पेलोड के एलिमेन्ट्स को ढोने की क्षमता वाला सिस्टम।</p> <p>टिप्पणी: यह वर्ग ग्लाइडरों, हॉट एअर बेलून्स आदि जैसे अनपार्वड एअरबोर्न वाहनों को नियन्त्रित नहीं करता।</p> <p>ज. हथियारों या स्फोटक-शीर्ष के लिए सेफिंग, आर्मिंग, प्लूजिंग और फाइरिंग तन्त्र।</p>

झ. 5ख के लिए इक्विपमेंट या मटीरियल हेतु विशेष रूप से निर्मित उत्पादन सुविधाएं और उत्पादन उपकरण।

ज. 5ख के लिए निर्दिष्ट उपकरण, सामग्री या साफ्टवेयर के विकास, उत्पादन या प्रयोग हेतु प्रौद्योगिकी।

ट. 5ख के लिए निर्दिष्ट उपकरण या सामग्री के प्रयोग या विकास, उत्पादन हेतु साफ्टवेयर।

ठ. 5ख में निर्दिष्ट सिस्टम्स में प्रयोग के लिए विशेष रूप से निर्मित या विकसित एक से अधिक सबसिस्टम के समन्वय के लिए साफ्टवेयर।

5ग	रॉकेट सिस्टम्स (बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स, स्पेस लांच वाहनों और साउंड रॉकेटों सहित), मानवरहित एरियल वाहनों और क्रूस मिसाइलों में प्रयोग के लिए निर्मित या विकसित एवियानिक्स और नेविगेशन सिस्टम्स।
5ग001	गाइडेन्स सिस्टम्स और इसके उपकरण जैसे जाइरोस और इनर्शियल रेफरेंस यूनिट्स तथा विशेष रूप से निर्मित उपकरण।
5ग002	इंटेरेटेड फ्लाइट इन्स्ट्रुमेंट सिस्टम्स जिसमें जाइरोस्टेब्लाइजर्स या आटोमेटिक पाइलेट्स और इसके विशेष रूप से निर्मित उपकरण शामिल हैं।
5ग003	कम्पास (जाइरो-एस्ट्रो कम्पासों सहित), जाइरोस्कोप्स, एक्सीलेटोमीटर्स और इनर्शियल उपकरण और विशेष रूप से निर्मित साफ्टवेयर तथा विशेष रूप से निर्मित उपकरण।
5ग004	एक्सीलेरोमीटर्स या ऐसे उपकरण को समाविष्ट करने वाले सिस्टम्स का प्रयोग करने वाले इनर्शियल या अन्य उपकरण और विशेष रूप से निर्मित इन्टेरेशन साफ्टवेयर।
5ग005	एनक्रिप्टेड टेलीमेट्री सिस्टम्स, उपकरण और इसके साफ्टवेयर।
5ग006	इस सिस्टम के लिए निर्मित या विकसित फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम (सर्वो वाल्स सहित) निम्नलिखित हैः क. हाइड्रोलिक, मकैनिकल, इलैक्ट्रो-आप्टिकल या इलैक्ट्रो-मकैनिकल फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम्स (फ्लाई-बाई-वायर सिस्टम सहित) ; ख. एटिच्यूड कंट्रोल उपकरणः ग. रॉकेट सिस्टम ट्रेजेक्टरी को इष्टतम बनाने के लिए फ्लाइट कंट्रोल, गाइडेन्स और प्रोपलशन डाटा तथा फ्लाइट मेनेजमेंट सिस्टम हेतु डिजाइन प्रौद्योगिकी।

	घ. विशेष रूप से निर्मित टेरस्ट, कैलीबरेशन और इसके एलाइन्मेंट।
5ग007	इनर्शियल मेजरमेंट डिवाइस को समाविष्ट करने वाला इंटिग्रेटेड नेविगेशन सिस्टम (उदाहरण: एटिच्यूड और हैंडिंग रेफरेंस सिस्टम, इनर्शियल रेफरेंस यूनिट या इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम); सम्पूर्ण उड़ान के दौरान पोजिशन और/या वेलोसिटी को अद्यतन बनाने के लिए समय-समय पर या लगातार प्रयुक्त एक या अधिक सेन्सर (उदाहरण: सेटेलाइट नेविगेशन रिसीवर, रेडार अल्टीमीटर और/या डोप्लर रेडार); इंटिग्रेशन हार्डवेयर और साफ्टवेयर।
5ग008	5ग001-5ग004 और 5ग007 में निर्दिष्ट उपकरण के साथ योग में लाए जाने हेतु तैयार अथवा संशोधित उत्पादन उपकरण और अन्य परीक्षण, कैलिब्रेशन और अलाइनमेंट उपकरण।
5ग009	स्केटरोमीटर, रिफ्लेक्टोमीटर और प्रोफिलोमीटर जैसे उर जाइरोस और इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट (आईएमयू मोड्यूल) टेरस्टर, एमा प्लेटफार्म टेरस्टर, आईएमयू स्टेबल एलिमेंट हैंडलिंग फिक्सचर, एमा प्लेटफार्म टेरस्ट स्टेशन, जाइरो डाइनेमिक बेलेंस स्टेशन, जाइरो रन-डाइरेक्टर टेरस्ट स्टेशन, जाइरो एवाकुएशन और फिलिंग स्टेशन, जाइरो-रन बियरिंग्स के लिए सैंट्रिफ्यूज फिक्सचर, एक्सेलेरोमीटर एक्सिस अलाइन स्टेशन और एक्सेलेरोमीटर टेरस्ट स्टेशन जैसे अन्य इनर्शियल उपकरणों के लिए दर्पण की विशेषता बताने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण।
5ग010	एवायनिक उपकरण और एम्बेडिड या विशेष रूप से निर्मित साफ्टवेयर और इसके उपकरण, इसमें शामिल किन्तु सीमित नहीं- <ul style="list-style-type: none"> क. अल्टीमीटर सहित रेडार और लेजर रेडार सिस्टम; ख. इलैक्ट्रानिक एसेम्बलीज और उपकरण; ग. ब्राह्य स्ट्रोतों से इलैक्ट्रो मैग्नेटिक पल्स (ईएमपी) और इलैक्ट्रो-मैग्नेटिक इन्टरफीयरेंस (ईएमआई) हर्जाई के विरुद्ध एवियानिक और इलैक्ट्रिकल सब सिस्टम्स की सुरक्षा के लिए डिजाइन प्रौद्योगिकी। घ. इलैक्ट्रोमैग्नेटिक सोर्सेज (डायरेक्शन फाइंडिंग डिवाइसेज) या टेरेन करेक्टरस्टिक्स की बियरिंग्स के निर्धारण के लिए पेसिव सेन्सर्स। ड. ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम्स (जीएनएसएस: उदाहरणार्थ जीपीएस, जीएलओएनएसएस, जीएएलआईएलईओ) के लिए रिसीविंग उपकरण जो एअरक्राफ्ट स्पीड और आल्टीच्यूड्स या ऊपर ऑपरेट करने की क्षमता रखता हो।

	<p>च. टेरेन कोन्ट्रुर मैपिंग उपकरण, सीन मैपिंग और कोरिलेशन (डिजिटल और एनालोन दोनों) उपकरण, डोपलर नेविगेशन रेडार उपकरण, पेसिव इन्टर-फोरेमीटर उपकरण और इमेजिंग सेंसर उपकरण (एक्टिव और पैसिव दोनों)।</p> <p>छ. इलैक्ट्रोमेग्नेटिक शील्डिंग सिस्टम्स, हार्डन्ड इलैक्ट्रिकल सर्किट्स और सबसिस्टम्स के कनफिगरेशन और हार्डनिंग क्राइटेरिया के निर्धारण के लिए डिजाइन प्रौद्योगिकी।</p>
5ग011	ऑन-बोर्ड इलैक्ट्रानिक उपकरण, डिवाइज और इसका डिजाइन तथा विनिर्माण संबंधी जानकारी (वारहेड फ्यूजस, टाइमर्स और सीक्वेन्सर्स के अलावा) और एम्बेडेड या इसके लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया साफ्टवेयर।
5ग012	न्यूक्लीयर प्रभाव के विरुद्ध रॉकेट सिस्टम्स, मानवरहित एरियल वाहनों और क्रूज मिसाइलों की सुरक्षा के लिए डिजाइन्ड या विकसित डिटेक्टर्स (उदाहरणार्थ: इलैक्ट्रोमेग्नेटिक पल्स (ईएमपी), एक्स-रे, कम्बाइन्ड ब्लास्ट और थर्मल प्रभाव)।
5ग013	न्यूक्लीयर प्रभाव के विरुद्ध रॉकेट सिस्टम्स, मानवरहित एरियल वाहनों और क्रूज मिसाइलों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रेडिएशन हार्डन्ड माइक्रो सर्किट्स (उदाहरणार्थ: इलैक्ट्रो-मेग्नेटिक पल्स (ईएमपी), एक्स-रे, कम्बाइन्ड ब्लास्ट और थर्मल प्रभाव)।
5ग014	इनफ्लाइट पोजिशन और बेलोसिटी को रियलटाइम माप प्रदान करने के लिए या तो सर्फेस या एअरबोर्न रेफरेन्स या नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम्स के साथ कंजंक्शन में रॉकेट या मानव रहित एरियल वाहनों पर इन्स्टाल्ड कोड ट्रांसलेटर का प्रयोग करके प्रसीजन ट्रेकिंग सिस्टम्स: एसोसिएटेड आप्टिकल/इनफ्ररेड ट्रेकर्स और सम्बद्ध साफ्टवेयर सहित रैंज इन्स्ट्रमेंटेशन रेडार।
5ग015	रोटर्स/एसेम्बलीज को बेलेस करने और दो या अधिक हवाई जहाजों में अनबेलेस को ठीक करने वाली बेलेसिंग मशीनें।
5ग016	बेलेसिंग मशीनों के साथ इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन्ड या मोडिफाइड इन्डेक्टर हेड्स या बेलेसिंग इन्स्ट्रमेंट।
5ग017	निम्नलिखित सभी विशेषताओं वाले मोशन सिमुलेटर्स/रेट टेबल्स (सिमुलेटिंग मोशन करने वाले उपकरण); दो एक्सेज या अधिक स्लिप रिंग्स जो इलैक्ट्रिकल पावर और/या सिग्नल इन्फारेंशन ट्रांसमिट करने की क्षमता रखते

	हों।
5ग018	पोजीशन टेबल्स (किसी भी एक्सेज में प्रिसाइज रोटेरी पोजिशनिंग की क्षमता वाले उपकरण) जिनमें दो या अधिक एक्सेज हों और पोजिशन एकुरेसी बराबर या 5 आर्क सैकेप्ड से बेहतर हों।
5ग019	सेन्ट्रिफ्यूजेज जिनमें एकसीलरेशन की क्षमता हो और ट्रांसमिटिंग इलैक्ट्रिकल पावर और सिग्नल इन्फोमेशन क्षमता वाले स्लिप रिंग्स हों।
5ग020	मानव रहित एरियल वाहन सिस्टम्स के लिए डिजाइन्ड या मोडिफाइड एअर वाहन फ्यूसलेज, प्रोपल्शन सिस्टम और लिफ्टिंग कंट्रोल सर्फेसिंज के इन्टेरेशन हेतु डिजाइन प्रौद्योगिकी ताकि मानव रहित एरियल वाहन सिस्टम के फ्लाइट रिजिम के दौरान एरोडाइनेमिक परफारमेंस को अधिकतम किया जा सके।
5ग021	ट्रेजेक्टरी को इष्टतम बनाने के लिए कम्पलीट सॉकेट सिस्टम्स, मानव रहित एरियल वाहनों और क्रूज मिसाइलों के लिए डिजाइन्ड या मोडिफाइड फ्लाइट मेनेजमेंट सिस्टम के लिए फ्लाइट कंट्रोल, गाइडेंस और प्रोपल्शन डाटा के इन्टेरेशन हेतु डिजाइन प्रौद्योगिकी।
5ग022	विकास, उत्पादन या 5ग में मदों के प्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी।
5ग023	विकास, उत्पादन या 5ग में मदों के प्रयोग के लिए साफ्टवेयर।
5ग024	5ग में निर्दिष्ट सिस्टम्स में प्रयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन्ड या मोडिफाइड साफ्टवेयर।
5घ	मैन्ड-एअरक्राफ्ट, एअरो-इंजन्स, सम्बद्ध उपकरण और संघटक: टिप्पणी:- ये वर्ग विदेशी मिलिट्री एअरक्राफ्ट या मिलिट्री पंजीकरण संख्या वाले भारतीय एअरक्राफ्ट को नियंत्रित नहीं करता है।
5घ001	कम्बैट एअरक्राफ्ट और इसके लिए विशेष रूप से डिजाइन्ड कम्पोनेट्स: क. मिलिट्री रिकॉनसेन्स, एसल्ट, मिल्ट्री ट्रेनिंग, द्रान्सपोर्टेशन और एअर-ड्रोपिंग टूप्स या मिलिट्री उपकरण, लोजिस्टिक्स सपोर्ट और इसके विशेष रूप से डिजाइन्ड अवयवों सहित मिलिट्री प्रयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन्ड या मोडिफाइड अन्य एअरक्राफ्ट; ख. मिलिट्री प्रयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन्ड या मोडिफाइड एअरो-इंजन्स और इसके विशेष रूप से डिजाइन्ड कम्पोनेट्स;

ग. 5घ001क या 5घ001ख द्वारा नियंत्रित एअर क्राफ्ट या 5घ001ग द्वारा नियंत्रित एअरो-इंजन्स और विशेष रूप से डिजाइन्ड अवयवों के साथ प्रयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन्ड एअरबोर्न रिफ्यूलिंग उपकरण सहित एअरबोर्न उपकरण;

घ. प्रेशर रिफ्यूलर्स, प्रेशर रिफ्यूलिंग उपकरण, कन्फाइन्ड क्षेत्रों में संचालन सुविधा के लिए विशेष रूप से डिजाइन्ड उपकरण और 5घ 001क या 5घ001ख द्वारा नियंत्रित एअरक्राफ्ट या 5घ001ग द्वारा नियंत्रित एअरो-इंजन्स के लिए विशेष रूप से विकसित ग्राउंड उपकरण;

ड. एअरक्राफ्ट एन्टी-जी सूट्स, मिलिट्री क्रेश हेल्मेट्स में प्रयोग के लिए प्रेशराइज्ड ब्रीथिंग उपकरण और पार्श्वियल प्रेशर सूट्स और एअरक्राफ्ट या मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाले प्रोटेक्टिव मास्क्स, लिकिड आक्सीजन कन्वर्टर्स और एअरक्राफ्ट से कार्मिकों की आकस्मिक बचाव के लिए केटापुल्ट्स और कार्टिज एक्चूएटेड डिवाइस;

च. पैराशूट:

1. ड्रोपिंग बॉडिज के लिए स्टेबलाइजेशन और एटिच्यूड कंट्रोल हेतु पेराग्लाइडर्स, ड्रेग पैराशूट (उदाहरणार्थः रिकवरी केप्सूल्स, इजेक्शन सीट्स, बम्ब);
2. आकस्मिक पैराशूटों के विकास तथा इन्फ्लेशन सीवर्केस रिग्युलेशन के लिए इजेक्शन सीट सिस्टम्स के साथ प्रयोग के लिए ड्रोग पैराशूट;
3. गाइडेड मिसाइलों, ड्रोन्स या स्पेस वाहनों के लिए रिकवरी पैराशूट;
4. एप्रोच पैराशूट और लैंडिंग डिसेलरेशन पैराशूट।

छ. पैराशूट लोड्स के लिए ऑटोमेटिक पाइलेटिंग सिस्टम्स, किसी भी ऊंचाई से कंट्रोल्ड ओप्रिंग जम्प्स के लिए मिलिट्री प्रयोग हेतु विशेष रूप से डिजाइन्ड या मोडिफाइड उपकरण, आक्सीजन उपकरण सहित।

टिप्पणी 1. 5घ001ख मिलिट्री प्रयोग के लिए एअरक्राफ्ट या विशेष रूप से डिजाइन्ड इस एअरक्राफ्ट के वेरिएन्ट्स को नियंत्रित नहीं करता है जिसे:

- भारतीय नागरिक उड़डयन प्राधिकरण द्वारा नागरिक प्रयोग के लिए प्रमाणित किया गया है, और
- मिलिट्री प्रयोग के लिए समनुरूप नहीं है और मिलिट्री प्रयोग के लिए विशेष रूप से डिजाइन्ड या मोडिफाइड उपकरण या एटेचमेंट्स से फिटिड नहीं हैं।

टिप्पणी 2. मिलिट्री प्रयोग के लिए नॉन मिलिट्री मोडिफाइड एअरक्राफ्ट या एअरो इंजन्स हेतु विशेष रूप से डिजाइन्ड कम्पोनेंट्स और संबद्ध उपकरण के बारे में 5घ001ख और 5घ001ग में नियन्त्रण मिलिट्री प्रयोग के लिए मोडिफिकेशन हेतु आवश्यक इन मिलिट्री कम्पोनेंट्स और मिलिट्री से सम्बद्ध उपकरण पर लागू हैं।

5ड. माइक्रोलाइट एअर क्राफ्ट और पावर्ड 'हैंग-ग्लाइडर्स'

श्रेणी 6 (आरक्षित)

श्रेणी 7	इलैक्ट्रानिक्स, कम्प्यूटर्स और सूचना सुरक्षा सहित सूचना प्रौद्योगिकी
7क	इलैक्ट्रानिक्स
7क001	31 जीएचजेड से अधिक फ्रीक्वेंसी पर आपरेटिंग ट्यूबें, ट्रेवलिंग वेव ट्यूबें (टी डब्ल्यू टी) और फेज शिफ्टर्स और कन्टीन्यूस वेव और पल्स हाई पावर माइक्रो वेव ट्रेवलिंग वेव ट्यूब एम्पलीफार्यर्स (टी डब्ल्यू टी ए) और इसकी पावर सप्लाई सहित हाई पावर माइक्रोवेव डिवाइस।
7क002	3जीएचजेड से अधिक फ्रीक्वेंसी पर आपरेटिंग माइक्रोवेव मोनोलिथिक इन्टिग्रेटेड सर्किट्स (एमएमआईसी) और 2.5 जीएचजेड से अधिक फ्रीक्वेंसी पर आपरेटिंग सर्फेस एकोस्टिक वेव (एस ए डब्ल्यू) डिवाइस।
7क003	फेज्ड अरे एन्टिना और इनके एलिमेंट्स।
7क004	रेडियशन-हार्डन्ड माइक्रो-प्रोसेसर्स, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट अरे और सोलिड स्टेट मेमोरी डिवाइस।
7क005	माइक्रोप्रोसेसर माइक्रो सर्किट्स, माइक्रो-कम्प्यूटर माइक्रो सर्किट्स, माइक्रो कंट्रोलर माइक्रो सर्किट्स, कम्पाउंड सेमीकंडक्टर से विनिर्मित स्टोरेज इन्टेरेटेड

	<p>सर्किट्स, एनलॉग-टु-डिजिटल कंवर्टर और डिजिटल-टु-एनालॉग कंवर्टर, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड या मोड्यूल्स, सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन्ड इलैक्ट्रो आप्टिकल या आप्टिकल इन्टेरेटेड सर्किट, फील्ड प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, न्यूरल नेटवर्क इन्टेरेटेड सर्किट, कस्टम इन्टेरेटेड सर्किट, जिसके फंक्शन का पता नहीं है या उपकरण के कंट्रोल स्टेटस का पता नहीं है, जिसमें इन्टेरेटेड सर्केट का इस्तेमाल किया जायेगा, फास्ट फ्यूरियर ट्रांसफोर्म (एफएफटी), इलैक्ट्रिकल इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड-ऑनली मेमोरीज (ईईपीआरओएम), फ्लैश मेमोरीज या स्टेटिक रैम-एक्सेस मेमोरीज (एसआरएएम) जिनमें निम्नलिखित हों-</p> <p>क. 398 के (+ 125° सी) से अधिक एम्बीएंट तापमान पर आपरेशन के लिए रेटेड।</p> <p>ख. 218 के (- 55° सी) से कम एम्बीएंट तापमान पर आपरेशन के लिए रेटेड: या</p> <p>ग. 218 के (- 55° सी) से 398 के (+ 125° सी) तक एम्बीएंट तापमान रेंज पर आपरेशन के लिए रेटेड।</p>
7क006	<p>रेडिएशन-हार्डन्ड एनालॉग-टु-डिजिटल और डिजिटल-टु-एनालॉग कंवर्टर इन्टेरेटेड सर्किट:</p> <p>क. निम्नलिखित किसी भी विशेषता वाले एनालॉग-टु-डिजिटल कंवर्टर:</p> <ol style="list-style-type: none"> कुल कंवर्शन टाइम 5 एनएस से कम के साथ 8 बिट या इससे अधिक रेजोल्युशन किन्तु 12 बिट से कम; 12 बिट रेजोल्युशन, कुल कंवर्शन टाइम 200 एनएस से कम; या 12 बिट से अधिक रेजोल्युशन, कुल कंवर्शन टाइम 2 माइक्रो सैकण्ड से कम। <p>ख. डिजिटल-टु-एनालॉग कंवर्टर्स, 12 बिट या इससे अधिक रेजोल्युशन, और सेटलिंग टाइम 10 एनएस से कम।</p>
7क007	<p>थर्मल इनफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे और गामा रे स्पेक्ट्रम में आपरेटिंग डिटेक्टर यूनिट।</p>
7क008	<p>विजिबल, नीयर और थर्मल इनफ्रारेड स्पेक्ट्रम में आपरेटिंग इमेजिंग कैमरों के लिए फोकल प्लेन एसेम्बलीज।</p>

7क009	7क005 और 7क006 में निर्दिष्ट मदों के विकास, उत्पादन या प्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी।
7ख	इलैक्ट्रानिक टेस्ट इविपमेंट
7ख001	फ्रीक्वेंसी सिंथेसाइजर सिग्नल जेनरेटर-अधिकतम फ्रीक्वेंसी 31 जीएचजेड से अधिक।
7ख002	40 जीएचजेड से अधिक फ्रीक्वेंसी पर आपरेटिंग नेटवर्क एनालाइजर।
7ग	कम्प्यूटर
7ग001	<p>डिजिटल कम्प्यूटर और साफ्टवेयर:</p> <p>क. 75000 (पचहत्तर हजार) मिलियन थिओरेटिकल आपरेशन्स प्रति सैकेण्डस (एमटीओपीएस) से अधिक कम्पोजिट थिओरेटिकल परफार्मेन्स (सीटीपी) वाले डिजिटल कम्प्यूटर।</p> <p>ख. साफ्टवेयर, और/या कम्प्यूटर इन्टर-कनेक्शन स्कीम्स, (क) डिजाइन्ड दु 'पेरालेलाइज' डिजिटल कम्प्यूटर के साथ को-सप्लाइड हो या न हो (व्यक्तिगत कोई सीटीपी रेटिंग) ताकि 'पेरालेलाइज' समनुरूप द्वारा 75000 एमटीओपी से अधिक सीटीपी प्राप्त किया जा सके।</p> <p>तकनीकी टिप्पणियां-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कम्पोजिट थिओरेटिकल परफार्मेन्स (सीटीपी) रेटिंग का परिकलन इस संबंध में अलग से अधिसूचित परिकलन स्कीम के अनुसार किया जायेगा। 2. 75000 एमटीओपी या इससे कम सीटीपी रेटिंग के प्रत्येक व्यक्तिगत डिजिटल कम्प्यूटर के लिए किसी गन्तव्य या अन्तिम प्रयोक्ता के लिए निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी जबतक ऊपर (ख) के साथ इसकी आपूर्ति की गई हो। 3. डिजिटल कम्प्यूटर में शामिल हैं (1) हार्डवेर कम्प्यूटर्स इनकार्पोरेटिंग 'डिजिटल कम्प्यूटर्स' या ऊपर (क) में निर्दिष्ट, साइसोलिक अरे

	कम्प्यूटर्स, न्यूरल कम्प्यूटर्स, आप्टिकल कम्प्यूटर्स, सेक्टर प्रोसेसर्स, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स, लोजिकल प्रोसेसर्स (2) मेडिकल इमेजिंग (उदाहरणार्थ कैट स्कैनिंग) उपकरण के साथ इन्टेग्रल एडजेक्ट्स के रूप में सप्लाई के अलावा 'इमेज एन्हान्समेंट' या सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन्ड डिजिटल इलैक्ट्रॉनिक उपकरण।
7ग002	एनालॉग, डिजिटल या हार्डवर्ड कम्प्यूटर्स, डिजिटल, डिफरेनशियल एनालाइजर और प्रयोग या मॉडलिंग के लिए विशेष रूप से डिजाइन्ड साफ्टवेयर, सिमुलेशन या रॉकेट सिस्टम्स, मानव रहित एरियल वाहनों और क्रूज मिसाइलों के डिजाइन इन्टेग्रेशन।
7ग003	7ग002 में मर्दों के विकास, उत्पादन या प्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी।
7घ	सूचना सुरक्षा सहित सूचना प्रौद्योगिकी।
7घ001	साइफरिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल करके डाटा प्रोसेसिंग सुरक्षा उपकरण, डाटा सुरक्षा उपकरण और ट्रांसमीशन और सम्पर्क सेक्यूरिटी उपकरण।
7घ002	आईडेटिफिकेशन, अथेटिकेशन और किलोडर उपकरण और कि मनेजमेंट, मैनुफैक्चरिंग और वितरण उपकरण।
7ड.	(आरक्षित)

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2011

No. 38 (RE-2010)/2009-2014

S.O. 673(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 and Section 14 A of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 {FT(D&R) Act, 1992} as amended in 2010, the Central Government hereby notifies the list of specified goods, services and technologies, i.e. Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies (SCOMET) as per Annexure to this notification. Export of SCOMET items included in the Annexure shall be regulated as per conditions enumerated in the Annexure. Provisions of Chapter IV A of the FT(D&R) Act, 1992 as amended in 2010 shall apply to the goods, services and technologies specified in the Annexure.

2. Annexure to this notification will replace the existing 'Appendix 3' to Schedule- 2 of ITC (HS) Classifications of Export and Import Items, 2009-14.

3. Purpose of the notification: The FT(D&R) Act,1992 was amended in 2010. By this amendment, a new Chapter IV A has been introduced in the FT(D&R) Act,1992. It deals with controls on export of specified goods, services and technologies and empowers the Central Government to notify list of such goods, services and technologies. This notification lists the goods, services and technologies to which provisions of Chapter IV A of the FT (D&R) Act, 1992 as amended in 2010 shall apply. 'Appendix 3' to Schedule 2 of ITC (HS) Classifications of Export and Import Items, popularly known as SCOMET List, would accordingly be replaced by this list.

[F. No. 01/91/171/14/AM-11/Export Cell]

ANUP K. PUJARI, Director General of Foreign Trade
ANNEX

APPENDIX-3

Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies (SCOMET) export of which is regulated

Export of Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies (SCOMET) listed below shall be permitted only against an export licence issued in this behalf unless export is prohibited or is permitted without licence subject to fulfillment of conditions, if any, as indicated under/against any specific category or item.

Provisions of Chapter IV A of the FT(D&R) Act,1992 as amended in 2010 shall apply to the goods, services and technologies specified in the list below.

It is mandatory for all companies and their subsidiaries registered in India and all other business entities operating in India and involved in the manufacture, processing and use of Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies (SCOMET) listed below to obtain permission of the Central Government before entering into any arrangement or understanding that involves an obligation to facilitate or undertake site visits, on-site verification or access to records/ documentation, by foreign Governments or foreign third parties, either acting directly or through an Indian party or parties. Requests for such permissions shall be considered in the manner in which requests for export/import licence are considered.

Provided that where obligations involving site visits, on-site verification or access to records/ documentation by foreign governments or foreign third parties are to be undertaken pursuant to a bilateral agreement or a multilateral treaty to which India is a party, the provisions of the relevant agreement or treaty shall apply.

Exporters are advised to refer to the relevant guidelines relating to the export of SCOMET items in the Handbook of Procedures (Vol.I), as issued from time to time.

Glossary: Expressions used in the SCOMET List have the following meanings:

“Accuracy” usually measured in terms of inaccuracy, means the maximum deviation, positive or negative, of an indicated value from an accepted standard or true value.

“Active flight control systems” are systems that function to prevent undesirable “aircraft” and missile motions or structural loads by autonomously processing outputs from multiple

sensors and then providing necessary preventive commands to effect automatic control.

“Aircraft”: A fixed wing, swivel wing, rotary wing (helicopter), tilt rotor or tilt-wing airborne vehicle.

“Angular position deviation” means the maximum difference between angular position and the actual, very accurately measured angular position after the work piece mount of the table has been turned out of its initial position.

“Composite” means a “matrix” and an additional phase or additional phases consisting of particles, whiskers, fibres or any combination thereof, present for a specific purpose or purposes.

“Composite theoretical performance” (“CTP”) is a measure of computational performance given in millions of theoretical operations per second (Mtops), calculated using the aggregation of computing elements (CE).

“Contouring control” means two or more “numerically controlled” motions operating in accordance with instructions that specify the next required position and the required feed rates to that position. These feed rates are varied in relation to each other so that a desired contour is generated.

“CTP” is equivalent to “composite theoretical performance

“Designed or modified” describes equipment, parts or components which, as a result of “development,” or modification, have become endowed with specified properties that make them fit for a particular application.

“Development”: Activity related to all phases prior to “production” such as design, design research, design analysis, design concepts, assembly and testing of prototypes, pilot production schemes, design data, process of transforming design data into a product, configuration design, integration design, layouts.

“Digital computer” means equipment which can, in the form of one or more discrete variables, perform all of the following:

- a. Accept data;
- b. Store data or instructions in fixed or alterable (writable) storage devices;
- c. Process data by means of a stored sequence of instructions which is modifiable; and
- d. Provide output of data.

N.B.: Modifications of a stored sequence of instructions include replacement of fixed storage devices, but not a physical change in wiring or interconnections.

“Explosives”: Solid, liquid or gaseous substances or mixtures of substances which, in their application as primary, booster, or main charges in warheads, demolition and other applications, are required to detonate.

“Fibrous or filamentary materials” include:

- a. Continuous “monofilaments”;
- b. Continuous “yarns” and “rovings”;
- c. “Tapes”, fabrics, random mats and braids;
- d. Chopped fibres, staple fibres and coherent fibre blankets;
- e. Whiskers, either monocrystalline or polycrystalline, of any length;
- f. Aromatic polyamide pulp.

“Hybrid computer” means equipment which can perform all of the following:

- a. Accept data;
- b. Process data, in both analogue and digital representations; and
- c. Provide output of data.

“Image enhancement” means the processing of externally derived information-bearing images by algorithms such as time compression, filtering, extraction, selection, correlation, convolution or transformations between domains (e.g., fast Fourier transform or Walsh transform). This does not include algorithms using only linear or rotational transformation of a single image, such as translation, feature extraction, registration or false coloration.

“Information security” is all the means and functions ensuring the accessibility, confidentiality or integrity of information or communications, excluding the means and functions intended to safeguard against malfunctions. This includes cryptography, ‘cryptanalysis’, protection against compromising emanations and computer security.

N.B.: ‘Cryptanalysis’: analysis of a cryptographic system or its inputs and outputs to derive confidential variables or sensitive data, including clear text.

“Insulation” is applied to the components of a rocket motor, i.e. the case, nozzle, inlets, case closures, and includes cured or semi-cured compounded rubber sheet stock containing an insulating or refractory material. It may also be incorporated as stress relief boots or flaps.

“Interior lining” is suited for the bond interface between the solid propellant and the case or insulating liner. Usually a liquid polymer based dispersion of refractory or insulating materials, e.g. carbon filled hydroxyl terminated polybutadiene (HTPB) or other polymer with added curing agents sprayed or screeded over a case interior.

“Isolated live cultures” includes live cultures in dormant form and in dried preparations.

“Isostatic presses” mean equipment capable of pressurising a closed cavity through various media (gas, liquid, solid particles, etc.) to create equal pressure in all directions within the cavity upon a workpiece or material.

“Laser”: An assembly of components which produce both spatially and temporally coherent light that is amplified by stimulated emission of radiation.

“Linearity” (usually measured in terms of non-linearity) means the maximum deviation of the actual characteristic (average of upscale and downscale readings), positive or negative, from a straight line so positioned as to equalise and minimise the maximum deviations.

“Matrix” means a substantially continuous phase that fills the space between particles, whiskers or fibres.

“Measurement uncertainty” is the characteristic parameter which specifies in what range around the output value the correct value of the measurable variable lies with a confidence level of 95 %. It includes the uncorrected systematic deviations, the uncorrected backlash and the random deviations.

“Microcircuit”: A device in which a number of passive and/or active elements are considered as indivisibly associated on or within a continuous structure to perform the function of a circuit.

“Microprogrammes”: A sequence of elementary instructions maintained in a special storage, the execution of which is initiated by the introduction of its reference instruction register.

“Missiles” means complete rocket systems and unmanned aerial vehicle systems.

“Modified” in the context of “software” describes “software” which has been intentionally changed such that it has properties that make it fit for specified purposes or applications. Its properties may also make it suitable for purposes or applications other than those for which it was “modified.”

“Monofilament” or filament is the smallest increment of fibre, usually several micrometres in diameter.

“Monolithic integrated circuit” means a combination of passive or active ‘circuit elements’ or both which:

- Are formed by means of diffusion processes, implantation processes or deposition processes in or on a single semiconducting piece of material, a so-called ‘chip’;
- Can be considered as indivisibly associated; and
- Perform the function(s) of a circuit.

N.B.: ‘Circuit element’ is a single active or passive functional part of an electronic circuit, such as one diode, one transistor, one resistor, one capacitor, etc.

“Neural computer” means a computational device designed or modified to mimic the behaviour of a neuron or a collection of neurons, i.e., a computational device which is distinguished by its hardware capability to modulate the weights and numbers of the interconnections of a multiplicity of computational components based on previous data.

“Numerical control” means the automatic control of a process performed by a device that

makes use of numeric data usually introduced as the operation is in progress.

“Optical integrated circuit” means a “monolithic integrated circuit” or a hybrid integrated circuit, containing one or more parts designed to function as a photo sensor or photo emitter or to perform (an) optical or (an) electro-optical function(s).

“Precursors”: Speciality chemicals used in the manufacture of explosives.

“Pressure transducers” are devices that convert pressure measurements into an electrical signal.

“Production” means all production stages (e.g., product engineering, manufacture, integration, assembly (mounting), inspection, testing, quality assurance);

“Production equipment”: Tooling, templates, jigs, mandrels, moulds, dies, fixtures, alignment mechanisms, test equipment, other machinery and components therefor, limited to those specially designed or modified for “development” or for one or more phases of “production”.

“Production facilities”: Equipment and specially designed “software” therefor integrated into installations for “development” or for one or more phases of “production”.

“Programmes”: A sequence of instructions to carry out a process in, or convertible into, a form executable by an electronic computer.

“Propellants”: Substances or mixtures that react chemically to produce large volumes of hot gases at controlled rates to perform mechanical work.

“Public domain” means a domain that has no restrictions upon dissemination of information within or from it; the existence of any legal rights to the intellectual property in that information does not remove the information from being in “public domain”.

“Radiation hardened”: Means that the component or equipment is designed or rated to withstand radiation levels which meet or exceed a total radiation dose of 5×10^3 Gy or 5×10^5 rads (Si).

“Required”: As applied to “technology”, refers to only that portion of “technology” which is peculiarly responsible for achieving or exceeding the controlled performance levels, characteristics or functions. Such “required” “technology” may be shared by different products.

“Resolution” means the least increment of a measuring device; or on digital instruments, the least significant bit.

“Roving” is a bundle (typically 12-120) of approximately parallel ‘strands’.

N.B.: ‘Strand’ is a bundle of “monofilaments” (typically over 200) arranged approximately parallel.

“Settling time” means the time required for the output to come within one-half bit of the final value when switching between any two levels of the converter.

“Signal processing” means the processing of externally derived information-bearing signals by algorithms such as time compression, filtering, extraction, selection, correlation, convolution or transformations between domains (e.g., fast Fourier transform or Walsh transform).

“Software”: A collection of one or more “programmes”, or “micro-programmes”, fixed in any tangible medium of expression. However, unless otherwise provided for against any item on the SCOMET List, the List does not control “software” which is either in the public domain or is generally available to the public by being :

a. Sold from stock at retail selling points without restriction, by means of:

1. Over-the-counter transactions;
2. Mail order transactions; or
3. Telephone call transactions; and

b. Designed for installation by the user without further substantial support by the supplier.

“Space qualified”: Products designed, manufactured and tested to meet the special electrical, mechanical or environmental requirements for use in the launch and deployment of satellites or high altitude flight systems operating at altitudes of 100 km or higher.

“Stability” means the standard deviation (1 sigma) of the variation of a particular parameter from its calibrated value measured under stable temperature conditions. This can be expressed as a function of time.

“Specially designed” qualifies the description of equipment, parts, components or “software” which, as a result of “development”, have unique properties that distinguish them for certain predetermined purposes. For example, a piece of equipment that is “specially designed” will only be considered so if it has no other function or use. Thus a piece of manufacturing equipment that is “specially designed” to produce a certain type of component will only be considered such if it is not capable of producing other types of components.

“Tape” is a material constructed of interlaced or unidirectional “monofilaments”, ‘strands’, ‘rovings’, ‘tows’, or ‘yarns’, etc., usually preimpregnated with resin.

N.B.: ‘Strand’ is a bundle of “monofilaments” (typically over 200) arranged approximately parallel.

“Technology” means, except as otherwise provided for against any item in the SCOMET List, information (including information embodied in “software”) other than information in the “public domain”, that is capable of being used in:

- a. the development, production or use of any goods or software;
- b. the development of, or the carrying out of, an industrial or commercial activity or the

provision of a service of any kind.

Explanation: When technology is described wholly or partly by reference to the uses to which it (or the goods to which it relates) may be put, it shall include services which are provided or used, or which are capable of being used, in the development, production or use of such technology or goods.

“**Tow**” is a bundle of “monofilaments”, usually approximately parallel.

“**Toxins**” means toxins in the form of deliberately isolated preparations or mixtures, no matter how produced, other than toxins present as contaminants of other materials such as pathological specimens, crops, foodstuffs or seed stocks of “microorganisms”.

“**Unmanned Aerial Vehicle**” (“**UAV**”) means any aircraft capable of initiating flight and sustaining controlled flight and navigation without any human presence on board.

“**Usable in**,” “**usable for**,” “**usable as**” or “**capable of**” qualifies the description of equipment, parts, components, materials, technology or “software” which are suitable for a particular purpose. There is no requirement that the equipment, parts, components, technology or “software” should have been configured, modified or specified for that particular purpose. (Contrast with “specially designed” – see above).

“**Use**” includes operation; installation (including on site installation); maintenance; repair; overhaul; refurbishing.

“**Vaccine**” is a medicinal product in a pharmaceutical formulation licensed by, or having marketing or clinical trial authorisation from, the regulatory authorities of either the country of manufacture or of use, which is intended to stimulate a protective immunological response in humans or animals in order to prevent disease in those to whom or to which it is administered.

“**Yarn**” is a bundle of twisted ‘strands’.

N.B.: ‘Strand’ is a bundle of “monofilaments” (typically over 200) arranged approximately parallel.

Items on the SCOMET List are organized in the following categories.

Category 0 Nuclear materials, nuclear-related other materials, equipment and technology

- 0A Prescribed Substances
- 0A1 Source Material
- 0A2 Special Fissionable Material
- 0A3 Other Materials
- 0B Prescribed Equipment
- 0C Technology

Category 1 Toxic chemical agents and other chemicals

- 1A Prohibited chemicals
- 1B Chemicals permitted only to States party to the Chemical Weapons Convention
- 1C Chemicals permitted also to States not party to the Chemical Weapons Convention

Category 2	Micro-organisms, toxins
2A	Bacteria
2B	Fungi
2C	Parasites
2D	Viruses
2E	Rickettsials
2F	Toxins
2G	Plant pathogens
2H	Genetically Modified Organisms
Category 3	Materials, Materials Processing Equipment and related technologies
3A	Materials
3A1	Special materials
3A2	Structural materials
3A3	Rocket propellants and constituent chemicals
3A4	High explosives
3A5	Stealth materials
3B	Materials processing and production equipment, related technology and specially designed components and accessories therefor.
3C	[Reserved]
3D	Chemical and biomaterial manufacturing and handling equipment and facilities
Category 4	Nuclear-related other equipment and technology, not controlled under Category 0
4A	Equipment, assemblies, components including test and production equipment
4B	Equipment, assemblies, components including test and measurement equipment usable in development of nuclear explosive devices
4C	Technology
Category 5	Aerospace systems, equipment, including production and test equipment, related technology and specially designed components and accessories therefor.
5A	Rocket systems
5A1	Systems
5A2	Production and test equipment
5A3	Technology
5B	Unmanned aerial vehicles
5C	Avionics and navigation systems
5D	Manned-aircraft, aero-engines, related equipment and components
5E	Micro-light aircraft and powered 'hang-gliders'
Category 6	[Reserved]
Category 7	Electronics, computers, and information technology including information security
7A	Electronics
7B	Electronic test equipment
7C	Computers
7D	Information technology including information security
7E	[Reserved]

Category 0 Nuclear materials, nuclear-related other materials, equipment and technology

Note: Export of these items is regulated under the Atomic Energy Act, 1962 and rules framed, and notifications/orders issued thereunder from time-to-time by the Department of Atomic Energy. The licensing authority for items in this category is the Department of Atomic Energy. An application for licences to export prescribed equipment or/an prescribed substances shall be made in writing to the Joint Secretary, Department of Atomic Energy, Anushakti Bhavan, CSM Marg, Mumbai 400 001.

0A Prescribed Substances

Note: Any radioactive material in Category 0A shall additionally attract the provisions of Radiation Protection Rules, 2004 made under the Atomic Energy Act, 1962 and the provisions of Section-16 of the Atomic Energy Act, 1962.

0A1 Source Material

0A101 Uranium containing the mixture of isotopes occurring in nature.

0A102 Uranium depleted in the isotope 235.

0A103 Thorium.

0A104 Any of the foregoing in the form of metal, alloy, chemical compound, or concentrate or any substance.

0A105 Any other material containing one or more of the foregoing.

Prescribed quantitative limits: as given below and in any period of 12 months:

- a. Uranium (containing the mixture of isotopes in nature) exceeding 100 kilograms.
- b. Depleted uranium (uranium depleted in the isotope 235 below that occurring in nature) exceeding 1000 kilograms.
- c. Thorium exceeding 1000 kilograms.

0A2 Special Fissionable Material

0A201 Plutonium-239.

0A202 Uranium-233.

0A203 Uranium enriched in the isotopes 235 or 233.

0A204 Neptunium.

0A205 Any material containing one or more of the foregoing.

0A206 Such other fissionable material determined by the Central Government from time to time, but the term “special fissionable material” does not include source material.

Note: Any quantity of special fissionable material is prescribed substance.

0A3 Other Materials

‘Other Materials’ means non-nuclear materials for reactors, nuclear related dual-use materials indicated below and such materials as determined by the Central Government from time to time.

0A301 Deuterium, heavy water (deuterium oxide) and any other deuterium compound, in which the ratio of deuterium to hydrogen atoms exceeds 1:5000, in quantities exceeding 5 kilograms of deuterium in one consignment or 25 kilograms of deuterium in any period of 12 months.

0A302 Nuclear grade graphite / carbon, having a purity level better than 5 parts per million (ppm) boron equivalent and with a density greater than 1.5 gram/cc in quantities exceeding 30 metric tons in any period of 12 months.

0A303 Zirconium with hafnium content of less than 1 part to 500 parts of zirconium by weight (i.e. less than 2000 ppm) in the form of metal, its alloys, compounds, manufactures thereof, waste or scrap of any of the foregoing.

0A304 Beryllium, its compounds, alloys and its minerals / concentrates including Beryl but excluding:

- beryllium windows used for x-ray machines and gamma ray detectors and
- beryl in the form of emeralds or aquamarines.

0A305 Lithium enriched in the Lithium-6 (${}^6\text{Li}$) isotope to greater than its natural isotopic abundance (i.e. more than 7.5%) and the products or devices containing enriched lithium such as elemental lithium, alloys, compounds, mixtures containing lithium, manufactures thereof, waste or scrap of any of the foregoing.

0A306 Niobium and Tantalum, their metals, alloys and minerals including columbite and tantalite.

0A307 Titanium alloys having both of the following characteristics:

- ‘Capable of’ an ultimate tensile strength of 900 MPa or more at 293 K (20 degrees C); and

b. In the form of tubes or cylindrical solid forms (including forgings) with an outside diameter of more than 75 mm.

Technical note: The phrase 'capable of' encompasses titanium alloys before or after heat treatment.

0A308 Tritium, tritium compounds or mixtures containing tritium in which the ratio of tritium to hydrogen atoms exceeds 1 part in 1000, except when utilized in such quantities and for such purposes as for organic labelled compounds, Gas Filled Light Sources and as Tritiated Water for radiotracer studies.

0A309 Hafnium: (CAS 7440-58-6)

Hafnium metal, alloys containing more than 60% hafnium by weight, hafnium compounds containing more than 60% hafnium by weight, manufactures thereof, and waste or scrap of any of the foregoing.

0A310 Radium-226:

Radium-226 (226Ra), radium-226 alloys, radium-226 compounds, mixtures containing radium-226, manufactures thereof, and products or devices containing any of the foregoing, except medical applicators and a product or device containing less than 0.37 GBq (10mCi) of Ra-226 in any form.

0A311 Boron (CAS 7740-42-8)

Boron enriched in the Boron-10 (10B) isotope to greater than its natural isotopic abundance as follows:

Elemental boron, compounds, mixtures containing boron, manufactures thereof, waste or scrap of any of the foregoing.

0A312 Helium-3.

Helium-3 (3He), mixtures containing helium-3, and products or devices containing any of the foregoing.

Note: A product or device containing less than 1gm of Helium-3 is excluded.

0A313 Alpha-emitting radionuclides:

Alpha-emitting radionuclides having an alpha half-life of 10 days or greater but less than 200 years, in the following forms:

- a. Elemental;
- b. Compounds having a total alpha activity of 37 GBq per kg or greater;
- c. Mixtures having a total alpha activity of 37 GBq per kg or greater;
- d. Products or devices containing any of the foregoing.

Alpha emitters controlled by this item include:

Actinium-225	Actinium-227	Americium-242m
Californium-248	Californium-250	Californium-252
Californium-253	Californium-254	Curium-240
Curium-241	Curium-242	Curium-243
Curium-244	Einsteinium-252	Einsteinium-253
Einsteinium-254	Einsteinium-255	Fermium-257
Gadolinium-148	Mendelevium-258	Neptunium-235
Plutonium-236	Plutonium-237	Plutonium-238
Plutonium-241	Polonium-209	Polonium-210
Polonium-208	Radium-223	Thorium-228
Thorium-227	Uranium-230	Uranium-232

OB Prescribed Equipment

0B001 Nuclear Reactors; associated equipment, components, and systems specially designed, prepared, or adapted or used or intended to be used in such reactors:-

- a. Complete nuclear reactors
- b. Nuclear reactor vessels
- c. Nuclear reactor fuel charging and discharging machines
- d. Nuclear reactor control rods and equipment
- e. Nuclear reactor pressure tubes
- f. Zirconium tubes and assemblies of tubes in which hafnium to zirconium ratio is 1:500 or less
- g. Primary coolant pumps
- h. Nuclear reactor internals
- i. Heat exchangers (steam generators) for use in the primary coolant circuit of a nuclear reactor
- j. Neutron detection and measuring instruments for determining neutron flux levels within the core of a nuclear reactor.

0B002 Plants for processing, production, concentration, conversion or recovery of Prescribed Substances (such as uranium, plutonium, thorium, deuterium, heavy water, tritium, lithium); associated equipment, components and systems specially designed, prepared or adapted or used or intended to be used in such plants including but not limited to:

- a. Plants for production or concentration of deuterium, heavy water-
 - 1. Water - Hydrogen Sulphide Exchange Towers
 - 2. Blowers and Compressors for hydrogen-sulphide gas circulation
 - 3. Ammonia-Hydrogen Exchange Towers greater than or equal to 35 m in height with diameters of 1.5 m to 2.5 m
 - 4. Tower Internals and Stage Pumps
 - 5. Ammonia Crackers with operating pressures greater than or equal to 3 MPa

- 6. Infrared Absorption Analyzers capable of 'on-line' hydrogen/deuterium ratio analysis
- 7. Catalytic Burners for conversion of enriched deuterium gas into heavy water
- 8. Complete heavy water upgrade systems or columns therefor
- b. Plants for the conversion of uranium
- c. Plants for the conversion of plutonium
- d. Tritium facilities or plants, and equipment therefor
- e. Lithium isotope separation facilities or plants, and equipment therefor

OB003

Plants for reprocessing of irradiated nuclear fuel and equipment, components and systems specially designed, prepared or adapted or used or intended to be used in such plants, including but not limited to:

- a. Irradiated fuel element chopping machines designed for remote operation
- b. Dissolvers capable of withstanding hot and highly corrosive liquid for dissolution of irradiated nuclear fuel and which can be remotely loaded and maintained
- c. Solvent extractors and solvent extraction equipment resistant to the corrosive effect of nitric acid
- d. Chemical holding or storage vessels resistant to the corrosive effect of nitric acid
- e. Industrial equipment including assemblies and components as follows:
 - 1. High density (lead glass or other) radiation shielding windows
 - 2. Radiation hardened TV cameras, or lenses therefor
 - 3. 'Robots' or 'end effectors' specially designed for handling high explosives; and control units therefor
 - 4. Remote manipulators that can be used to provide remote actions in radiochemical separation operations or hot cells

OB004

Plants for treatment, handling, storage and transportation of radioactive wastes from nuclear reactors or from plants for processing Source Materials or Special Fissionable Materials or from nuclear reprocessing plants; irradiated nuclear fuel; Special Fissionable Materials, and equipment specially designed, prepared, adapted, or intended to be used therefor.

OB005

All systems, associated equipment, components for separation or enrichment of isotopes of uranium, plutonium, lithium or boron, other than analytical instruments, specially designed, prepared, adapted, used or intended to be used therefor as follows:

- a. Gas centrifuges and assemblies and components specially designed or prepared for use in gas Centrifuges
- b. Specially designed or prepared auxiliary systems, equipment and components for gas centrifuge enrichment plants
- c. Specially designed or prepared assemblies and components for use in

gaseous diffusion enrichment

- d. Specially designed or prepared auxiliary systems, equipment and components for use in gaseous diffusion enrichment
- e. Specially designed or prepared systems, equipment and components for use in aerodynamic enrichment plants
- f. Specially designed or prepared systems, equipment and components for use in chemical exchange or ion exchange enrichment plants.
- g. Specially designed or prepared systems, equipment and components for use in laser-based enrichment plants.
- h. Specially designed or prepared systems, equipment and components for use in plasma separation enrichment plants.
- i. Specially designed or prepared systems, equipment and components for use in electromagnetic enrichment plants.

0B006

Plants for the fabrication of nuclear reactor fuel elements, and equipment specially designed or prepared therefor including but not limited to:

- a. fully automatic pellet inspection stations specially designed or prepared for checking final dimensions and surface defects of the fuel pellets;
- b. automatic welding machines specially designed or prepared for welding end caps onto the fuel pins (or rods);
- c. automatic test and inspection stations specially designed or prepared for checking the integrity of completed fuel pins (or rods).

Item 'c' typically includes equipment for: 1) x-ray examination of pin (or rod) end cap welds, 2) helium leak detection from pressurized pins (or rods), and 3) gamma-ray scanning of the pins (or rods) to check for correct loading of the fuel pellets inside.

0B007

Plants or systems for production, handling, storage and transportation of Radioisotopes in quantities exceeding 100 Curies (3.7 X 10¹² Becquerel).

0B008

Neutron generators including neutron chain reacting assemblies and fusion assemblies of all kinds for producing fissile materials

0C

Technology

Technology and software for the development, production or use of prescribed substances or prescribed equipment specified in 0A or 0B.

Category 1 Toxic chemical agents and other chemicals

1A

Export of the following chemicals is prohibited:*(This corresponds to Schedule 1 to the Chemical Weapons Convention (CWC))*

Note: Where reference is made below to groups of di-alkylated chemicals, followed by a list of alkyl groups in parentheses, all chemicals possible by all possible combinations and alkyl groups listed in parentheses are considered prohibited unless explicitly exempted.

(1). O-Alky (\leq C10 , incl. cycloalkyl) alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonofluoridates

e.g. Sarin: O-Isopropyl methylphosphonofluoridate

Soman: O-Pinacolyl methylphosphonofluoridate

(2). O-Alkyl, (\leq C10, incl. cycloalkyl) N,N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidocyanides

e.g. Tabun: O-Ethyl N,N,-dimethyl phosphoramidocyanide

(3). O-Alkyl (H or \leq C10, incl. cycloalkyl) S-2-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethyl alkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphonothiolates and corresponding alkylated or protonated salts

e.g. VX: O-Ethyl S-2 diisopropylaminoethyl methyl phosphonothiolate

(4). Sulphur mustards:

2-Chloroethylchloromethylsulphide

Mustard gas: Bis (2-chloroethyl) sulphide

Bis (2-chloroethylthio) methane

Sesquimustard:1,2-Bis (2-chloroethylthio) ethane

1,3-Bis (2-chloroethylthio)-n-propane

1,4-Bis (2-chloroethylthio)-n-butane

1,5-Bis (2-chloroethylthio)-n-Pentane

Bis (2-Chloroethylthiomethyl) ether

O-Mustard: Bis (2-Chloroethylthiomethyl) ether

(5). Lewisites:

Lewisite 1: 2-Chlorovinyldichloroarsine

Lewisite 2: Bis (2-Chlorovinyl) chloroarsine

Lewisite 3: Tris (2-Chlorovinyl) arsine

(6). Nitrogen mustards:

HN1: Bis (2-chloroethyl) ethylamine

HN2: Bis (2-chloroethyl) Chloroarsine

HN3: Tris (2-chloroethyl) amine

(7). Saxitoxin

(8).Ricin

(9).Alkyl (Me, Et, n-Pr or I-Pr) phosphonyldifluorides
e.g. DF: Methyl phosphonyldifluoride

(10).O-Alkyl (H or \leq C10, incl. cycloalkyl) O-2 dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-aminoethylalkyl (Me, Et N-Pr or i-Pr) phosphonites and corresponding alkylated or protonated salts
e.g. QL: O-Ethyl O-2-diisopropylaminoethyl methyl phosphonite

(11).Chlorosarin: O-Isopropyl methylphosphonochloridate

(12).Chlorosoman: O-Pinacolyl methylphosphonochloridate

1B

Export of chemicals listed in 1B below is permitted only to States party to the Chemical Weapons Convention

(This corresponds to Schedule 2 to the Chemicals Weapons Convention)

Note to exporter:

(a) A list of States Parties can be obtained from the Disarmament & International Security Affairs Division of the Ministry of External Affairs (Room No. 40G, South Block, New Delhi) or at the official website of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons at www.opcw.org.

(b) A general permission valid for a period of two years may be applied for export of chemicals in this category. This permission shall be subject to the condition that for each export consignment, exporters shall, within 30 days of exports, notify the details to the National Authority, Chemical Weapons Convention, Cabinet Secretariat ; Ministry of External Affairs (D&ISA); Department of Chemicals and Petrochemicals and the Directorate General of Foreign Trade and submit to DGFT, a copy of Bill of Entry into the destination State Party within 30 days of delivery.

Note: Where reference is made below to groups of dialkylated chemicals, followed by a list of alkyl groups in parentheses, all chemicals possible by all possible combinations and alkyl groups listed in parentheses are included unless explicitly exempted.

1. Amiton 0,0-Diethyl S-[2-(diethylamino) ethyl] phosphorothiolate and corresponding alkylated or protonated salts
2. PFIB: 1,1,3,3,3,-Pentafluoro-2-(trifluoromethyl)1-propene
3. BZ: 3-Quinuclidinyl benzilate

4. Chemicals, except for those listed in Schedule 1, containing a phosphorus atom to which is bonded one methyl, ethyl or propyl (normal or iso) group but not further carbon atoms,
e.g. Methylphosphonyl dichloride

Dimethyl methylphosphonate

Exemption:- Fonofos: O-Ethyl S-phenyl ethylphosphonothiolothionate

5. N, N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) phosphoramidic dihalides

6. Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) N, N-dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr)-phosphoramidates

7. Arsenic trichloride

8. 2,2-Diphenyl-2 hydroxyacetic acid

9. Quinuclidine-3-ol

10. N,H-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethanes and corresponding protonated salts

11. N, N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane-2-ols and corresponding protonated salts
Exemptions: N,N-Dimethylaminoethanol and corresponding protonated salts
N,N-Diethylaminoethanol and corresponding protonated salts

12. N, N-Dialkyl (Me, Et, n-Pr or i-Pr) aminoethane-2-thiols and corresponding protonated salts

13. Thiodiglycol: Bis(2-hydroxyethyl) sulphide

14. Pinacolyl alcohol: 3,3-Dimethylbutane-2-ol

A List of commercially important Schedule-2 Chemicals of CWC is given below :

Sl. No.	Name of Chemical	Entry into Schedule	CAS (Chemical Abstract Service) Numbers	ITC(HS) codes
1.	2-Chloro N, N-Di-isopropyl ethylamine	2B10	4261-68-1	29211911
2.	Diethyl amino Ethanethiol	2B12	100-38-9	29221910

3.	O, O, Dimethyl Methyl Phosphonate	2B04	756-79-6	29209045
4.	2-Hydroxy N, N-Diisopropyl Ethylamine	2B11	96-80-0	29221111
5.	N, N-Diethyl Amino ethyl Chloride Hydrochloride	2B10	869-24-9	29221112
6.	Di-ethyl Amino ethanethiol Hydrochloride	2B12	1942-52-5	29221113
7.	Di-Methyl Amino ethyl chloride Hydrochloride	2B10	4584-46-7	29221114
8.	Di-Methyl Amino ethanethiol	2B12	108-02-1	29221115
9.	Di-Methyl Amino ethanethiol Hydrochloride	2B12	13242-44-9	29221116
10.	Phosphorothioic acid, S [2-(diethylamino) ethyl] O, O – diethyl ester	2A01	78-53-5	29201910
11.	1-Propene, 1,1, 3, 3, 3, - Pentafluoro – 2- (trifluoromethyl) (PFIB)	2A02	382-21-8	29033911
12.	Benzeneacetic acid, alphahydroxy – alpha-phenyl, 1 – azabicyclo [2.2.2.] oct-3-yl ester	2A03	6581-06-2	29392050
13.	Phosphonic Acid, Methyl-compound with (aminoimino methyl) urea (1: 1)	2B04	84402-58-4	29209047
14.	1-Propanaminium N, N, N-trimethyl – 3- [1-oxo-9 octadecenyl] amino]-. (Z)-methyl methylphosphonate	2B04	70055-71-9	29209048
15.	Phosphonic acid, [methyl bis (5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1, 3, 2-dioxaphosphorinan-5-yl) methyl] ester	2B04	42595-45-9	29209051
16.	Phosphonic acid, [methyl-(5-ethyl-2-methyl 2-oxido-1,3,2-dioxaphosphorinan-5-yl) methyl] ester	2B04	41203-81-0	29209052
17.	Phosphonic acid, propyl-dimethyl ester	2B04	18755-43-6	29209053
18.	Phosphonous acid, methyl-diethyl ester	2B04	15715-41-0	29209054
19.	Phosphonic acid, ethyl-	2B04	6779-09-5	29209055
20.	Phosphonic acid, propyl-	2B04	4672-38-2	29209056
21.	Phosphinic acid, methyl-	2B04	4206-94-4	29209057
22.	Phosphonochloridic acid, methyl-, methyl ester	2B04	1066-52-0	29209058
23.	Phosphonothioic dichloride, ethyl-	2B04	993-43-1	29209061
24.	Phosphonic acid methyl-	2B04	993-13-5	29209062
25.	Phosphonic acid, methyl-, dimethyl ester	2B04	756-79-6	29209063
26.	Phosphonic dichloride, methyl-	2B04	676-97-1	29209064
27.	Phosphonous dichloride, methyl-	2B04	676-83-5	29209065
28.	Phosphonic acid, ethyl-, diethyl ester	2B04	78-38-6	29209066
29.	Arsenous trichloride	2B07	7784-34-1	28121060
30.	Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-	2B08	76-93-7	29181910

	alpha-phenyl			
31.	1-Azabicyclo (2.2.2.) octan-3-ol	2B09	1619-34-7	29333930
32.	Ethanamine, 2-Chloro-N, N-dimethyl-	2B10	107-99-3	29211914
33.	Ethanol, 2-[bis(1-methylethyl) amino]-	2B11	96-80-0	29221920
34.	Ethanethiol, 2-(diethylamino)-	2B12	100-38-9	29221930
35.	Ethanol, 2, 2'-thiobis-	2B13	111-48-8	29309091
36.	2-Butanol, 3, 3-dimethyl-	2B14	464-07-3	29051910

1C **Export of Chemicals as specified below is allowed to State Parties to the CWC without an export licence subject to the condition that the exporter shall notify within 30 days of export to the National Authority, Chemicals Weapons Convention, Cabinet Secretariat; the Ministry of External Affairs (D&ISA); the Department of Chemicals & Petrochemicals, and the DGFT of such exports in the prescribed format (Aayat Niryat Form) along with the End-Use Certificate and submit to the DGFT a copy of the bill of entry into the destination State Party within 30 days of delivery. Export of chemicals as specified below to states not party to the Chemical Weapons Convention shall continue to be restricted and will be allowed only against an export licence, and in that case also exporters shall submit to the DGFT a copy of the bill of entry into the destination country within 30 days of export.**

Sl.No.	Name of Chemical	Entry into Schedule	CAS Numbers	ITC (HS) codes
1.	Phosgene : (Carbonyl dichloride)	3A01	75-44-5	28121010
2.	Cyanogen chloride [(CN) C1]	3A02	506-77-4	28530091
3.	Hydrocyanic acid	3A03	74-90-8	28111910
4.	Chloropicrin: Trichloronitro-Methane	3A04	76-06-2	29049080
5.	Phosphorus Oxychloride	3B05	10025-87-3	28121030
6.	Phosphorus trichloride	3B06	7719-12-2	28121021
7.	Phosphorous Pentachloride	3B07	10026-13-8	28121022
8.	Trimethyl Phosphite	3B08	121-45-9	29209041
9.	Triethyl Phosphite	3B09	122-52-1	29209042
10.	Dimethyl Phosphite	3B10	868-85-9	29209043
11.	Diethyl Phosphite	3B11	762-04-9	29209044
12.	Sulphur monochloride	3B12	10025-67-9	28121042
13.	Sulphur dichloride	3B13	10545-99-0	28121043
14.	Thionyl Chloride	3B14	7719-09-7	28121047
15.	Ethyldiethanolamine	3B15	139-87-7	29221211
16.	Methyldiethanolamine	3B16	105-59-9	29221212
17.	Triethanolamine	3B17	102-71-6	29221300

Category 2 Micro-organisms, toxins

2A **Bacteria, whether natural, enhanced or modified, either in the form of**

isolated live cultures or as material including living material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures for the following:

2A001	Bacillus anthracis
2A002	Bordetella bronchiseptica
2A003	Brucella abortus,
2A004	Brucella melitensis
2A005	Brucella suis
2A006	Chlamydia psittaci
2A007	Clostridium botulinum
2A008	Clostridium perfringens
2A009	Corynebacterium diphtheriae
2A010	Francisella tularensis
2A011	Klebsiella pneumoniae
2A012	Legionella pneumophila
2A013	Leptospira interrogans - all serotypes reported in India
2A014	Mycobacterium bovis
2A015	Mycobacterium tuberculosis
2A016	Mycoplasma mycoides - var mycoides
2A017	Mycoplasma mycoides - var Capri
2A018	Neisseria meningitidis
2A019	Pseudoturella multicoda type B
2A020	Pseudomonas mallei
2A021	Pseudomonas pseudomallei
2A022	Salmonella paratyphi
2A023	Shigella dysenteriae
2A024	Staphylococcus aureus
2A025	Streptococcus pneumoniae
2A026	Vibrio cholerae elter
2A027	Vibrio Cholerae 0139
2A028	Yersinia pestis

2B Fungi, whether natural, enhanced or modified, either in the form of isolated live cultures or as material including living material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures for the following:

2B001	Blastomyces dermatitidis
2B002	Coccidioides immitis
2B003	Histoplasma capsulatum
2B004	Nocardia asteroides
2B005	Paracoccidioides brasiliensis

2C Parasites, whether natural, enhanced or modified, either in the form of isolated live cultures or as material including living material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures

for the following:

- 2C001** Entamoeba histolytica
- 2C002** Babesia microti
- 2C003** Babesia divergens
- 2C004** Blostidium coli
- 2C005** Cryptosporidium spp.
- 2C006** Leishmania species
- 2C007** Naegleria australiensis
- 2C008** Naegleria fowleri
- 2C009** Plasmodium falciparum
- 2C010** Pneumocystis carinii
- 2C011** Schistosoma mansoni
- 2C012** Schistosoma japonicum
- 2C013** Schistosoma hemotobium
- 2C014** Toxoplasma gondii
- 2C015** Trichinella spiralis
- 2C016** Trypanosoma brucei

2D **Viruses, whether natural, enhanced or modified, either in the form of isolated live cultures or as material including living material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures for the following:**

- 2D001** African Horse Sickness virus
- 2D002** African Swine Fever virus
- 2D003** Avian influenza virus
- 2D004** Blue tongue virus
- 2D005** Camel pox virus
- 2D006** Chikungunya virus
- 2D007** Crimean-Congo hemorrhagic fever virus
- 2D008** Dengue virus
- 2D009** Eastern equine encephalitis virus
- 2D010** Ebola fever virus
- 2D011** Encephalomyocarditis virus (EMC)
- 2D012** Foot and Mouth Disease virus (all serotypes and subtypes)
- 2D013** Guanirito virus
- 2D014** Goatpox virus
- 2D015** Hantaan virus
- 2D016** Herpes virus simiae (monkey B virus)
- 2D017** Herpes ateles, Herpes saimiri
- 2D018** HIV- 1 & HIV-2 and other strains of SIV
- 2D019** Hog cholera virus
- 2D020** Human T-cell Leukemia virus
- 2D021** Junin virus
- 2D022** Japanese encephalitis virus

2D023	Kyasanur Forest Disease virus and Central European encephalitis viruses.
2D024	Korean hemorrhagic fever virus
2D025	Lymphocytic choriomeningitis virus (LCM)
2D026	Lassa virus
2D027	Marburg virus
2D028	Murrey valley encephalitis virus
2D029	Marchupo virus
2D030	Mason-pfizer monkey virus
2D031	Monkey pox virus
2D032	Newcastle disease virus
2D033	Omsk hemorrhagic fever virus
2D034	Peste des petits ruminant virus
2D035	Porcine enterovirus type I
2D036	Powassan virus
2D037	Rabies virus -all strains
2D038	Respiratory syncitial virus
2D039	Rift Valley Fever virus
2D040	Rinderpest virus
2D041	Sabia virus
2D042	Sheep pox (field strain)
2D043	Sin Nombre virus
2D044	Smallpox virus
2D045	St.Louis encephalitis virus
2D046	Swine Fever virus
2D047	Tick-borne encephalitis virus (Russian Spring Summer Encephalitis virus)
2D048	Teschen disease virus (Porcine entero virus type 1)
2D049	Variola virus
2D050	Venezuelan encephalitis virus
2D051	Vesicular stomatitis virus
2D052	Western encephalitis virus
2D053	Yellow fever virus, 17 D vaccine strain

2E **Rickettsials, whether natural, enhanced or modified, either in the form of isolated live cultures or as material including living material which has been deliberately inoculated or contaminated with such cultures for the following:**

2E001	Coxiella burnetti
2E002	Rickettsiae rickettsii
2E003	Rickettsia quintana
2E004	Rickettsia prowazebi

2F **Toxins**

2F001	Abrins
2F002	Aflatoxins

2F003	Anatoxins
2F004	Botulinum toxin (s) (<i>clostridium botulinum</i>)
2F005	Bungarotoxins
2F006	<i>Clostridium perfringens</i> toxins
2F007	<i>Corynebacterium diphtheriae</i> toxins
2F008	<i>Cyanoctinosins</i> (<i>Microcystins</i>) (<i>Microcystic aeuginosa</i>)
2F009	Enterotoxin (<i>Staphylococcus aureus</i>)
2F010	Neurotoxin (<i>Shigella dysenteriae</i>)
2F011	Ricins
2F012	Shigatoxins
2F013	Saxitoxins
2F014	Trichothecene mycotoxins
2F015	Tetanus toxin (<i>clostridium tetani</i>)
2F016	Tetrodotoxin (<i>Spherooides rufipes</i>)
2F017	Verrucologen (<i>M. verrucadia</i>)

2G **Plant pathogens**

2G001	<i>Bemisia tabaci</i>
2G002	<i>Colletotrichum coffeatum</i> var. <i>virulans</i>
2G003	<i>Clavicep purpurea</i>
2G004	<i>Dothistroma pini</i> (<i>Scirrhia pini</i>)
2G005	<i>Erwinia amylovora</i>
2G006	<i>Frankliniella occidentalis</i>
2G007	<i>Microcyclus ulei</i>
2G008	<i>Peronospora hyoscyami</i> de Bary f.sp. <i>tabacina</i> (Adam) skalicky
2G009	<i>Phytophthora infestans</i>
2G010	<i>Puccinia graminis</i>
2G011	<i>Puccinia erianthi</i>
2G012	<i>Puccinia striiformis</i> (<i>Puccinia glumarum</i>)
2G013	<i>Pyricularia oryzae</i>
2G014	<i>Pseudomonas solanacearum</i>
2G015	<i>Peronospora hyscyami</i> de Bary
2G016	<i>Ralstonia solanacearum</i>
2G017	Sugar cane Fiji disease virus
2G018	<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>
2G019	<i>Tilletia indica</i>
2G020	<i>Thrips palmi</i>
2G021	<i>Ustilago Maydis</i>
2G022	<i>Xanthomonas albilineans</i>
2G023	<i>Xanthomonas campestris</i> pv <i>citri</i>
2G024	<i>Xanthomonas campestris</i> pv <i>oryzae</i>

2H **Genetically Modified Organisms**

2H001	Genetically-modified micro-organisms or genetic elements that contain
--------------	---

nucleic acid sequences associated with pathogenicity and are derived from organisms specified above in 2A, 2B, 2C, 2D, 2E and 2H.

Genetically-modified micro-organisms or genetic elements that contain nucleic acid sequences coding for any of the toxins specified above in 2F.

Category 3 Materials, Materials Processing Equipment and related technologies

3A Materials

3A1 Special Materials

3A101 Zirconium, beryllium, magnesium, and alloys of these in particle size less than 60 μm

3A102 Maraging steel in any form in which any linear dimension exceeds 75 mm, or in the form of sheet, plate or tubing with a wall or plate thickness equal or less than 5 mm.

3A103 Tungsten (CAS 12070-12-1), molybdenum (CAS 1317-33-5), and alloys of those metals in the form of uniform spherical or atomized particles of size less than 500 μm

3A104 Germanium

3A105 Gallium

3A106 Indium

3A107 Titanium alloys including Titanium-stabilised Duplex Stainless Steel (Ti-DSS) (other than as specified at 0A307)

3A108 Aluminium alloys in any form 'capable of acquiring' an ultimate tensile strength of 460 MPa or more at 293 K (20 degrees C)

Note: The phrase 'capable of acquiring' encompasses alloys before or after heat treatment

3A109 Bismuth having a purity of 99.99% or greater by weight and containing less than 10 parts per million by weight of silver

3A110 Calcium containing less than 1000 parts per million by weight of metallic impurities other than magnesium and containing less than 10 parts per million by weight of Boron

3A111 Chlorine trifluoride (ClF₃)

3A112 Magnesium containing less than 200 parts per million by weight of metallic impurities other than calcium and containing less than 10 parts per million by weight of boron

3A113 Tungsten, tungsten carbide, and alloys containing more than 90% tungsten by weight in forms with a hollow cylindrical symmetry (including cylinder segments) with an inside diameter between 100 and 300 mm and a mass greater than 20 kg.

3A114

- Nickel powder of purity 99.0% or greater by weight and having a mean particle size of less than 10 μm ;
- Porous nickel metal produced from the nickel powder specified above

3A115 Natural boron, boron carbide or metal borides having a boron purity of 85% or more.

3A116 Fibrous or filamentary materials, and prepregs, as follows:

- Carbon or aramid fibrous or filamentary materials having 'specific modulus' of 12.7×10^6 m or greater; or 'specific tensile strength' of 23.5×10^4 m or greater;
- Glass fibrous or filamentary materials having 'specific modulus' of 3.18×10^6 m or greater; and 'specific tensile strength' of 7.62×10^4 m or greater;
- Thermoset resin impregnated continuous yarns, rovings, tows or tapes with a width of 15 mm or less (prepregs), made from carbon or glass fibrous or filamentary materials specified in (a) or (b) above.

3A117 Carbon - carbon composites.

3A2 **Structural Materials**

3A201 Structural materials such as:

- Composite structures, laminates, resin impregnated fibre prepregs and metal coated fibre preforms made either with an organic matrix or metal matrix utilizing fibrous or filamentary reinforcements, and manufactures thereof, specially designed for use in rocket systems (including ballistic missile systems, space launch vehicles and sounding rockets), unmanned aerial vehicles and cruise missiles and subsystems thereof;
- Resaturated pyrolyzed (i.e. Carbon-Carbon) materials specially designed for rocket systems (including ballistic missile systems, space launch vehicles and sounding rockets), unmanned aerial vehicles and cruise missiles;

- c. Fine grain re-crystallised bulk graphites and pyrolytic or fibrous reinforced graphites usable for rocket nozzles and re-entry vehicles nose tips;
- d. Ceramic composite materials (dielectric constant less than 6 at any frequency from 100 MHz to 100 GHz) for use in missile radomes;
- e. Materials and coatings for reduced radar reflectivity;
- f. Bulk machinable silicon-carbide reinforced unfired ceramic usable in re-entry vehicles nose tips.

3A3

Rocket propellants and constituent chemicals:

3A301

Propulsive substances – Hydrazine (CAS-302-01)and its derivatives usable as rocket fuel substances including Monomethylhydrazine (MMH)(CAS 60-34), Unsymmetrical di-methyl hydrazine (UDMH), (CAS 57-14-7)Hydrazine nitrate, (except aromatic hydrazines and their salts, adipic acid dihydrazide), ammonium perchlorate, spherical aluminium powder(CAS 7429-90-5);

3A302

Metal fuels containing any of the following: Zirconium(CAS 7440-67-7), beryllium(CAS 7440-41-7), magnesium, titanium, tungsten, boron and boron alloys, zinc, and alloys of magnesium(CAS 7439-95-4);

3A303

Polymeric substances:

Carboxyl-terminated polybutadiene (CTPB)

Hydroxy-Terminated Polybutadiene (HTPB)

Glycidyl azide polymer (GAP)

Polybutadiene acrylic acid (PBAA)

Polybutadiene acrylonitrile (PBAN)

3A304

Composite propellants and composite modified double base propellants;

3A305

High energy density materials such as boron slurry;

3A306

Oxidizers/fuels - Perchlorates, chlorates or chromates mixed with powdered metals or other high energy fuel components; Dinitrogen trioxide, Nitrogen dioxide / Dinitrogen tetroxide, Mixed Oxides of Nitrogen (MON), Dinitrogen pentoxide, Inhibited red fuming nitric acid (IRFNA) (CAS 8007-58-7), Ammonium perchlorate (CAS 7790-98-9), Ammonium Dinitramide (ADN) (CAS 140456-78-6), Hydrazinium Nitroformate (HNF), Compounds composed of fluorine and one more of other halogens, oxygen or nitrogen.

3A307

Bonding agents - Tris (1-2 (2-methyl)) aziridinyl phosphine oxide (MAPO)(CAS 57-39-6), Trimesoyl-1-(2-ethyl) aziridene (HX-868, BITA)(CAS 7722-73-8), Tepanol (HX-878)(CAS 68412-46-4), Tepan (HX-879) re action product of tetraethylpentamine and acrylonitrile (CAS 68412-45-3), and Polyfunctional aziridine amides with isophthalic,

trimesic, isocyanuric, or trimethyladipic backbone also having a 2-methyl or 2-ethyl aziridine group including 1,1'-Isophthaloyl-bis(2-methylaziridene (CAS 7652-64-4), (HX-752, HX-874, and HX-877);

3A308 Curing agents and reaction catalysts - Triphenyl bismuth (TPB)(CAS 603-33-8);

3A309 Burning rate modifiers –

a. Carboranes, decaboranes, pentaboranes and derivatives thereof;

b. Ferrocene derivatives, as follows:

1. Catocene (CAS 37206-42-1);

2. Ethyl ferrocene;

3. Propyl ferrocene(CAS 1273-89-8)

4. n-Butyl ferrocene(CAS 31904-29-7);

5. Pentyl ferrocene (CAS 1274-00-6);

6. Dicyclopentyl ferrocene(CAS 20773-28-8);

7. Dicyclohexyl ferrocene;

8. Diethyl ferrocene;

9. Dipropyl ferrocene;

10. Dibutyl ferrocene(CAS 1274-08-4);

11. Dihexyl ferrocene (CAS 93894-59-8);

12. Acetyl ferrocenes;

13. Ferrocene Carboxylic acids;

14. Butacene;

c. Other ferrocene derivatives usable as rocket propellant burning rate modifiers.

3A310 Nitrate esters and nitrated plasticisers as follows:

a. Triethylene glycol dinitrate (TEGDN);

b. Trimethylolethane trinitrate (TMETN)(CAS 3032-55-1) ;

c. 1,2,4-butanetriol trinitrate (BTTN)(CAS 6659-60-5) ;

d. Diethylene glycol dinitrate (DEGDN).

3A311 Stabilisers as follows:

a. 2-Nitrodiphenylamine (CAS 119-75-5);

b. N-methyl-p-nitroaniline (CAS 100-15-2).

3A4 **High explosives**

3A401 High explosives, and propellants or mixtures containing any of the following;

a. Cyclotermethylenetetrinitramine (HMX);

b. Cyclotrimethylenetrinitramine (RDX);

c. Triaminotrinitrobenzene (TATB);

d. Hexanitrostilbene (HNS).

License applications for the export of items at 3A401a and 3A401b will normally be denied.

3A5 Stealth materials

3A501 a. Materials for reduced observables such as radar reflectivity, ultraviolet/infrared signatures and acoustic signatures;
b. Devices, including made from non-stealth material, for reduced observables such as radar reflectivity, ultraviolet/infrared signatures and acoustic signatures;

3A502 Materials and coatings (including paints) specially designed for reduced or tailored reflectivity or emissivity in the microwave, infrared or ultraviolet spectra other than coatings (including paints) when specially used for thermal control of satellites.

3A503 Technology related to the development, production or use of items in 3A.

3B **Materials processing and “production equipment”, related “technology” and specially designed components and accessories therefor.**

3B001 Remote manipulators that provide mechanical translation of human operator actions by electrical, hydraulic or mechanical means and operating arm and terminal fixture that can be used to provide remote actions;

3B002 Multidirectional, multidimensional weaving and interlacing machines, including adapters and modification kits for weaving, interlacing or braiding fibres to fabricate composite structures except textile machinery which has not been modified for rocket systems;

3B003 Equipment designed or modified for production of fibrous or filamentary materials as follows: converting polymeric substances; vapour deposition on heated filament substrates; wet spinning of refractory ceramics.

3B004 Equipment designed or modified for special fibre surface treatment or for producing prepregs and preforms, including rollers, tension stretchers, coating equipment, cutting equipment and clicker dies;

3B005 Chemical vapour deposition furnaces designed or modified for the densification of carbon-carbon composites.

3B006 Pyrolytic deposition and densification equipment including:

- Technology for producing pyrolytically derived materials formed on a mould, mandrel or other substrate from precursor gases.
- Specially designed nozzles for the above process.
- Equipment and process controls and specially designated software thereof, specially designed or modified for densification and pyrolysis of structural composite rocket nozzles and re-entry vehicle nose tips.

3B007 Production equipment usable for or specially designed or modified for production, handling, mixing, curing, casting, pressing, machining or acceptance testing of the solid or liquid rocket propellants or rocket propellant constituents and related technology.

3B008 Refrigeration units and equipment capable of cooling hydrogen or helium to -250 degrees Celsius (23K) or lower.

3B009 Continuous nitrators.

3B010 Dehydration presses.

3B011 Screw extruders usable for or specially designed or modified for high explosive extrusion.

3B012 Cutting machines for the sizing of extruded propellant.

3B013 Sweetie barrels (tumblers) 1.85 m or more in diameter and having over 227 kg product capacity;

3B014 Continuous mixers or batch mixers with provision for mixing under vacuum.

3B015 Fluid energy mills usable for grinding or milling any of the items in 3A3.

3B016 Equipment to achieve both sphericity and uniform particle size in metal powders.

- Metal powder production equipment usable for production, in a controlled environment, of spherical or atomized materials including:
- Plasma generators (high frequency arc-jets) usable for obtaining sputtered or spherical metallic powders with organisation of the process in an argon-water environment
- Electroburst equipment usable for obtaining sputtered or spherical metallic powders with organisation of the process in an argon-water environment.

3B017 Sputter ion pumps

3B018	Technical data (including processing conditions) and procedures for the regulation of temperature, pressure or atmosphere in autoclaves or hydroclaves when used for the production of composites or partially processed composites.
3B019	Software specially designed or modified for the use of equipment for the production and handling of materials specified in 3A
3B020	Technology for the development, production or use of items in 3B
3C	[Reserved]
3D	Chemical and biomaterial manufacturing and handling equipment and facilities:
3D001	<p>Reaction vessels, reactors or agitators, storage tanks, containers or receivers, heat exchangers or condensers, distillation or absorption columns, valves, remotely operated filling equipment, multi-walled piping, bellows, diaphragm pumps, vacuum pumps, fans, compressors, blowers, gas (including air) handling or other substance-transfer equipment wholly or partly made from any of the following materials;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nickel or alloys with more than 40% nickel by weight b. Alloys with more than 25% nickel and 20% chromium by weight (e.g. 'Hastelloy', 'In illum', 'Inconel', 'Incoloy') c. Fluoropolymers d. Glass or glass lined (including vitrified or enamelled coating) e. Graphite f. Tantalum or tantalum alloys g. Titanium or titanium alloys h. Zirconium or zirconium alloys i. Ceramics j. Ferrosilicon

Note: 3D001 does not control the following items:

- a. Open vessels fabricated from glass sheets (such as aquariums, water tanks etc.); or cookware, table-ware, decorative glass or ceramic items (such as vases, art objects, etc.)
- b. Glass-ware (whether or not metal-jacketed) or glass-lined reaction vessels or reactors, whether or not equipped with agitators, provided that the total internal (geometric) volume of each vessel or reactor is greater than 20,000 litres (20 m³) or less than or equal to 100 litres (0.1 m³). Examples of the latter capacity glass or ceramic-ware include standard laboratory equipment such as test tubes, flasks, retorts etc.

3D002 Incinerators designed to destroy any chemicals specified in Category 1.

3D003 Combustors or pyrolyzers capable of a heat-zone ('burner') temperature greater than 1,273 K (1000 Degree Centigrade), and in which any surfaces that come into direct contact with material coming into the containing chamber are made from, or lined with, any of the following materials:

- Alloys with more than 25% nickel and 25% chromium by weight; (e.g., 'Hatelloy', 'Illiun', 'Inconel', 'Incoloy')
- Nickel, or alloys with more than 40% nickel by weight; or
- Titanium;
- Ceramics.

3D004 Equipment related to P3, P4 facilities such as protective suits and class III safety cabinets.

No licenses shall be granted for complete containment facilities at P3, P4, containment level as specified in the World Health Organization (WHO) bio-safety manual.

3D005 Technology related to the development, production or use of items in 3D

Category 4 Nuclear-related other equipment, assemblies and components; test and production equipment; and related technology not controlled under Category 0

4A Equipment, assemblies, components including test and production equipment

4A001 Flow-forming machines, spin-forming machines capable of flow-forming functions, and mandrels, as follows:

- For flow forming machines refer to 5A205.
- Spin forming machines having both of the following characteristics:
 - Three or more rollers (active or guiding); and
 - which can be equipped with 'numerical control' units or a computer control.
- Rotor-forming mandrels designed to form cylindrical rotors of inside diameter between 75 and 400 mm.

Note: Item 4A001a and 4A001b include machines which have only a single roller designed to deform metal plus two auxiliary rollers which support the mandrel, but do not participate directly in the deformation process.

4A002 Machine tools, as follows, for removing or cutting metals, ceramics, or composites, which, according to the manufacturer's technical specifications, can be equipped with electronic devices for simultaneous contouring control in two or more axes:

a. Machine tools for turning, that have positioning accuracies with all compensations available better (less) than $6 \mu\text{m}$ along any linear axis (overall positioning) for machines capable of machining diameters greater than 35mm;

Note: Item 4A002a does not control bar machines, limited to machining only bar feed through, if maximum bar diameter is equal to or less than 42 mm and there is no capability of mounting chucks. Machines may have drilling and/or milling capabilities for machining parts with diameters less than 42 mm.

b. Machine tools for milling, having any of the following characteristics:

1. Positioning accuracies with all compensations available better (less) than $6 \mu\text{m}$ along any linear axis (overall positioning); or
2. Two or more contouring rotary axes;

Note: Item 4A002b does not control milling machines having both of the following characteristics:

1. X-axis travel greater than 2 m; and
2. Overall positioning accuracy on the x-axis worse (more) than $30 \mu\text{m}$.

c. Machine tools for grinding, having any of the following characteristics:

1. Positioning accuracies with all compensations available better (less) than $4 \mu\text{m}$ along any linear axis (overall positioning); or
2. Two or more contouring rotary axes;

Note: Item 4A002c does not control grinding machines as follows:

1. Cylindrical external, internal, and external-internal grinding machines having all the following characteristics:
 - a. Limited to cylindrical grinding;
 - b. A maximum work-piece outside diameter or length of 150 mm;
 - c. Not more than two axes that can be coordinated simultaneously for contouring control; and
 - d. No contouring c-axis;
2. Jig grinders with axes limited to x, y, c, and a, where c-axis is used to maintain the grinding wheel normal to the work surface, and the a-axis is configured to grind barrel cams;
3. Tool or cutter grinding machines with software specially designed for the manufacturing of tools or cutters;
4. Crankshaft or camshaft grinding machines.

d. Non-wire type Electrical Discharge Machines (EDM) that have two or more contouring rotary axes and that can be coordinated

simultaneously for contouring control.

Note: Stated positioning accuracy levels derived under the following procedures from measurements made according to ISO 230/2 (1988) or national equivalents may be used for each machine tool model if provided to, and accepted by, national authorities instead of individual machine tests.

Stated positioning accuracy are to be derived as follows:

1. Select five machines of a model to be evaluated;
2. Measure the linear axis accuracies according to ISO 230/2 (1988);
3. Determine the accuracy values (A) for each axis of each machine. The method of calculating the accuracy value is described in the ISO 230/2 (1988) standard;
4. Determine the average accuracy value of each axis. This average value becomes the stated positioning accuracy of each axis for the model ($\bar{A}_x, \bar{A}_y \dots$);
5. Since Item 4A002 refers to each linear axis, there will be as many stated positioning accuracy values as there are linear axes;
6. If any axis of a machine tool not controlled by Items 4A002a, 4A002b, or 4A002c has a stated positioning accuracy of 6 μm or better (less) for grinding machines, and 8 μm or better (less) for milling and turning machines, both according to ISO 230/2 (1988), then the builder should be required to reaffirm the accuracy level once every eighteen months.

Technical Notes

1. Axis nomenclature shall be in accordance with International Standard ISO 841, Numerical Control Machines Axis and Motion Nomenclature.
2. Not counted in the total number of contouring rotary axes are secondary parallel contouring rotary axes the centre line of which is parallel to the primary rotary axis.
3. Rotary axes do not necessarily have to rotate over 360 degrees. A rotary axis can be driven by a linear device, e.g., a screw or a rack and-pinion.

4A003

Dimensional inspection machines, instruments, or systems, as follows:

- a. Computer controlled or numerically controlled dimensional inspection machines having both of the following characteristics:
 1. Two or more axes; and
 2. A one-dimensional length measurement uncertainty equal to or better (less) than $(1.25 + L/1000) \mu\text{m}$ tested with a probe of an

accuracy of better (less) than $0.2 \mu\text{m}$ (L is the measured length in millimetres);

b. 'Linear displacement' measuring instruments, as follows:

1. Non-contact type measuring systems with a resolution equal to or better (less) than $0.2 \mu\text{m}$ within a measuring range up to 0.2 mm ;
2. Linear variable differential transformer (LVDT) systems having both of the following characteristics:
 - a. Linearity equal to or better (less) than 0.1% within a measuring range up to 5 mm ; and
 - b. Drift equal to or better (less) than 0.1% per day at a standard ambient test room temperature $\pm 1 \text{ K}$;
3. Measuring systems having both of the following characteristics:
 - a. Contain a laser; and
 - b. Maintain for at least 12 hours, over a temperature range of $\pm 1 \text{ K}$ around a standard temperature and a standard pressure:
 1. A resolution over their full scale of $0.1 \mu\text{m}$ or better; and
 2. With a measurement uncertainty equal to or better (less) than $(0.2 + L/2000) \mu\text{m}$ (L is the measured length in millimetres);

Note: Item 4A003b3 does not control measuring interferometer systems, without closed or open loop feedback, containing a laser to measure slide movement errors of machine tools, dimensional inspection machines, or similar equipment.

Technical Note: In Item 4A003b 'linear displacement' means the change of distance between the measuring probe and the measured object.

c. Angular displacement measuring instruments having an angular position deviation equal to or better (less) than 0.00025° ;

Note: Item 4A003c does not control optical instruments, such as autocollimators, using collimated light to detect angular displacement of a mirror.

d. Systems for simultaneous linear-angular inspection of hemi-shells, having both of the following characteristics:

1. Measurement uncertainty along any linear axis equal to or better (less) than $3.5 \mu\text{m}$ per 5 mm ; and
2. Angular position deviation equal to or less than 0.02° .

Notes: 1. Item 4A003 includes machine tools that can be used as measuring machines if they meet or exceed the criteria specified for the measuring machine function.

2. Machines described in Item 4A003 are controlled if they exceed the threshold specified anywhere within their operating range.

Technical Note: All parameters of measurement values in this item represent plus/minus, i.e., not total band.

4A004

Controlled atmosphere (vacuum or inert gas) induction furnaces, and power supplies therefor, as follows:

- a. Furnaces having all of the following characteristics:
 1. Capable of operation at temperatures above 1123 K (850 °C);
 2. Induction coils 600 mm or less in diameter; and
 3. Designed for power inputs of 5 kW or more;

Note: Item 4A004a does not control furnaces designed for the processing of semiconductor wafers.

- b. Power supplies, with a specified output power of 5 kW or more, specially designed for furnaces specified in Item 4A004a.

4A005

‘Isostatic presses’, and related equipment, as follows:

- a. ‘Isostatic presses’ as specified in 5A208;
- b. Dies, moulds, and controls specially designed for the ‘isostatic presses’ specified in Item 4A005a.

Technical Notes:

1. In Item 4A005 ‘Isostatic presses’ means equipment capable of pressurizing a closed cavity through various media (gas, liquid, solid particles, etc.) to create equal pressure in all directions within the cavity upon a work piece or material.
2. In Item 4A005 the inside chamber dimension is that of the chamber in which both the working temperature and the working pressure are achieved and does not include fixtures. That dimension will be the smaller of either the inside diameter of the pressure chamber or the inside diameter of the insulated furnace chamber, depending on which of the two chambers is located inside the other.

4A006

Vibration test systems, equipment, and components as follows:

- a. Electrodynami c vibration test systems, having all of the following characteristics:
 1. Employing feedback or closed loop control techniques and incorporating a digital control unit;
 2. Capable of vibrating at 10 g RMS or more between 20 and 2000 Hz; and

- 3. Capable of imparting forces of 50 kN or greater measured 'bare table';
- b. Digital control units, combined with software specially designed for vibration testing, with a real-time bandwidth greater than 5 kHz and being designed for a system specified in Item 4A006a;
- c. Vibration thrusters (shaker units), with or without associated amplifiers, capable of imparting a force of 50 kN or greater measured 'bare table', which are usable for the systems specified in Item 4A006a;
- d. Test piece support structures and electronic units designed to combine multiple shaker units into a complete shaker system capable of providing an effective combined force of 50 kN or greater, measured 'bare table,' which are usable for the systems specified in Item 4A006a.

Technical Note : In Item 4A006 'bare table' means a flat table, or surface, with no fixtures or fittings.

4A007 Vacuum or other controlled atmosphere metallurgical melting and casting furnaces and related equipment, as follows:

- a. Arc re-melt and casting furnaces having both of the following characteristics:
 - 1. Consumable electrode capacities between 1000 and 20000 cm³; and
 - 2. Capable of operating with melting temperatures above 1973 K (1700 °C);
- b. Electron beam melting furnaces and plasma atomisation and melting furnaces, having both of the following characteristics:
 - 1. A power of 50 kW or greater; and
 - 2. Capable of operating with melting temperatures above 1473 K (1200 °C);
- c. Computer control and monitoring systems specially configured for any of the furnaces specified in Item 4A007a or 4A007b.

4A008

Crucibles made of materials resistant to liquid actinide metals, as follows:

- a. Crucibles having both of the following characteristics:
 - 1. A volume of between 150 cm³ (150 ml) and 8000 cm³ (8 litres); and
 - 2. Made of or coated with any of the following materials, having a purity of 98% or greater by weight:
 - a. Calcium fluoride (CaF₂);
 - b. Calcium zirconate (metazirconate) (CaZrO₃);
 - c. Cerium sulphide (Ce₂S₃);
 - d. Erbium oxide (erbia) (Er₂O₃);
 - e. Hafnium oxide (hafnia) (HfO₂);

- f. Magnesium oxide (MgO);
- g. Nitrided niobium-titanium-tungsten alloy (approximately 50% Nb, 30% Ti, 20% W);
- h. Yttrium oxide (yttria) (Y₂O₃); or
- i. Zirconium oxide (zirconia) (ZrO₂);
- b. Crucibles having both of the following characteristics:
 - 1. A volume of between 50 cm³ (50 ml) and 2000 cm³ (2 litres); and
 - 2. Made of or lined with tantalum, having a purity of 99.9% or greater by weight;
- c. Crucibles having all of the following characteristics:
 - 1. A volume of between 50 cm³ (50 ml) and 2000 cm³ (2 litres);
 - 2. Made of or lined with tantalum, having a purity of 98% or greater by weight; and
 - 3. Coated with tantalum carbide, nitride, boride, or any combination thereof.

4A009 Platinized catalysts specially designed or prepared for promoting the hydrogen isotope exchange reaction between hydrogen and water for the recovery of tritium from heavy water or for the production of heavy water.

4A010 Composite structures in the form of tubes having both of the following characteristics:

- a. An inside diameter of between 75 and 400 mm; and
- b. Made with any of the materials specified in Item 3A116.

4A011 Frequency changers or generators having all of the following characteristics:

- a. Multiphase output capable of providing a power of 40 W or greater;
- b. Capable of operating in the frequency range between 600 and 2000 Hz;
- c. Total harmonic distortion better (less) than 10%; and
- d. Frequency control better (less) than 0.1%.

Note: Frequency changers and generators especially designed or prepared for the gas centrifuge process are controlled under Prescribed Equipment (0B Category).

Technical Note: Frequency changers in Item 4A011 are also known as converters or inverters.

4A012 Lasers, laser amplifiers and oscillators as follows:

- a. Copper vapour lasers having both of the following characteristics:
 - 1. Operating at wavelengths between 500 and 600 nm; and
 - 2. An average output power equal to or greater than 40 W;

- b. Argon ion lasers having both of the following characteristics:
 - 1. Operating at wavelengths between 400 and 515 nm; and
 - 2. An average output power greater than 40 W;
- c. Neodymium-doped (other than glass) lasers with an output wavelength between 1000 and 1100 nm having either of the following:
 - 1. Pulse-excited and Q-switched with a pulse duration equal to or greater than 1 ns, and having either of the following:
 - a. A single-transverse mode output with an average output power greater than 40 W; or
 - b. A multiple-transverse mode output with an average output power greater than 50 W;

or

- 2. Incorporating frequency doubling to give an output wavelength between 500 and 550 nm with an average output power of greater than 40 W;
- d. Tuneable pulsed single-mode dye laser oscillators having all of the following characteristics:
 - 1. Operating at wavelengths between 300 and 800 nm;
 - 2. An average output power greater than 1 W;
 - 3. A repetition rate greater than 1 kHz; and
 - 4. Pulse width less than 100 ns;
- e. Tuneable pulsed dye laser amplifiers and oscillators having all of the following characteristics:
 - 1. Operating at wavelengths between 300 and 800 nm;
 - 2. An average output power greater than 30 W;
 - 3. A repetition rate greater than 1 kHz; and
 - 4. Pulse width less than 100 ns;

Note: Item 4A012e does not control single mode oscillators.

- f. Alexandrite lasers having all of the following characteristics:
 - 1. Operating at wavelengths between 720 and 800 nm;
 - 2. A bandwidth of 0.005 nm or less;
 - 3. A repetition rate greater than 125 Hz; and
 - 4. An average output power greater than 30 W;
- g. Pulsed carbon dioxide lasers having all of the following characteristics:
 - 1. Operating at wavelengths between 9000 and 11000 nm;
 - 2. A repetition rate greater than 250 Hz;
 - 3. An average output power greater than 500 W; and

4. Pulse width of less than 200 ns;

Note: Item 4A012g does not control the higher power (typically 1 to 5 kW) industrial CO₂ lasers used in applications such as cutting and welding, as these latter lasers are either continuous wave or are pulsed with a pulse width greater than 200 ns.

- h. Pulsed excimer lasers (XeF, XeCl, KrF) having all of the following characteristics:
 - 1. Operating at wavelengths between 240 and 360 nm;
 - 2. A repetition rate greater than 250 Hz; and
 - 3. An average output power greater than 500 W;
- i. Para-hydrogen Raman shifters designed to operate at 16 μm output wavelength and at a repetition rate greater than 250 Hz.

4A013

Valves having all of the following characteristics:

- a. A nominal size of 5 mm or greater;
- b. Having a bellows seal; and
- c. Wholly made of or lined with aluminium, aluminium alloy, nickel, or nickel alloy containing more than 60% nickel by weight.

Technical Note: For valves with different inlet and outlet diameter, the nominal size parameter in Item 4A013a refers to the smallest diameter.

4A014

Superconducting solenoidal electromagnets having all of the following characteristics:

- a. Capable of creating magnetic fields greater than 2 T;
- b. A ratio of length to inner diameter greater than 2;
- c. Inner diameter greater than 300 mm; and
- d. Magnetic field uniform to better than 1% over the central 50% of the inner volume.

Note: Item 4A014 does not control magnets specially designed for and exported as part of medical nuclear magnetic resonance (NMR) imaging systems. ('As part of' does not necessarily mean physical part in the same shipment. Separate shipments from different sources are allowed, provided the related export documents clearly specify the 'as part of' relationship.)

4A015

High-power direct current power supplies having both of the following characteristics:

- a. Capable of continuously producing, over a time period of 8 hours, 100

V or greater with current output of 500 A or greater; and

b. Current or voltage stability better than 0.1% over a time period of 8 hours.

4A016 High-voltage direct current power supplies having both of the following characteristics:

a. Capable of continuously producing, over a time period of 8 hours, 20 kV or greater with current output of 1 A or greater; and

b. Current or voltage stability better than 0.1% over a time period of 8 hours.

4A017 Pressure transducers capable of measuring absolute pressures at any point in the range 0 to 13 kPa and having both of the following characteristics:

a. Pressure sensing elements made of or protected by aluminium, aluminium alloy, nickel, or nickel alloy with more than 60% nickel by weight; and

b. Having either of the following characteristics:

1. A full scale of less than 13 kPa and an accuracy of better than \pm 1% of full scale; or
2. A full scale of 13 kPa or greater and an accuracy of better than \pm 130 Pa.

Technical Notes:

1. In Item 4A017 pressure transducers are devices that convert pressure measurements into an electrical signal.
2. In Item 4A017 accuracy includes non-linearity, hysteresis and repeatability at ambient temperature.

4A018 Vacuum pumps having all of the following characteristics:

a. Input throat size equal to or greater than 380 mm;

b. Pumping speed equal to or greater than 15 m³/s; and

c. Capable of producing an ultimate vacuum better than 13.3 mPa.

Technical Notes:

1. The pumping speed is determined at the measurement point with nitrogen gas or air.
2. The ultimate vacuum is determined at the input of the pump with the input of the pump blocked off.

4A019 Electrolytic cells for fluorine production with an output capacity greater than 250 g of fluorine per hour.

4A020

Rotor fabrication or assembly equipment, rotor straightening equipment, bellows-forming mandrels and dies, as follows:

- a. Rotor assembly equipment for assembly of gas centrifuge rotor tube sections, baffles, and end caps;

Note: Item 4A020a includes precision mandrels, clamps, and shrink fit machines.

- b. Rotor straightening equipment for alignment of gas centrifuge rotor tube sections to a common axis;

Technical Note: In Item 4A020b such equipment normally consists of precision measuring probes linked to a computer that subsequently controls the action of, for example, pneumatic rams used for aligning the rotor tube sections.

- c. Bellows-forming mandrels and dies for producing single -convolution bellows.

Technical Note: The bellows referred to in Item 4A020c have all of the following characteristics:

1. Inside diameter between 75 and 400 mm;
2. Length equal to or greater than 12.7 mm;
3. Single convolution depth greater than 2 mm; and
4. Made of high-strength aluminium alloys, maraging steel, or high strength fibrous or filamentary materials.

4A021

Centrifugal multi-plane balancing machines, fixed or portable, horizontal or vertical, as follows:

- a. Centrifugal balancing machines designed for balancing flexible rotors having a length of 600 mm or more and having all of the following characteristics:

1. Swing or journal diameter greater than 75 mm;
2. Mass capability of from 0.9 to 23 kg; and
3. Capable of balancing speed of revolution greater than 5000 rpm;

- b. Centrifugal balancing machines designed for balancing hollow cylindrical rotor components and having all of the following characteristics:

1. Journal diameter greater than 75 mm;
2. Mass capability of from 0.9 to 23 kg;

3. Capable of balancing to a residual imbalance equal to or less than 0.010 kg x mm/kg per plane; and
4. Belt drive type.

4A022

Filament winding machines and related equipment, as follows:

- a. Filament winding machines as specified in 5A206.
- b. Coordinating and programming controls for the filament winding machines specified in Item 4A022a;
- c. Precision mandrels for the filament winding machines specified in Item 4A022a.

4A023

Electromagnetic isotope separators designed for, or equipped with, single or multiple ion sources capable of providing a total ion beam current of 50 mA or greater.

Notes:

1. Item 4A023 includes separators capable of enriching stable isotopes as well as those for uranium.
2. A separator capable of separating the isotopes of lead with a one-mass unit difference is inherently capable of enriching the isotopes of uranium with a three-unit mass difference.
3. Item 4A023 includes separators with the ion sources and collectors both in the magnetic field and those configurations in which they are external to the field.

Technical Note: A single 50 mA ion source cannot produce more than 3 g of separated highly enriched uranium (HEU) per year from natural abundance feed.

4A024

Mass spectrometers capable of measuring ions of 230 atomic mass units or greater and having a resolution of better than 2 parts in 230, as follows, and ion sources therefor:

- a. Inductively coupled plasma mass spectrometers (ICP/MS);
- b. Glow discharge mass spectrometers (GDMS);
- c. Thermal ionisation mass spectrometers (TIMS);
- d. Electron bombardment mass spectrometers which have a source chamber constructed from, lined with or plated with materials resistant

to UF6;

e. Molecular beam mass spectrometers having either of the following characteristics:

1. A source chamber constructed from, lined with or plated with stainless steel or molybdenum, and equipped with a cold trap capable of cooling to 193 K (-80 °C) or less; or
2. A source chamber constructed from, lined with or plated with materials resistant to UF6;

f. Mass spectrometers equipped with a micro-fluorination ion source designed for actinides or actinide fluorides.

Note: Mass spectrometers especially designed or prepared for analyzing on-line samples of uranium hexafluoride are controlled under Prescribed Equipment (0B Category).

4A025

Specialized packings which may be used in separating heavy water from ordinary water, having both of the following characteristics:

- a. Made of phosphor bronze mesh chemically treated to improve wettability; and
- b. Designed to be used in vacuum distillation towers.

4A026

Pumps capable of circulating solutions of concentrated or dilute potassium amide catalyst in liquid ammonia (KNH₂/NH₃), having all of the following characteristics:

- a. Airtight (i.e., hermetically sealed);
- b. A capacity greater than 8.5 m³/h; and
- c. Either of the following characteristics:
 1. For concentrated potassium amide solutions (1% or greater), an operating pressure of 1.5 to 60 MPa; or
 2. For dilute potassium amide solutions (less than 1%), an operating pressure of 20 to 60 MPa.

4A027

Turbo-expanders or turbo-expander-compressor sets having both of the following characteristics:

- a. Designed for operation with an outlet temperature of 35 K (- 238 °C) or less; and
- b. Designed for a throughput of hydrogen gas of 1000 kg/h or greater.

4A028

Water-hydrogen sulphide exchange tray columns and internal contactors, as follows:

- a. Water-hydrogen sulphide exchange tray columns, having all of the

following characteristics:

1. Can operate at pressures of 2 MPa or greater;
2. Constructed of carbon steel having an austenitic ASTM (or equivalent standard) grain size number of 5 or greater; and
3. With a diameter of 1.8 m or greater;

b. Internal contactors for the water-hydrogen sulphide exchange tray columns specified in Item 4A028a.

Note: For columns which are especially designed or prepared for the production of heavy water, see Prescribed Equipment (0B002).

Technical Note: Internal contactors of the columns are segmented trays which have an effective assembled diameter of 1.8 m or greater; are designed to facilitate counter current contacting and are constructed of stainless steels with a carbon content of 0.03% or less. These may be sieve trays, valve trays, bubble cap trays or turbo grid trays.

4A029 Hydrogen-cryogenic distillation columns having all of the following characteristics:

- a. Designed for operation at internal temperatures of 35 K (-238 °C) or less;
- b. Designed for operation at internal pressures of 0.5 to 5 MPa;
- c. Constructed of either:
 1. Stainless steel of the 300 series with low sulphur content and with an austenitic ASTM (or equivalent standard) grain size number of 5 or greater; or
 2. Equivalent materials which are both cryogenic and H₂-compatible; and
- d. With internal diameters of 1 m or greater and effective lengths of 5 m or greater.

4A030 Ammonia synthesis converters or synthesis units, in which the synthesis gas (nitrogen and hydrogen) is withdrawn from an ammonia/hydrogen high-pressure exchange column and the synthesized ammonia is returned to said column.

4B **Equipment, assemblies and components, including test and measurement equipment usable in development of nuclear explosive devices**

4B001 Photomultiplier tubes having both of the following characteristics:

- a. Photocathode area of greater than 20 cm²; and
- b. Anode pulse rise time of less than 1 ns.

4B002

Flash X-ray generators or pulsed electron accelerators having either of the following sets of characteristics:

- An accelerator peak electron energy of 500 keV or greater but less than 25 MeV; and
- With a figure of merit (K) of 0.25 or greater;

or

 - An accelerator peak electron energy of 25 MeV or greater; and
 - A peak power greater than 50 MW.

Note: Item 4B002 does not control accelerators that are component parts of devices designed for purposes other than electron beam or X-ray radiation (electron microscopy, for example) nor those designed for medical purposes.

Technical Notes:

- The figure of merit K is defined as: $K=1.7 \times 10^3 V^{2.65} Q$. V is the peak electron energy in million electron volts. If the accelerator beam pulse duration is less than or equal to 1 μ s, then Q is the total accelerated charge in Coulombs. If the accelerator beam pulse duration is greater than 1 μ s, then Q is the maximum accelerated charge in 1 μ s. Q equals the integral of i with respect to t, over the lesser of 1 μ s or the time duration of the beam pulse ($Q=\int idt$) where i is beam current in amperes and t is the time in seconds.
- Peak power = (peak potential in volts) x (peak beam current in amperes).
- In machines based on microwave accelerating cavities, the time duration of the beam pulse is the lesser of 1 μ s or the duration of the bunched beam packet resulting from one microwave modulator pulse.
- In machines based on microwave accelerating cavities, the peak beam current is the average current in the time duration of a bunched beam packet.

4B003

Multistage light gas guns or other high-velocity gun systems (coil, electromagnetic, and electrothermal types, and other advanced systems) capable of accelerating projectiles to 2 km/s or greater.

4B004

Mechanical rotating mirror cameras, as follows, and specially designed components therefor:

- Framing cameras with recording rates greater than 225000 frames per second;
- Streak cameras with writing speeds greater than 0.5 mm/ μ s.

Note: In Item 4B004 components of such cameras include their synchronizing electronics units and rotor assemblies consisting of turbines, mirrors, and bearings.

4B005 Electronic streak cameras, electronic framing cameras, tubes and devices, as follows:

- Electronic streak cameras capable of 50 ns or less time resolution;
- Streak tubes for cameras specified in Item 4B005a;
- Electronic (or electronically shuttered) framing cameras capable of 50 ns or less frame exposure time;
- Framing tubes and solid-state imaging devices for use with cameras specified in Item 4B005c, as follows:
 - Proximity focused image intensifier tubes having the photocathode deposited on a transparent conductive coating to decrease photocathode sheet resistance;
 - Gate silicon intensifier target (SIT) vidicon tubes, where a fast system allows gating the photoelectrons from the photocathode before they impinge on the SIT plate;
 - Kerr or Pockels cell electro-optical shuttering;
 - Other framing tubes and solid-state imaging devices having a fast image gating time of less than 50 ns specially designed for cameras specified in Item 4B005c.

4B006 Specialized instrumentation for hydrodynamic experiments, as follows:

- Velocity interferometers for measuring velocities exceeding 1 km/s during time intervals of less than 10 μ s;
- Manganin gauges for pressures greater than 10 GPa;
- Quartz pressure transducers for pressures greater than 10 GPa.

Note: Item 4B006a includes velocity interferometers such as VISARs (Velocity interferometer systems for any reflector) and DLIs (Doppler laser interferometers).

4B007 High-speed pulse generators having both of the following characteristics:

- Output voltage greater than 6 V into a resistive load of less than 55 ohms; and
- 'Pulse transition time' less than 500 ps.

Technical Note: In Item 4B007b 'pulse transition time' is defined as the time interval between 10% and 90% voltage amplitude

4B008 Detonators and multipoint initiation systems, as follows:

- Electrically driven explosive detonators, as follows:
 - Exploding bridge (EB);
 - Exploding bridge wire (EBW);
 - Slapper;

- 4. Exploding foil initiators (EFI);
- b. Arrangements using single or multiple detonators designed to nearly simultaneously initiate an explosive surface over an area greater than 5000 mm² from a single firing signal with an initiation timing spread over the surface of less than 2.5 μ s.

Note: Item 4B008 does not control detonators using only primary explosives, such as lead azide.

Technical Note: In Item 4B008 the detonators of concern all utilize a small electrical conductor (bridge, bridge wire, or foil) that explosively vaporizes when a fast, high-current electrical pulse is passed through it. In nonslapper types, the exploding conductor starts a chemical detonation in a contacting high-explosive material such as PETN (pentaerythritoltetranitrate). In slapper detonators, the explosive vaporization of the electrical conductor drives a flyer or slapper across a gap, and the impact of the slapper on an explosive starts a chemical detonation. The slapper in some designs is driven by magnetic force. The term exploding foil detonator may refer to either an EB or a slapper-type detonator. Also, the word initiator is sometimes used in place of the word detonator.

4B009

Firing sets and equivalent high-current pulse generators, as follows:

- a. Explosive detonator firing sets designed to drive multiple controlled detonators specified by Item 4B008 above;
- b. Modular electrical pulse generators (pulsers) having all of the following characteristics:
 - 1. Designed for portable, mobile, or ruggedized-use;
 - 2. Enclosed in a dust-tight enclosure;
 - 3. Capable of delivering their energy in less than 15 μ s;
 - 4. Having an output greater than 100 A;
 - 5. Having a 'rise time' of less than 10 μ s into loads of less than 40 ohms;
 - 6. No dimension greater than 25.4 cm;
 - 7. Weight less than 25 kg ; and
 - 8. Specified to operate over an extended temperature range of 223° to 373° K (-50 °C to 100 °C) or specified as suitable for aerospace applications.

Note: Item 4B009b includes xenon flashlamp drivers.

Technical Note: In Item 4B009b5 'rise time' is defined as the time

interval from 10% to 90% current amplitude when driving a resistive load.

4B010 Switching devices as follows:

- a. Cold-cathode tubes, whether gas filled or not, operating similarly to a spark gap, having all of the following characteristics:
 - 1. Containing three or more electrodes;
 - 2. Anode peak voltage rating of 2.5 kV or more;
 - 3. Anode peak current rating of 100 A or more; and
 - 4. Anode delay time of 10 μ s or less;

Note: Item 4B010a includes gas krytron tubes and vacuum sprytron tubes.

- b. Triggered spark-gaps having both of the following characteristics:
 - 1. Anode delay time of 15 μ s or less; and
 - 2. Rated for a peak current of 500 A or more;
- c. Modules or assemblies with a fast switching function having all of the following characteristics:
 - 1. Anode peak voltage rating greater than 2 kV;
 - 2. Anode peak current rating of 500 A or more; and
 - 3. Turn-on time of 1 μ s or less.

4B011 Pulse discharge capacitors having either of the following sets of characteristics:

- a. 1. Voltage rating greater than 1.4 kV;
 2. Energy storage greater than 10 J;
 3. Capacitance greater than 0.5 μ F; and
 4. Series inductance less than 50 nH;

or

- b. 1. Voltage rating greater than 750 V;
 2. Capacitance greater than 0.25 μ F; and
 3. Series inductance less than 10 nH.

4B012 Neutron generator systems, including tubes, having both of the following characteristics:

- a. Designed for operation without an external vacuum system; and
- b. Utilizing electrostatic acceleration to induce a tritium-deuterium nuclear reaction.

4C**Technology**

Technology for the development, production or use of items in 4A and 4B.

5

Aerospace systems, equipment including production and test equipment, related technology, and specially designed components and accessories therefor.

5A

Rocket Systems (including ballistic missiles, space launch vehicles and sounding rockets)

5A1

Systems

5A101

Systems for missiles and rockets, including:

- a. complete rocket systems (including ballistic missile systems, space launch vehicles and sounding rockets)
- b. complete rocket stages with engines
- c. solid or liquid fuel rocket engines and their control systems including liquid propellant apogee engines designed or modified for satellites

Note: 5A101 does not control JATO units, propulsion units for flares, ejection seats, emergency escape equipment and rockets for display fireworks.

5A102 Subsystems and components usable in missiles and rockets including:

- a. rocket motor cases, interior lining, insulation and nozzles;
- b. rocket staging mechanisms, separation mechanisms and inter-stages;
- c. liquid and slurry propellant (including oxidizers), control systems, and components thereof, specially designed or modified for resistance to vibration;
- d. re-entry vehicles and equipment including
 - 1. Heat-shields and components thereof, fabricated of ceramic or ablative materials;
 - 2. Heat sinks and components thereof, fabricated of light weight, high heat capacity materials;
 - 3. Electronic equipment specially designed for re-entry vehicles.
- e. guidance systems and their components such as gyros and inertial reference units;
- f. thrust-vector control subsystems including methods of achieving thrust vector control such as flexible nozzle, fluid or secondary gas injection, movable engine or nozzle, deflection of exhaust gas stream (jet vanes or probes) and use of thrust tabs;
- g. hybrid rocket motors and components thereof;

- h. safing, arming, fusing and firing mechanisms for weapons or warhead.
- i. software specially designed for reduced observables such as radar reflectivity, ultraviolet/infrared signatures and acoustic signatures.

5A2 Production and Test Equipment.

5A201 Transonic, supersonic, hypersonic wind tunnels; gun tunnels; aeroballistic ranges.

5A202 Test and production equipment and facilities designed to handle systems in 5A1.

5A203 Test benches/stands, usable for complete rocket systems and subsystems (including ballistic missile systems, space launch vehicles and sounding rockets) which have the capacity to handle solid or liquid propellant rockets, motors or engines, or which are capable of simultaneously measuring the three axial thrust components.

5A204 Vibration test equipment (vibration test systems and vibration thrusters) and components using digital control techniques and feedback or closed loop test equipment and software thereof (Refer 4A006).

5A205 Flow-forming machines and specially designed components thereof which, according to the manufacturers technical specification,

1. can be equipped with numerical control units or a computer control,

even when not equipped with such units at delivery; and

2. have more than two axes which can be coordinated simultaneously for contouring control.

Note: Item 5A205 includes machines which have only a single roller designed to deform metal plus two auxiliary rollers which support the mandrel, but do not participate directly in the deformation process.

5A206 Filament winding machines for which the motion for positioning wrapping and winding fibres can be coordinated and programmed in two or more axes; precision mandrels thereof, and coordinating and programming controls;

5A207 Tape-laying machines of which the motions for positioning and laying tape and sheets can be coordinated and programmed in two or more axes;

5A208 Isostatic presses having all of the characteristics of maximum working pressure equal to or greater than 69 MPa or greater; designed to achieve and maintain a controlled thermal environment of 600°C or greater; and

possessing a chamber cavity with an inside diameter of 152 mm or greater.

5A209 Environmental chambers simulating vibration environments, with altitudes equal to or greater than 15 km, or temperature ranging between minus 50 and plus 125 degrees centigrade.

5A210 Environmental chambers simulating acoustic pressure level of 140 dB or greater or rated acoustic power output of 4 KW or greater, with altitudes equal to or greater than 15 km, or temperature ranging between minus 50 and plus 125 degrees centigrade.

5A211 Accelerators delivering electro-magnetic radiation produced by Bremsstrahlung from accelerated electrons.

5A212 Pulsed electron accelerators

5A213 Radial ball bearings having all tolerances specified in accordance with ISO 492 Tolerance Class 2 or better and having all the following characteristics:
a. An inner ring bore diameter between 12 and 50 mm;
b. An outer ring outside diameter between 25 and 100 mm; and
c. A width between 10 and 20 mm.

5A214 Liquid propellant tanks specially designed for the propellants controlled in Item 3A3 or other liquid propellants used in the systems specified in 5A and 5B.

5A215 Production facilities and production equipment specially designed for equipment or materials for 5A101 and 5A102.

5A216 Production equipment and specially designed components thereof, for the production, handling or acceptance testing of liquid propellants or propellant constituents as referred in 3A3;

5A217 Launch and ground support equipment and facilities usable for rocket systems (including ballistic missile systems, space launch vehicles and sounding rockets), unmanned airborne system and cruise missiles as follows:-
a. apparatus, devices and vehicles, designed or modified for the transport, handling, control, activation and launching of the systems.
b. gravity meters (gravimeters), gravity gradiometers, and specially designed components thereof, designed or modified for airborne or marine use usable for complete rocket systems and for complete unmanned aerial vehicle systems (including cruise missile systems

target drones and reconnaissance drones)

- c. telemetry and tele-command equipment, including ground equipment, designed or modified for complete rocket systems and complete unmanned aerial vehicle systems and cruise missiles, excluding control equipment designed or modified for manned aircraft or satellites, control ground based equipment designed or modified for terrestrial or marine application, and control equipment designed for commercial, civil or 'safety of life' (e.g. data integrity, flight safety) GNSS services
- d. radomes designed to withstand a combined thermal and pressure shock usable in protecting rocket systems, unmanned aerial vehicles and cruise missiles against nuclear effects (eg. electro-magnetic pulse (EMP), X-rays, combined blast and thermal effects).
- e. Software which processes post-flight, recorded data, enabling determination of vehicle position throughout its flight path.

5A218 Systems, specially designed for radar cross section measurement, usable for rocket systems (including ballistic missile systems, space launch vehicles and sounding rockets), unmanned airborne system and cruise missiles and their subsystems.

5A3 **Technology**

5A301 Technology related to the development, production, testing and use of items in 5A1 and 5A2.

5A302 Software for the development, production, and testing and use of items in 5A1 and 5A2.

5A303 Software which coordinates the function of more than one subsystem, specially designed or modified for use in the systems specified in 5A1 and 5A2.

5B **Unmanned aerial vehicles including cruise missiles, target drones and reconnaissance drones and related equipment, and specially designed components therefor:**

- a. Unmanned aerial vehicles including Remotely Piloted air Vehicles (RPVs) and autonomous programmable vehicles;
- b. Associated launchers and ground support equipment;
- c. Related equipment for command and control.
- d. Complete unmanned aerial vehicle systems (including cruise missile systems, target drones and reconnaissance drones)
- e. Light weight Turbojet and turbofan engines (including turbo

compound engines).

- f. Ramjet / Scramjet / pulse jet/ combined cycle engines, including devices to regulate combustion, and specially designed components.
- g. Complete unmanned aerial vehicle systems having an autonomous flight control and navigation capability or capability of controlled flight out of the direct vision range involving a human operator, designed or modified to incorporate an aerosol dispensation mechanism, or capable of carrying elements of a payload in the form of a particulate or liquid other than fuel components of such vehicles.

Note: This category does not control unpowered airborne vehicles such as gliders, hot air balloons etc.

- h. Safing, arming, fusing and firing mechanisms for weapons or warhead.
- i. Production facilities and Production equipment specially designed for equipment or materials for 5B.
- j. Technology, for the development, production or use of equipment, materials or software specified for 5B.
- k. Software, for the development, production or use of equipment or materials specified for 5B.
- l. Software which coordinates the function of more than one subsystem, specially designed or modified for use in the systems specified in 5B.

5C Avionics and navigation systems designed or modified for use in, or usable in rocket systems (including ballistic missile systems, space launch vehicles and sounding rockets), unmanned aerial vehicles and cruise missiles

5C001 Guidance systems and their components such as gyros and inertial reference units, and specially designed components therefor;

5C002 Integrated flight instrument systems which include gyrostabilizers or automatic pilots, and specially designed components therefor;

5C003 Compasses (including gyro-astro compasses), gyroscopes, accelerometers and inertial equipment and specially designed software thereof and specially designed components therefor.

5C004 Inertial or other equipment using accelerometers or systems incorporating such equipment, and specially designed integration software therefor;

5C005 Encrypted telemetry systems, equipment and software thereof.

5C006 Flight control system (including servo valves) designed or modified for the systems as follows:

- a. Hydraulic, mechanical, electro-optical or electro-mechanical flight control systems (including fly-by-wire systems);
- b. Attitude control equipment;

- c. Design technology for integration of flight control, guidance, and propulsion data into a flight management system for optimisation of rocket system trajectory.
- d. Specially designed test, calibration, and alignment thereof.

5C007	Integrated navigation system incorporating an inertial measurement device (example: an attitude and heading reference system, inertial reference unit, or inertial navigation system), one or more external sensor used to update the position and/or velocity, either periodically or continuously throughout the flight (example: satellite navigation receiver, radar altimeter and/or Doppler radar); integration hardware and software
5C008	Production equipment and other test, calibration and alignment equipment, designed or modified to be used with equipment specified in 5C001 – 5C004 and 5C007.
5C009	Equipment used to characterize mirrors for laser gyros such as scatterometer, reflectometer and profilometer and for other inertial equipments such as Inertial measurement unit (IMU Module) tester, IMU Platform tester, IMU stable element handling fixture, Gyro tuning test station, Gyro dynamic balance station, Gyro run-in/motor test station, Gyro evacuation and filling station, Centrifuge fixture for gyro bearings, Accelerometer axis align station and Accelerometer test station.
5C010	Avionics equipment and embedded or specially designed software and components thereof, including but not limited to: <ul style="list-style-type: none"> a. Radar and laser radar system including altimeter; b. Electronic assemblies and components; c. Design technology for protection of avionics and electrical subsystems against electromagnetic pulse (EMP) and electromagnetic interference (EMI) hazards from external sources. d. Passive sensors for determining bearings to electromagnetic sources (direction finding devices) or terrain characteristics e. Receiving equipment for Global Navigation Satellite Systems (GNSS: e.g. GPS, GLONASS, GALILEO), capable of operating at aircraft speeds and altitudes or above. f. Terrain contour mapping equipment, Scene mapping and correlation (both digital and analogue) equipment, Doppler navigation radar equipment, Passive interferometer equipment and Imaging sensor equipment (both active and passive) g. Design technology for electromagnetic shielding systems, the configuration of hardened electrical circuits and subsystems and for the determination of hardening criteria.
5C011	On-board electronic equipment, devices and their design and

manufacturing know-how (except warhead fuses, timers and sequencers), and embedded or specially designed software thereof.

5C012 Detectors designed or modified, in protecting rocket systems, unmanned aerial vehicles and cruise missiles against nuclear effects (eg. electro-magnetic pulse (EMP), X-rays, combined blast and thermal effects).

5C013 Radiation Hardened microcircuits usable in protecting rocket systems, unmanned aerial vehicles and cruise missiles against nuclear effects (e.g. electro-magnetic pulse (EMP), X-rays, combined blast and thermal effects).

5C014 Precision tracking systems using a code translator installed on the rocket or unmanned aerial vehicle in conjunction with either surface or airborne references or navigation satellite systems to provide real-time measurement of inflight position and velocity; Range instrumentation radars including associated optical/infrared trackers and related software.

5C015 Balancing machines capable of balancing rotors/assemblies and correcting unbalance in two planes or more.

5C016 Indicator heads or balancing instrumentation designed or modified for use with balancing machines

5C017 Motion simulators/rate tables (equipment capable of simulating motion) having all of the following characteristics two axes or more slip rings capable of transmitting electrical power and/or signal information

5C018 Position tables (equipment capable of precise rotary positioning in any axes) having two axes or more and a position accuracy equal to or better than 5 arc second

5C019 Centrifuges capable of imparting accelerations and having slip rings capable of transmitting electrical power and signal information

5C020 Design technology for integration of air vehicle fuselage, propulsion system and lifting control surfaces designed or modified for the unmanned aerial vehicle systems to optimize aerodynamic performance throughout the flight regime of an unmanned aerial vehicle system

5C021 Design technology for integration of the flight control, guidance, and propulsion data into a flight management system, designed or modified for the complete rocket systems, unmanned aerial vehicles and cruise missiles for optimization of the trajectory.

5C022 Technology for the development, production, or use of items in 5C.

5C023 Software for the development, production and use of items in 5C.

5C024 Software specially designed or modified for use in the systems specified in 5C.

5D. Manned-aircraft, aero-engines, related equipment and components:

Note: This category does not control foreign military aircraft or an Indian aircraft carrying a military registration number.

5D001 Combat aircraft and specially designed components thereof;

- Other aircraft specially designed or modified for military use, including military reconnaissance, assault, military training, transporting and air-dropping troops or military equipment, logistics support, and specially designed components thereof;
- Aero-engines specially designed or modified for military use, and specially designed components thereof;
- Airborne equipment, including airborne refuelling equipment, specially designed for use with the aircraft controlled by 5D001a or 5D001b or the aero-engines controlled by 5D001c, and specially designed components thereof;
- Pressure refuellers, pressure refuelling equipment, equipment specially designed to facilitate operations in confined areas and ground equipment, developed specially for aircraft controlled by 5D001a or 5D001b or for aero-engines controlled by 5D001c;
- Pressurized breathing equipment and partial pressure suits for use in aircraft anti-g suits, military crash helmets and protective masks, liquid oxygen converters used for aircraft or missiles, and catapults and cartridge actuated devices for emergency escape of personnel from aircraft;
- Parachutes:
 - Paragliders, drag parachutes, drogue parachutes for stabilization and attitude control of dropping bodies, (e.g. recovery capsules, ejection seats, bombs);
 - Drogue parachutes for use with ejection seat systems for deployment and inflation sequence regulation of emergency parachutes;
 - Recovery parachutes for guided missiles, drones or space vehicles;
 - Approach parachutes and landing deceleration parachutes.
- Automatic piloting systems for parachuted loads, equipment specially designed or modified for military use for controlled opening jumps at any height, including oxygen equipment.

Note 1: 5D001b does not control aircraft or variants of those aircraft specially designed for military use which:

1. Have been certified for civil use by the civil aviation authority of India, and
2. Are not configured for military use and are not fitted with equipment or attachments specially designed or modified for military use;

Note 2: The control in 5D001b and 5D001c on specially designed components and related equipment for non-military aircraft or aero-engines modified for military use applies only to those military components and to military related equipment required for the modification to military use.

5E **Microlight aircraft and powered 'hang-gliders'**

Category 6 [Reserved]

Category 7: **Electronics, computers, and information technology including information security**

7A **Electronics**

7A001 High-power microwave devices including tubes, travelling wave tubes (TWT) and phase shifters, and continuous wave and pulsed high power microwave travelling wave tube amplifiers (TWTa) operating at frequencies higher than 31 GHz, and their power supplies.

7A002 Microwave monolithic integrated circuits (MMIC) operating at frequencies above 3 GHz and surface acoustic wave (SAW) devices operating at frequencies above 2.5 GHz.

7A003 Phased array antennas and their elements

7A004 Radiation-hardened microprocessors, field programmable gate arrays and solid state memory devices

7A005 Microprocessor microcircuits, microcomputer microcircuits, microcontroller microcircuits, storage integrated circuits manufactured from a compound semiconductor, analogue-to-digital converter, and digital-to-analogue converter, printed circuit boards or modules, electro-optical or optical integrated circuits designed for signal processing, field programmable logic devices, neural network integrated circuits, custom integrated circuits for which either the function is unknown or the control status of the equipment in which the integrated circuit will be used is unknown, Fast Fourier Transform (FFT) processors, electrical erasable

programmable read-only memories (EEPROMs), flash memories or static random-access memories (SRAMs), having any of the following:

- a. Rated for operation at an ambient temperature above 398 K (+125°C);
- b. Rated for operation at an ambient temperature below 218 K (-55°C); **or**
- c. Rated for operation over the entire ambient temperature range from 218 K (-55°C) to 398 K (+125°C).

7A006 Radiation-hardened analogue-to-digital and digital-to-analogue converter integrated circuits, as follows:

- a. Analogue-to-digital converters having any of the following:
 1. A resolution of 8 bit or more, but less than 12 bit, with a total conversion time of less than 5 ns;
 2. A resolution of 12 bit with a total conversion time of less than 200 ns; **or**
 3. A resolution of more than 12 bit with a total conversion time of less than 2 μ s;
- b. Digital-to-analogue converters with a resolution of 12 bit or more, and a settling time of less than 10 ns.

7A007 Detector units operating in the thermal infrared, ultraviolet, x-ray and gamma ray spectrum.

7A008 Focal plane assemblies for imaging cameras operating in the visible, near and thermal infrared spectrum

7A009 Technology for the development, production or use of items specified in 7A005 and 7A006.

7B **Electronic test equipment**

7B001 Frequency synthesized signal generators with maximum frequency greater than 31 GHz

7B002 Network analysers operating at frequencies above 40 GHz

7C **Computers**

7C001 Digital computers and software as follows:

- a. Digital computers having a composite theoretical performance (CTP) exceeding 75000 (seventy-five thousand) million theoretical operations per second (Mtops)
- b. Software, and/or computer inter-connection schemes, whether or not

co-supplied with (a) designed to 'parallelise' digital computers (individually or any CTP rating) enabling a CTP of more than 75000 Mtops to be achieved by the 'parallelised' configuration

Technical notes:

1. The Composite Theoretical Performance (CTP) rating is to be calculated in accordance with the calculation scheme separately notified in this regard.
2. Individual digital computers each with a CTP rating of 75000 Mtops or less do not require an export license to any destination or end-user, unless supplied with (b) above.
3. Digital Computers' includes (1) hybrid computers incorporating 'digital computers' or specified in (a) above, systolic array computers, neural computers, optical computers, vector processors, digital signal processors, logical processors (2) digital electronic equipment designed for 'image enhancement' or signal processing other than when supplied as integral adjuncts to medical imaging (eg CAT-scanning) equipment.

7C002 Analogue, digital or hybrid computers, digital differential analysers, and specially designed software therefor, for use in, or for modelling, simulation, or design integration of rocket systems, unmanned aerial vehicles and cruise missiles.

7C003 Technology for the development, production or use of items in 7C002.

7D **Information technology including information security**

7D001 Data processing security equipment, data security equipment and transmission and signalling line security equipment, using ciphering processes.

7D002 Identification, authentication and keyloader equipment and key management, manufacturing and distribution equipment.

7E **[Reserved]**